ระบบกำจัดมอดข้าวประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ในครัวเรือน



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

HIGH EFFICIENCY WEEVILS CONTROL SYSTEM FOR

HOME-USE APPLICATION



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Electronic Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2018

ระบบกำจัดมอดข้าวประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ในครัวเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



(ศ. คร.สันติ แม้นศิริ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาณุพงษ์ แซ่อึ้ง : ระบบกำจัดมอดข้าวประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ในครัวเรือน (HIGH EFFICIENCY WEEVILS CONTROL SYSTEM FOR HOME-USE APPLICATION) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ คร.ชาญชัย ทองโสภา, 97 หน้า.

แนวโน้มการบริโภคของผู้คนกำลังเข้าสู่การบริโภคแบบคลืนที่ เป็นอาหารปลอดสารเคมี โดยเฉพาะสารเคมีที่อยู่กับผลผลิตทางการเกษตร แม้แต่ในข้าวก็มีสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลง มอดข้าว การกำจัดมอดข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีการ ก้นคว้าวิจัยเรื่อยมาคือการกำจัดมอดข้าวด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค (Dielectric heating) หรือ RF (Radio frequency) heating งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาระบบกำจัดมอดข้าวให้สามารถใช้ งานภายในครัวเรือน ด้วยการใช้อุปกรณ์ขยายขนาดเล็กสัญญาณประสิทธิภาพสูง Laterally Diffused MOSFET (LDMOS) ที่มีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการออกแบบสำหรับเครื่องขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน การออกแบบพัฒนาระบบกำจัดมอดข้าวนี้ เพื่อทดแทนการกำจัดมอดข้าวให้สามารถใช้ สารเคมีแบบดั้งเดิม ที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเนื่องจากสารเคมีตกค้างในอาหาร อีกทั้งยังทำให้ ชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายเนื่องจากสารเคมีดังกล่าว

ผลการทคลองการออกแบบเพลตขนาคพบว่า เมื่อขนาคเพลตขนานใหญ่ขึ้นส่งผลให้ กวามถี่ที่เพลต Resonance ต่ำลง อีกทั้งอัตราส่วนของเพลตไม่มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญ การเลือกใช้ กวามถี่ส่งผลต่ออัตราการให้กวามร้อนของข้าวและมอดข้าว โดยที่กวามถี่ต่ำอัตราการให้กวามร้อน ต่ำ แต่มีการกระจายตัวของกวามร้อนสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกันข้ามกับกวามถี่สูงที่ให้อัตราการให้กวาม ร้อนที่ดี แต่มีการกระจายตัวที่แย่ ด้วยการออกแบบเพลตขนานที่เหมาะสมกับกวามถี่ที่ใช้งานจะทำ ให้กวามเข้มสนามไฟฟ้าสูง และส่งผลให้การกระจายตัวของสนามไฟฟ้ามีกวามสม่ำเสมอ

ผลการทดลองระบบกำจัดมอดข้าว โดยใช้ RF power 300 W และ 773 W ที่ระยะเวลาการ ให้ความร้อน 2, 4, 10 วินาที พบว่ามอดข้าวมีอัตราการตายสูงเมื่ออยู่ภายใต้ความเข้มสนามไฟฟ้าสูง เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับพลังงานที่มอดได้รับ แต่แปรผกผันกับคุณภาพ ของข้าว เพราะข้าวเสียหายจากการที่อุณหภูมิสูงมากเกินไป ต้นทุนค่าไฟฟ้าในการกำจัดมอดจาก การทดลองสามารถแทนที่การกำจัดมอดด้วยสารเคมี ระบบกำจัดมอดข้าวที่พัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ที่ 64%

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์</u> ปีการศึกษา 2561

ลายมือชื่อนักศึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	

PHANUPONG SAEUNG : HIGH EFFICIENCY WEEVILS CONTROL SYSTEM FOR HOME-USE APPLICATION. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. CHANCHAI THONGSOPA, Ph.D., 97 PP.

DIELECTRIC HEATING/RICE WEEVIL CONTROL/SSPA/HIGH EFFICIENCY

Thai people trending about food was going to food safety they will care much about their food and worrying health being affected from residue pesticide and others chemical in food. Rice has been one of favorited food in Thailand. One of major problem about rice was rice weevil (Sitophilus oryzae [Linnaeus]). Rice weevil causing rice damaged including reduced quality, weight losses, reduced nutrition, low germination rate, increased bacteria and fungi and many more. Rice weevil can be eliminated by using chemical fumigation. However, only adult rice weevil will be killed, and not too long rice will be infested with rice weevil again. Generally, in order to eliminate all stage of rice weevil in one process dielectric heating has been used. Dielectric heating in rice also not harmful to health and environments. To have this dielectric heating works for home-use the Laterally Diffused MOSFET (LDMOS) is selected as active device in RF amplifier. Therefore, the parallel plate applicator was studied to work together with RF amplifier.

It was found that for larger parallel plate caused resonance frequency to lower. It has no significant to change the ratio of plate. Selecting frequency for dielectric heating found that using low frequency has better heat uniformly but poor heat rate and using in high frequency has good heat rate but heat uniformly was unacceptable. By designing the parallel plate to the appropriate frequency will yield good heat rate and heat uniformly.

The experimental of rice weevil insect pest control system using dielectric heating compared two RF powers 300 and 773 W both used same exposure time 2, 4 and 10 second. The results gave that rice weevil has high elimination rate when exposed to high strength electric field and long exposure time. The mortality was proportional to the RF energy but inverse-proportional to the quality of rice. The results of using the prototype SSPA insect pest control system in rice weevil pest control, 64% overall efficiency was obtained. This rice weevil insect pest control is capable of replacing the traditional chemical fumigation in term of cost. The advantage of high efficiency in dielectric heating not only for insect pest control but also could apply to any related applications that use dielectric heating.



School of <u>Electronic Engineering</u>

Student's Signature	
0	

Academic Year 2018

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งในด้านวิชาการและด้านการดำเนินงานวิจัย จากบุคคลและกลุ่ม บุคคลดังต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ คร.ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เมตตาให้การ อบรมสั่งสอน ชี้แนะ ช่วยเหลือในการทำก<mark>ารศึ</mark>กษาวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำในการเขียน และ ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ ที่กรุณาให้การแนะนำ คำปรึกษา ชี้แนะ แนวทางการเขียน และช่วยตรวจทานเนื้อหาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ คร.สำราญ สันทาลุนัย ที่กรุณาให้การแนะนำ และตรวจทานเนื้อหาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ คร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ ที่กรุณาให้การแนะนำ คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี ที่ให้ทุนสนับสนุนใน การทำวิจัย รวมถึงบุคลากรประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทค โน โลยี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการทำวิจัย

> ะ รักษาลัยเทคโนโลยีสุรุบา

ภาณุพงษ์ แซ่อิ้ง

สารบัญ

บทคัดย	่อ (ภาษ	าไทย)	ุก
บทคัดย	่อ (ภาษ	าอังกฤษ)	า
กิตติกร	รมประ	กาศ	१
สารบัญ	ļ		ງ
สารบัญ	ุตาราง <u>.</u>		¥
สารบัญ	เรูป <u></u>		<u> </u>
บทที่			
1	บทน <u>ำ</u>	<u> </u>	1
	1.1	ความเป็นมาและ <mark>ควา</mark> มสำคัญของปัญหา	1
	1.2	จุดประสงค์งานวิจัย	4
	1.3	สมมุติฐานของการวิจัย	4
	1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2	ทบทว	นวรรณกรรม งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
	2.1	ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
	2.2	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	20
		2.2.1 ตัวเก็บประจุแบบเพลตขนาน (Parallel plate capacitor)	20
		2.2.2 วัสคุใดอิเล็กทริก Dielectric materials	20
3	การออ	າກແບນກາ ຮ ົວຈັຍ	28
	3.1	พารามิเตอร์ของเพลตที่เกี่ยวข้อง <u>.</u>	30
	3.2	การจำลองทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเคลของเพลตใน CST	31
	3.3	วัสคุที่ใช้สร้างเพลต	36
	3.4	ค่าสภาพยอมของข้าว (Permittivity of rice)	36
		3.4.1 การวัดค่าสภาพยอมของข้าว (Measured of permittivity of rice)	37
	3.5	การออกแบบเครื่องกำจัดมอดข้าวสำหรับครัวเรือน	40

สารบัญ (ต่อ)

		3.5.1 การออกแบบเพลตสำหรับการให้ความร้อนแบบไคอิเล็กทริค	40
		3.5.2 การเลือกใช้เครื่องขยายสัญญาณความถี่สูงกำลังสูง	41
	3.6	การออกแบบวงจร Matching network	42
	3.7	ประสิทธิภาพ	43
		3.7.1 ประสิทธิภาพของเครื <mark>่อง</mark> ขยายสัญญาณ	43
		3.7.2 ประสิทธิภาพการแ <mark>ลกเปลี่ย</mark> นความร้อน	44
		3.7.3 ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ	45
	3.8	การกำจัดมอดข้าวด้วยกา <mark>ร</mark> ให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค <u></u>	<u></u> 46
	3.9	การประเมินคุณภาพข <mark>อง</mark> ข้าวหลังก <mark>ารก</mark> ำจัคมอคด้วยการให้ความร้อนแบบ	
		ใดอิเล็กทริก	47
4	ผลกา	รวิจัย และอภิปรา <mark>ยผล</mark>	48
	4.1	ผลการศึกษาพารามิเตอร์เพลตที่เกี่ยวข้อง	48
		4.1.1 ความยาวของเพลต	51
		4.1.2 ความกว้างของเพลต	55
		4.1.3 พื้นที่ของเพลต	
		4.1.4 สนามไฟฟ้าภายใ <mark>นวัสดุที่อยู่ระหว่างเพล</mark> ต	
		4.1.5 ระยะห่างระหว่างเพลต	
	4.2	ผลการวัดค่าสภาพยอมของข้าว (Permittivity of rice)	
	4.3	ผลการทดสอบ Power amplifier	70
	4.4	การออกแบบสร้างเพลตขนานสำหรับการให้ความร้อนแบบไคอิเล็กทริค <u></u>	74
	4.5	ผลการทดสอบระบบกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริค	
	4.6	ผลการทดลองการกำจัดมอดข้าวด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค	
		และคุณภาพของข้าว	
5	สรุปผ	เลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	90
	5.1	สรุปผลการวิจัย	90
	5.2	ข้อเสนอแนะ	90

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

รายการอ้างอิง	92
ภาคผนวก บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา	95
ประวัติผู้เขียน	97



สารบัญตาราง

ตาราง	งที่ หน้า	l
4.1	ผลการจำลองความถี่ที่เพลต Resonant เมื่อขนาดความยาวของเพลตเปลี่ยน52	2
4.2	ผลการจำลองกวามถี่ที่เพลต Resonant เมื่อขนาดกวามยาวของเพลตเปลี่ยน	
	โดยมีเงื่อนใขเริ่มต้น ที่ความกว้างเพล <mark>ตเท</mark> ่ากับ 50 mm และระยะห่างระหว่าง	
	เพลตเท่ากับ 10 mm51	3
4.3	ผลการจำลองความถี่ที่เพลต Resonant เมื่อ <mark>ข</mark> นาดความยาวของเพลตเปลี่ยน	
	โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 10 mm และระยะห่างระหว่าง	
	เพลตเท่ากับ 50 mm54	4
4.4	ผลการจำลองความถี่ที่เพลต Resonant เมื่องนาค <mark>ควา</mark> มกว้างของเพลตเปลี่ยน50	6
4.5	ผลการจำลองขนาดของเพ <mark>ลต</mark> ที่อัตราส่วน และพื้ <mark>นที่ข</mark> องเพลตต่างกัน	
	เพื่อหาความสัมพันธ์ของความถี่ที่ Resonance และการสะท้อนกลับ58	8
4.6	ความเข้มของสนามไฟฟ้าเมื่อมุมเฟสเปลี่ยนไป ของเพลตที่ Resonance ที่ 10 MHz6	1
4.7	ความเข้มของสนา <mark>มไฟฟ้าเมื่อมุมเฟสเปลี่ยนไป ของเ</mark> พลตที่ Resonant ที่ 80 MHz6	6
4.8	Power dissipation ที่เกิดขึ้นในมอดที่ความถี่ 1 – 2450 MHz เมื่อให้ $2\pi E^2 \varepsilon_0 = 1$ 7	1
4.9	ผลการวัด Harmonics ของ RF Oscillator ที่ความถี่ 80 MHz	3
4.10	อัตราการตาขของมอดกับระยะเวลาในการให้ความร้อนและกำลังที่ใช้8	7
	^{เอ} กยาลัยเทคโนโลยีสุระ	

สารบัญรูป

รูปที่	หน้	์ก
1.1	วงจรชีวิตมอดข้าว (S. oryzae) จากไข่เป็นตัวอ่อน ดักแด้ และตัวโตเต็มวัย	
	(Davis, 2011)	_2
2.1	แผนภาพคลื่นตกกระทบกับวัสคุไคอิเ <mark>ล็ก</mark> ทริคที่มีบางส่วนสะท้อนออกมา	
	และระยะความลึกที่เรียกว่า Penetration depth ซึ่งขึ้นกับความถี่และชนิดของวัสดุ	
	คังสมการ (2.3) (Hou et al., 2016)	10
2.2	ผลการ Simulation ของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริคกับวัตถุรูปร่าง	
	ต่างแบบกัน 10 แบบ (Ferrari-John et al., 2 <mark>016)</mark>	1
2.3	เครื่องกำจัดแมลงด้วย Dielectric heating แบบสายพาน (Zhou & Wang, 2016b)	4
2.4	เครื่องกำจัดแมลงด้วยการ <mark>ให้ค</mark> วามร้อนแบบไดอิเ <mark>ล็กท</mark> ริกแบบปล่อยข้าวไหลในแนวดิ่ง	
	(Vearasilp et al., 2015)	15
2.5	เครื่องกำจัดแมลงโดยใช้สนามไฟฟ้าสลับแรงสูง (ซ้าย) แบบ Coaxial	
	และ (ขวา) แบบเพลตขนาน (Ponomaryova et al., 2009)1	15
2.6	Setup ของชุดอุปก <mark>รณ์ให้คว</mark> ามร้อนเพื่อศึกษาผลกระท <mark>บทาง</mark> ความร้อนที่มีต่อตัวมอดข้าว	
	(Yan et al., 2014)	16
2.7	ผลการทดลองจากการศึกษาผลกระทบทางความร้อนต่อตัวมอด (Yan et al., 2014)1	16
2.8	(ซ้าย) โมเดลสามมิติ Y-maze chamber และ (ขวา) ภาพ cross section ของ cross section	
	แสดงตำแหน่งทางเข้าของมอดข้าว บริเวณมืดและบริเวณที่ใช้แสง (Jeon et al., 2012)1	18
2.9	อัตรารอคของมอคข้าวเมื่อถูกรมด้วย Basil oil ความเข้มข้น 10% และชุคควบคุม	
	ที่ไม่ผ่านการใช้ Basil oil (Follett et al., 2014)	19
2.10	(ซ้าย) Set up ของการให้ความร้อนแบบอินฟราเรคเพื่อกำจัคไข่มอค และ (ขวา) จุคที่	
	เหมาะสมสำหรับการให้ความร้อนแบบอินฟราเรค ที่ให้อัตราการตายของไข่มอคสูงใน	
	ขณะที่ยังรักษาคุณภาพของข้าว (Duangkhamchan et al., 2017)1	19
2.11	การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของเพลตขนานที่มีประจุ Q2	22
2.12	เส้นทางการอินทิเกรต เพื่อหาสนามไฟฟ้าระหว่างเพลตขนาน2	22
2.13	ค่า Dielectric permittivity ที่ขึ้นกับความถี่ ทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพ (Kasap, 2006)2	23

รูปที่	۱	าน้ำ
2.14	เมื่อมีสนามไฟฟ้าคงที่ค่าหนึ่งเปลี่ยนจาก $E_{ m o}$ เป็น E อย่างกะทันหัน ทำให้	
	Induced dipole moment ลดลงจาก $lpha_{_d}(0) E_{_0}$ เป็น $lpha_{_d}(0) E$ การลดลงนี้เกิดขึ้นจาก	
	Random collisions ของโมเลกุล (Kasap, 2006)	26
2.15	ค่า Relative permittivity ในรูปของจ <mark>ำนว</mark> นเชิงซ้อน และเกิด Relaxation peak ที่	
	$\omega = 1/\tau$ (Kasap, 2006)	_27
2.16	(ซ้าย)ตัวเก็บประจุแบบเพลตขนานท <mark>ี่มีแรงค</mark> ันไฟฟ้าสลับแบบ Sinusodal มีความ	
	สมมาตรเท่ากับฝั่ง (ขวา) วงจรสมมู <mark>ล</mark> ของตั <mark>ว</mark> เก็บประจุที่มีความนำ G_{μ} ขนานกับ	
	ตัวเก็บประจุ (Kasap, 2006)	27
3.1	ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการ <mark>ออกแบบต้นแบบ</mark> การกำจัดมอดข้าวสำหรับ	
	ใช้ในครัวเรือน	28
3.2	IR camera หรือ Imaging infrared thermometer (U5857A, Keysight)	29
3.3	หน้าจอหลักของ CST เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา	31
3.4	หน้า Summary ของการสร้าง Template ใน CST	32
3.5	วงจรของโหลดเพ <mark>ลตข</mark> นานพร้อมชุด Matching network (Inductor)	<u>33</u>
3.6	3D โมเคลของเพล <mark>ตขนานพร้อม Port และ Matching netwo</mark> rk ที่ขึ้นรูปใน CST	34
3.7	ผลลัพธ์ค่า S11 ที่ได้จากกา <mark>รใช้โปรแกรมจำลองทางคอ</mark> มพิวเตอร์ <u>.</u>	35
3.8	ขั้นตอนการศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเพลตขนาน โดยใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ช่วย <u>.</u>	35
3.9	เครื่องบดวัสคุ Cross beater mill (PULVERISETTE 16, FRITSCH GmbH)	38
3.10	การจัดชุดการวัดค่าไดอิเล็กทริกของข้าวโดยใช้ Dielectric probe	40
3.11	ระบบการกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูง	_45
3.12	ระยะเวลาที่ให้ความร้อนเทียบกับอุณหภูมิ และพื้นที่ของการกำจัดแมลงในขณะที่	
	ยังรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ (Hou et al., 2016)	_46
4.1	ค่าไคอิเล็กทริคของข้าว (Wheat) และมอดข้าวในช่วง 5 kHz – 20 GHz (ซ้าย)	
	เปรียบเทียบค่า Dielectric constant ของข้าวและมอค (ขวา) เปรียบเทียบค่า	
	Dielectric loss factor ข้าว และมอดข้าว โดยมีจุด Relaxation peak ของมอดที่	
	ประมาณ 40 MHz (Nelson, 2005)	<u>49</u>

รูปที่		หน้า
4.2	กำหนดก่าไดอิเล็กทริคของวัสดุใน CST เพื่อให้มีก่าคุณสมบัติใกล้เกียงกับข้าว	
	ในความเป็นจริง (ซ้าย) กำหนด Dielectric dispersion ที่กำหนด โดย User (ขวา)	
	กำหนดจุดของ ค่าไดอิเล็กทริค โดยกำหนดสามจุดความถื่	<u>49</u>
4.3	ค่าคุณสมบัติของวัสดุที่กำหนดโดยผู้ใ <mark>ช้ง</mark> าน โดยกำหนดให้มีความใกล้เคียงกับค่า	
	ใดอิเล็กทริกของข้าว เพื่อให้การจำลอ <mark>งผ</mark> ลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความแม่นตรง <u>.</u>	50
4.4	ขนาดเริ่มต้นของเพลตขนาน 10 x 1 <mark>0 x</mark> 10 mm โดยใช้ PCB เป็นเพลตและมีวัสดุ	
	ใดอิเล็กทริคอยู่ภายในระหว่างเพลต <u>.</u>	50
4.5	ผลการจำลองค่าพารามิเตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดของเพลต ค่า S11 มีแนวโน้ม	
	ทางกวามถี่ต่ำลงเมื่อขนาดกวาม <mark>ยา</mark> วเพลตเพิ่มขึ้น ที่กวามกว้างเพลตเท่ากับ 10 mm	
	และระยะห่างระหว่างเพลต <mark>เท่า</mark> กับ 10 mm	51
4.6	ผลการจำลองค่าพารามิเต <mark>อร์</mark> S11 ของการเปลี่ยนข <mark>นาด</mark> ของเพลต ค่า S11 มีแนวโน้ม	
	ทางความถี่ต่ำลงเมื่อขนาคความยาวเพลตเพิ่มขึ้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 50 mm	
	และระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm	53
4.7	ผลการจำลองค่าพ <mark>ารามิ</mark> เตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดข <mark>องเพ</mark> ลต ค่า S11 มีแนวโน้ม	
	ทางความถี่ต่ำลงเมื่อขนาดความยาวเพลตเพิ่มขึ้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 10 mm	
	และระยะห่างระหว่างเพล <mark>ตเท่ากับ 50 mm</mark>	54
4.8	ผลการจำลองก่าพารามิเตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดของเพลต ก่า S11 มีแนวโน้ม	
	ทางความถี่ต่ำลงเมื่อขนาดความกว้างเพลตเพิ่มขึ้น ที่ความยาวเพลตเท่ากับ 10 mm	
	และระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm	_56
4.9	สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณเพลตขนานที่มุมเฟส () องศา (ซ้าย) มุมมองด้านบนเพลต	
	สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในเพลตมีความเป็น Uniform สูง ถึงแม้บริเวณขอบจะมี	
	การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าแบบ Fringing fields แต่สนามไฟฟ้าบริเวณภายใน	
	วัสคุไคอิเล็กทริคยังคงมีความ Uniform (ขวา) มุมมองค้านข้างของเพลต ที่ขอบ	
	ของเพลตมีสนามไฟฟ้ากระจายตัวออกมาจากเพลตเล็กน้อย	60
4.10	สนามไฟฟ้าที่กะจายตัวบริเวณเพลต (บน) ที่สนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงสุดที่มมเฟส	
	60 องศา และ (ล่าง) ที่สนามไฟฟ้ามีความเข้มต่ำที่สุดที่มุมเฟส 150 องศา	<u>60</u>

รูปที่	·	หน้า
4.11	การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในเพลต จากซ้ายไปขวาที่มุมเฟส0, 45, 90 และ	
	120 องศา ที่ความถี่ 80 MHz, 500 MHz และ 1200 MHz	62
4.12	การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของเพลตที่ Resonant ที่ 80 MHz ที่มุมเฟส 90 องศา	
	ซึ่งทำให้มีความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุด	65
4.13	ภาพตัดขวางของวัสดุไดอิเล็กทริกที่อยู่ <mark>ระ</mark> หว่างเพลต (ซ้าย) การกระจายตัวของ	
	Power loss density และ (ขวา) การกระจายตัวของ SAR	67
4.14	ภาพตัดขวางของวัสดุไดอิเล็กทริกที <mark>่อ</mark> ยู่ระห <mark>ว่</mark> างเพลต เพื่อดูการกระจายตัวของ	
	Power loss density (ซ้าย) การเพิ่ม Margin ที่ขอบของด้านความกว้างเพลต	
	5mm และ (ขวา) เพิ่ม Margin ทั้งด้านกว้างและด้านยาวเพลตด้านละ 5 mm	67
4.15	ผลการวัคค่าไคอิเล็กทริคข <mark>องข</mark> ้าวสาร (เส้นทึบ) <mark>และ</mark> ข้าวเหนียว (เส้นจุค) ที่ความถี่	
	10 – 1000 MHz (บน) ผล <mark>การ</mark> วัดค่า Dielectric con <mark>stan</mark> t คุณสมบัติทางไคอิเล็กทริคของ	
	ข้าวสองชนิคมีค่าใกล้เ <mark>กี่</mark> ยงกัน โค <mark>ยข้าวสารมีค่าคงที่ไคอิ</mark> เล็กทริกต่ำกว่าข้าวเหนียวโคย	
	เฉลี่ย 0.37 และ (ล่าง) ผลการ วัดค่า Dielectric loss factor ช่วงความถี่ที่ต่ำกว่า 300 MHz	
	มีบางช่วงที่มีค่าติ <mark>คลบ</mark> ซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนื่องจาก Dielectric probe	
	ที่ใช้เป็นประเภทคว <mark>ามถี่สูง แต่ในทางต</mark> รวจสอบควา <mark>มแตกต่</mark> างระหว่างวัสคุไดอิเล็กทริค	
	สองชนิด สามารถใช้ระบุถึ <mark>งความแตกต่างกันหรือควา</mark> มเหมือนกันได้ ผลการวัคที่ได้	
	ข้าวสารมีค่าต่ำกว่าข้าวเหนียว โดยเฉลี่ย 0.10 ซึ่งแทบจะ ไม่แตกต่างกัน <u></u>	69
4.16	การทคสอบ Oscillator ที่ความถี่ 80 MHz โคยวัคกำลังส่งและ Harmonic ของสัญญาณ	72
4.17	การทดสอบ Power amplifier ที่ความถี่ 80MHz	74
4.18	เพลตที่ใช้ VNA วัค Impedance และ วัคค่า S11 (ซ้าย) เพลตขนาคเล็ก (5 x 5 x 1 cm)	
	(ขวา) เพลตขนาดกลาง (12 x 12 x 2 cm)	75
4.19	ผลการวัดเพลตขนานโดยใช้ VNA (ซ้าย) วัดเพลตขนาคเล็ก S11 อยู่ที่ความถึ่	
	77.13 MHz มีค่าประมาณ -25 dB และ (ขวา) ผลการวัดของเพลตขนาดกลาง S11	
	อยู่ที่ความถี่ 57.6 MHz ที่ -21 dB	75
4.20	การใช้เครื่อง Impedance analyzer วัด Impedance ของเพลตขนานที่สร้างขึ้น	78
4.21	เพลตขนาด 4.5x7x13 cm ใด้ Impedance 50.5-j510 Ω ที่ความถี่ 19.37 MHz	78

รูปที่		หน้า
4.22	ออกแบบเพลตขนาด 12x3.5x7 cm ให้ใช้ได้กับระบบ 50 Ω ที่ 95 MHz	79
4.23	ยืนยันผลการออกแบบเพลต โดยใช้ VNA ในการวัดค่า S11 ได้ -10.24dB @95 MHz	79
4.24	การทดสอบเพลต (ซ้ำย) ชุดทดสอบ RF power amplifier และเพลต (ขวา) วัดความ	
	ร้อนของข้าวในเพลต	80
4.25	การออกแบบวงจร Impedance matching โดยใช้ Smith chart	80
4.26	การทคสอบผลการออกแบบเพลต <mark>10</mark> 0 kg/hr ได้ S11 -10.2 dB ที่ความถี่ 95 MHz	81
4.27	การทดสอบให้ความร้อนแบบ Dielectric heating ของการออกแบบเพลต 100 kg/hr	
	ที่ความถี่ 95 MHz	82
4.28	การจัดชุดการทดลองระบบ <mark>กำ</mark> จัดมอดข้าวด้วยกา <mark>รให้</mark> กวามร้อนแบบไดอิเล็กทริก <u></u>	84
4.29	ข้อมูลภาพที่ได้จาก IR camera (U5857A, Keysight) ของการให้ความร้อนแบบ	
	ใดอิเล็กทริคด้วยกำลัง 300 W ตั้งแต่เวลา 0 – 60 วินาที (บน) ที่เวลา 0 วินาที อุณหภูมิ	
	ของทั้งสามจุดใกล้เ <mark>คีย</mark> งอุ <mark>ณหภูมิพื้นหลังที่ 25 °C (กล</mark> าง) เมื่อผ่านไป 7 วินาที อุณหภูมิ	
	ของข้าวอยู่ที่ประ <mark>มาณ</mark> 50 °C ซึ่งเพียงพอต่อการกำจัดมอดข้าว อุณหภูมิที่ Matching	
	network เพิ่มขึ้นจา <mark>กเดิม 3 °C และอุณหภูมิพื้นหลังยังคงเท่า</mark> เดิม และ (ล่าง) ที่เวลา	
	ผ่านไป 60 วินาที อุณหภูมิของข้าวเท่ากับ 152 °C	85
4.30	อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (Heat rate) ของการให้ความร้อนแบบไคอิเล็กทริกกับวัสคุ	
	ใดอิเล็กทริกที่เป็นข้าว (เส้นทึบ) ใช้กำลัง RF power 773 W Heat rate ที่ดีที่สุดเท่ากับ	
	10.5 °C/s และ (เส้นประ) RF power เท่ากับ 300 W ใด้ Heat rate เท่ากับ 4.76 °C /s	86

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้อาหารปลอดสารพิษได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกหนึ่งในอาหารที่ ้เป็นอาหารหลักของคนไทยคือ ข้าว ปัญหาข<mark>อง</mark>การเก็บข้าวที่สีแล้ว (Milled rice) คือมีแมลงมอดข้าว (Rice weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Sitophilus oryzae (Linnaeus) (ย่อ S. oryzae) มาทำลายข้าว ้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณขอ<mark>งข้าวที่เ</mark>ก็บ สร้างความเสียหาย รวมทั้งยังส่งผลต่อความ เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไป นอก<mark>งา</mark>กนี้ข้<mark>าว</mark>ที่ปนเปื้อนมอดข้าวยังสร้าง Bacteria และ Fungi ู้ขึ้นมาอย่างมาก ก่อให้ข้าวมีเชื้อโรค สก<mark>ป</mark>รก และ<mark>อ</mark>าจทำให้ส่งผลเสียต่อการบริโภคข้าวที่ปนเปื้อน เหล่านี้ (Zakladnoy, 2018) จึงมีวิธีก<mark>ำจั</mark>คมอดข้าว<mark>ด้ว</mark>ยการรมสารเคมีเพื่อทำลายมอด (Chemical fumigation) การกำจัดมอดข้าวด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มโรงสีผ้ผลิตข้าวมาก เนื่องจากมี ์ ต้นทุนไม่สูง มอคตัวโตเต็มวัย<mark>ถูกก</mark>ำจัคหมุคสิ้น อีกทั้งไ<mark>ม่มีส</mark>ารเคมีหลงเหลือเนื่องจากสารเคมีที่ใช้ ในการรมข้าวคือ Methyl bromide (CH₃Br) ซึ่งมีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 3 °C ที่อุณหภูมิปกติ ในประเทศไทยมีค่าระหว่าง 20 - 35 °C สารเคมีนี้จะเดือดและระเหยเป็นไอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ้อย่างไรก็ตามผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับการตกค้างของสารเคมีในข้าว รวมถึงความกังวล เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ โ<mark>ลก เนื่องจาก Methyl bromide เมื่อระเ</mark>หยกลายเป็น ไอ จะลอยเข้าสู่ชั้น ้บรรยากาศโลกและทำลายชั้นโอโซนบริเวณขั้วโลก ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่อาจจะ เกิดจากการที่มีสารเคมีตกก้างในอาหาร ซึ่งสามารถส่งผลแบบเฉียบพลันหากสัมผัสโดยตรง รวมถึง อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้หากมีการบริโภคสะสมในปริมาณมาก และความกังวลเกี่ยวกับ ้สภาพสิ่งแวคล้อมที่ส่งผลต่อทกชีวิตบนโลก ทำให้มีการห้ามใช้และนำเข้าสินค้าที่มีสารเคมี เช่น Methyl Bromide, Methyl Parathion, Methoxy Ethyl Mercuric Chloride, Monocrotophos, Sodium Cyanide และอีกหลาย ๆ ชนิด ในหลายประเทศ ซึ่งอาจมีผล ต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งในระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนี้การถูกทำลายของชั้นโอโซนในบรรยากาศโลกโดยสารเคมีที่ใช้ในการ ้ควบคุมแมลง ได้มีหลายประเทศตระหนักถึงปัญหานี้ซึ่งนำไปสู่การทำสนธิสัญญาร่วมกัน เพื่อ ต่อต้านการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง ในปี 1992 ชื่อว่าสนธิสัญญา Montreal protocol (United States Environmental Protection Agency) เป็นการผลักคันให้ผู้คนตระหนัก ถึงภัยอันตรายที่กำลัง ก่อตัวขึ้นจากการใช้สารเคมีในอาหาร

การใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงมอดข้าวไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อมบนโลกด้วย แต่หากไม่ใช้สารเคมี แมลงมอดข้าวก็จะทำลายข้าวทำให้ข้าวเสียหายจาก การเก็บข้าว เกษตรกรในประเทศไทยที่ทำนาเอง หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำข้าวไปสีเอาเปลือกข้าวออก แล้วเก็บข้าวที่สีแล้วไว้ ข้าวที่เก็บหากมีมอดข้าวปนเปื้อนจะเจอปัญหาน้ำหนักข้าวตก ราคาขายไม่ดี หากจะนำข้าวมากินเอง ข้าวก็สูญเสียคุณภาพ การเก็บข้าวเป็นระยะเวลานานไม่สามารถทำได้หาก ไม่กำจัดมอดเสียก่อน มอดข้าวที่ปนเปื้อนอยู่ในข้าวจะอาศัยอยู่ในเมล็ดข้าวโดยการเจาะรูเข้าไปใน เมล็ดข้าว วงจรชีวิตของมอดข้าวเริ่มจากตัวโตเต็มวัยสืบพันธุ์แล้วเจาะเมล็ดข้าวไดยการเจาะรูเข้าไปใน เมล็ดข้าว วงจรชีวิตของมอดข้าวเริ่มจากตัวโตเต็มวัยสืบพันธุ์แล้วเจาะเมล็ดข้าวไปวางไข่ไว้ จากนี้ ใข่จะพัฒนาเป็นดักแด้ พัฒนาต่อจนเป็นด้วย่อนช่วงนี้ตัวอ่อนจะยังอยู่ในเมล็ดข้าวไปวางไข่ไว้ จากนี้ ใข่จะพัฒนาเป็นดักแด้ พัฒนาต่อจนเป็นด้วย่อนช่วงนี้ตัวอ่อนจะยังอยู่ในเมล็ดข้าวไปวางไข่ไว้ จากนี้ ใข่จะพัฒนาเป็นดักแด้ พัฒนาต่อจนเป็นด้วย่อนช่วงนี้ตัวอ่อนจะยังอยู่ในเมล็ดข้าวไปวางไข่ไว้ จากนี้ ใจจะพัฒนาเป็นดักแล้ ค้าแล้วมอดข้าวเริ่มจากตัวโตเข้มวงนี้ก้ามีชีวิตอยู่ประมาณ 90 – 180 วัน (Davis, 2011) ตามรูปที่ 1.1 นอกจากมอดจะใช้เมล็ดข้าวเป็นที่ขยายพันธุ์ ยังใช้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัย ใน ทุกกระบวนการที่มอดทำส่งผลให้มีการเจาะทำลายข้าว ข้าวที่มีการปนเปื้อนแมลงมอดข้าวจะเป็น ข้าวที่คุณภาพแย่ ลักษณะของข้าวจะแตกหักเป็นผงใช้เป็นอาหารไม่ได้ สูญเสียมูลก่าจากน้ำหนักที่ ลดลง แม้ว่าการกำจัดมอดข้าวจะนิยมใช้สารเคมีเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูก แต่ยังมีวิธีทางเลือกอื่นที่ ได้รับความสนใจและพัฒนาวิจัยเรื่อยมาถึงปัจจุบัน คือการกำจัดแมลงด้วยการให้กวามร้อนแบบ ใดอิเล็กทริก (Dielectric heating for insect control)



รูปที่ 1.1 วงจรชีวิตมอดข้าว (S. oryzae) จากไข่เป็นตัวอ่อนดักแด้ และตัวโตเต็มวัย (Davis, 2011)

การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค (Dielectric heating) คือการให้วัสดุที่ต้องการให้ความ ร้อนอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้า พลังงานจากสนามไฟฟ้าภายนอกจะทำให้วัสดุที่มีโมเลกุลแบบมีขั้ว โมเลกุลจะถูกบังคับไปตามทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า ฉะนั้นหากให้สนามไฟฟ้ามีทิศแบบสลับขั้ว โมเลกุลจะหมุนตัวตามทิศของสนามไฟฟ้าภายนอก ซึ่งการหมุนของโมเลกุลในวัสดุหากหมุนใน ความถี่ที่เหมาะสม (Resonance frequency and relaxation) จะทำให้เกิดความร้อนจากโมเลกุล เป็น การเกิดความร้อนภายในวัสดุ สนามไฟฟ้าไม่มีความร้อนเกิดขึ้นภายในสนาม แต่การนำวัสดุที่เป็น โมเลกุลแบบมีขั้วอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าสลับ จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นจากการหมุนของโมเลกุล ภายใน วัสดุต่างชนิดกันอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าเดียวกัน อาจมีความร้อนเกิดขึ้นไม่เท่ากัน เป็นเพราะ ค่าสภาพยอม (Permittivity) ของวัสดุต่างชนิดไม่เหมือนกัน จากข้อเท็จจริงนี้ทำให้สามารถเลือกให้ ความร้อนแก่วัสดุบางชนิดได้แม้ว่าวัสดุนั้นจะอยู่ปนกับวัสดุอื่น เช่น แมลงมอดข้าวในข้าว

มอดข้าวที่ปนเปื้อนอยู่ในข้าวสามารถกำจัด ด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก โดย เลือกความถี่ที่เหมาะสมที่จะทำให้มอดข้าวเกิดความร้อนภายในสูงที่สุด ในขณะทำให้ข้าวมีความ สูญเสียน้อยที่สุด เพราะการให้สนามไฟฟ้าแก่มอดข้าวและข้าว ย่อมทำให้ข้าวสามารถเกิดความ ร้อนได้ เนื่องจากเมล็ดข้าวมีส่วนประกอบของโมเลกุลที่มีขั้ว

ในช่วงแรกการนำการให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริคมาใช้กับการกำจัดแมลง มีความกังวล เกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีนี้ ทั้งในเรื่องต้นทุนอุปกรณ์ที่สูง รวมถึงค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจาก หลอดสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพราว ๆ 50% เมื่อมองข้อนกลับไปเทียบกับค่าใช้จ่ายของการใช้ สารเคมีกำจัดแมลง ทำให้ยากที่จะมีผู้ลงทุนกับวิธีกำจัดแบบไม่ใช้สารเคมี แต่การพัฒนาก็ไม่ได้หยุด นักวิจัยยังคงค้นคว้ามาเรื่อย ๆ จนสามารถอยู่ในอุตสาหกรรมได้ ที่ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้า กระแสตรงไปเป็นกระแสสลับความถี่สูง (DC to AC conversion) อยู่ที่ 50 – 65% สำหรับหลอด สุญญากาศ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษา และพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่การแปลงไฟฟ้า กระแสตรงไปเป็นกระแสสลับความถี่สูง แต่ยังรวมประสิทธิภาพทั้งระบบ จากไฟฟ้า 220 V, 50 Hz เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นต่อวินาทีในข้าว เปรียบเทียบใช้กำลังไฟฟ้าเทียบกับกำลังที่เกิดขึ้นกับข้าวใน รูปแบบความร้อน โดยใช้ LDMOS (Laterally Diffused MOSFET) ในวงจรงยายสัญญาณความถี่สูง กำลังสูง SSPA (Solid-State Power Amplifier) แทนวงจรหลอดสุญญากาศ LDMOS มีข้อได้เปรียบ เช่น ประสิทธิภาพอยู่ที่ 70 – 85% ขนาดเล็ก และเหมาะกับการพัฒนาอุปกรณ์กำจัดแมลงขนาดเล็ก สำหรับใช้ตามครัวเรือน

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือสร้างอุปกรณ์กำจัดมอดข้าวที่ปนเปื้อนในข้าวขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้สำหรับครัวเรือน เพื่อลดความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับข้าวจากการปนเปื้อน ของมอดข้าว รวมถึงธุรกิจกรอบกรัวรายย่อย ที่ต้องการสร้างรายได้จากการรับกำจัดมอดข้าวในข้าว นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังเล็งเห็นความเป็นไปได้ที่จะกำจัดแมลงชนิดอื่นที่ชอบอาศัยอยู่ในข้าว เช่น มด เนื่องจากมดจะมาทำรังในข้าวที่เกีบไว้ ทำให้ข้าวเกิดความเสียหาย

1.2 จุดประสงค์งานวิจัย

 เพื่อศึกษา และออกแบบอุปกรณ์กำจัดมอดในข้าวสำหรับครัวเรือน ประสิทธิภาพไม่ต่ำ กว่า 60%

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย

- มอดข้าวเป็นวัสดุไดอิเล็กทริดที่สามารถให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริดได้
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ SSPA สามารถใช้กับงานให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริคแทน หลอดสุญญากาศ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ระบบกำจัดแมลงมอดข้าว ที่สามารถใช้ทดแทนกับระบบกำจัดแมลงมอดข้าวที่มีอยู่ใน ครัวเรือน และอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่าย และยังคงคุณภาพ ที่ดีของข้าว
- เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน
 เพื่อยกระดับสินค้าประเภทผลผลิตทางการเกษตรส่งออก และภายในประเทศ



บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

้โดยทั่วไปการกำจัดแมลงศัตรูพืชผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest pest control) นิยมทำกันอยู่หกวิธี (Wang & Tang<mark>, 2</mark>001) หนึ่งกำจัดแมลงด้วยการรมสารเคมี (Chemical fumigation treatment) เป็นวิธีที่มีราคาถกแล<mark>ะน</mark>ิยมใช้มากที่สุด สำหรับมอดข้าวใช้เวลาประมาณ ้สามชั่วโมงเพื่อให้ตัวโตเต็มวัยของมอคต<mark>าย ได้อั</mark>ตราการผลิตสูง โดยทั่วไปจะใช้ Methyl bromide (MeBr) ความเข้มข้นประมาณ 80 – 95% <mark>ห</mark>ลังจาก<mark>ร</mark>มเสร็จแล้วจะปล่อยสารทิ้งสู่บรรยากาศ MeBr มี ้งุดเดือดต่ำดังนั้นเมื่อปล่อยสาร สารดังก<mark>ล่</mark>าวจะระ<mark>เห</mark>ยออกอย่างรวดเร็ว เป็นการลดสารตกก้างเหลือ ้ทิ้งไว้ในข้าวให้น้อยที่สด นอกจากเ<mark>รื่อ</mark>งสารตก<mark>ก้าง</mark>ในข้าวยังมีเรื่องของการที่ MeBr ทำลายชั้น บรรยากาศโลก โดยมีการตั้งสน<mark>ธิสั</mark>ญญา Montreal Protocol ประกาศสั่งห้ามไม่ให้ใช้ MeBr เพื่อ ปกป้องรักษาชั้นบรรยากาศโ<mark>ลก</mark> สองการใช้รังสี (Ionizing radiation treatment) เป็นการใช้รังสี แกมมา (Gamma ray) ที่มีพลังงานสูงเข้าทำลาย DNA (Deoxyribonucleic acid) ของแมลงหรือ แบคทีเรียไม่ให้สามารถสืบพันธ์ต่อได้ เนื่องจากรังสีแกมมาสามารถทะลุทะลวงได้สูง และไม่ ้ จำเป็นต้องใช้ความเข้ม<mark>รังสี</mark>สูง เพียง 0.3 kGy ก็สามารถกำจั<mark>ดแมถ</mark>งหรือแบคทีเรียได้โดยยังรักษา ้คุณภาพของผลผลิตไว้ได้ <mark>วิธีนี้จะไม่ทำให้แมลงตาย 100% ในทัน</mark>ที แต่จะทำให้แมลงหรือแบคทีเรีย ้ไม่สามารถมีรุ่นลูกต่อไปได้ วิ<mark>ธีการทำถาย DNA โดยใช้รั</mark>งสีมีสองกลไก คือหนึ่งการเข้าทำถาย โดยตรง (Direct) รังสีที่มีพลังงานสูงจะทำลายพันธะสาย DNA ของแมลง โดยตรง สองการทำลาย โดยอ้อม (Indirect) รังสีแกมมาเมื่อกระทบกับโมเลกุลของน้ำ (${
m H}_2{
m O}$) น้ำจะแตกตัวเป็นไฮครอกไซด์ OH^{-} จาก $H_2O + photon --> H^{+} + OH^{-}$ ซึ่ง OH^{-} นี้คือประจุไอออนที่แตกตัวออกมาจากน้ำและประจุ ้ดังกล่าวนี้เมื่อไปชน DNA พันธะจะถูกทำลาย ปัญหาหลักของวิธีการใช้รังสีคือมีต้นทุนการสร้างสูง ทั้งการควบคุม การป้องกันรังสีรั่วไหล รวมถึงความตระหนักของผู้บริโภคที่ระแวงถึงการตกค้าง ของรังสีในอาหาร และยังมีปัญหาการกำจัดกากรังสีหลังการใช้ สามการควบคุมระดับออกซิเจนใน บรรยากาศ (Controlled atmosphere treatments) ลดระดับของออกซิเจน (O₂) ในบรรยากาศให้ลดลง และเพิ่มระคับของการ์บอนไดออกไซด์ (CO,) ให้มากขึ้น โดยปกติแล้วจะนำผลผลิตที่มีแมลง ้ปนเปื้อนไว้ในโรงที่ปีคสนิทขนาคใหญ่ จากนั้นเริ่มลคระดับของออกซิเจนให้ต่ำกว่า 1% และเพิ่ม ระดับของการ์บอนไดออกไซด์ให้มากกว่า 20%

การกำจัดแมลงด้วยวิธีการควบคุมระดับออกซิเจนนี้สามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อน ้ผลผลิตได้ 100% แต่เป็นวิธีกำจัดแมลงที่มีรากาสูง ใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งได้รับรายงานว่าการ ให้ผลผลิตอยู่ในภาวะที่มีระดับออกซิเจนต่ำ มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลไม้บางชนิด สี่การกำจัด ด้วยการแช่แข็ง (Cold treatment) โดยลดอุณหภูมิของผลผลิตทางการเกษตรลด หากใช้เวลานาน พอจะสามารถกำจัดแมลงให้ตายได้ แต่ปัญหาก่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพื่อคงอุณหภูมิ ทั้งยังใช้ ระยะเวลานานกว่าแมลงจะตายทั้งหมด ห้าการใช้ความร้อนกำจัดแมลงแบบคั้งเดิม (Conventional heating treatment) เป็นการใช้ลมร้อนหรือน้ำร้อน หรือทั้งสองอย่างเวียนผ่านผลผลิต วิธีนี้เป็นวิธีที่ ้ง่ายทั้งการสร้างและการควบคุม ใช้แทนวิธีการใช้สารเคมีได้ดี ปกติแล้วจะให้ผลผลิตเคลื่อนใน ้สายพานการผลิตอย่างช้า และใช้เวลาในการ<mark>ให้</mark>ความร้อน 20 – 360 นาที ตามแต่ชนิดของผลผลิต ที่ ้อุณหภูมิ 40 – 52 °C ด้วยวิธีนี้สามารถกำ<mark>จัดแมล</mark>งได้ถึง 99.9968% ปัญหาของการกำจัดแมลงด้วย ้ความร้อนในระยะเวลานาน อาจทำให้มีผ<mark>ล</mark>ต่อคุณภาพของผลผลิต เช่น ความอ่อนนุ่มของผลไม้บาง ้ชนิดที่เปลี่ยนไป การใช้ความร้อนเป็นร<mark>ะ</mark>ยะเวล<mark>า</mark>นานไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพของสินค้าในการผลิต ระดับอุตสาหกรรม หกการกำจัดแม<mark>ลงด้</mark>วยการให<mark>้คว</mark>ามร้อนแบบไดอิเล็กทริค (Dielectric heating treatment) เป็นการใช้สนามความถี่ในย่านความถี่วิทยุ RF (Radio frequency) หรือ คลื่นความถี่สูง ้ย่านความถี่ใมโครเวฟ MW (Microwave) ทั้งสองอย่างนี้ RF และ MW คือหลักการให้ความร้อน แบบไดอิเล็กทริก ซึ่งจะได้ผล<mark>ด</mark>ีกับวัสดุที่เป็นวัสดุไดอิเล็กทริก (Dielectric material) วัสดุพวกนี้กือ วัสดุที่มีโมเลกุลเป็นขั้ว (Polar molecules) เมื่อให้วัสดุอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic field) ขั้วของโมเลกุลจ<mark>ะหมุนเคลื่อนที่ตามทิศของสนาม</mark>แม่เหล็กไฟฟ้าก่อให้เกิคความร้อนจาก ภายในวัสดุ โดยทั่วไปใ<mark>ช้ความถ</mark>ี่ 12 – 2450 MHz ในอุตสาหกร</mark>รมการผลิคอาหาร ความร้อนที่ ้เกิดขึ้นจากพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic energy) อธิบายได้จากสมการ (2.1)

 $P_{vol} = \rho C_p \frac{\Delta T}{\Delta t} = \omega E^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r''$ (2.1)

เมื่อ

- ho คือ ความหนาแน่นของวัสคุ (kg/m³)
 - C_p คือ ค่าจำเพาะความจุกวามร้อนของวัสดุ (kj/kg°C)
 - ΔT คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ในช่วงเวลา Δt
 - ω คือ ความถี่เชิงมุม (rad)
 - E คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (V/m)
 - ε_0 ถือ Dielectric permittivity (8.8541x10⁻¹² F/m)
 - \mathcal{E}_r'' คือ Dielectric loss factor

การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริคสำหรับการควบคุมกำจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวเริ่ม ตั้งแต่ 1929 โดย Headlee และ Burdette (Nelson, 1996) ทำการทดลองกับแมลงบางชนิดในน้ำผึ้งที่ ความถี่ 12 MHz มีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมา ต่อมานาย Davis ได้ลิขสิทธิ์ในปี 1934 ในชื่อ High-Frequency Method and Equipment for Exterminating Insect Life in Seed, Grain, or Other Materials ในช่วงปี 1950 เริ่มมีการตระหนักถึงสุขภาพ และความปลอดภัยจากสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าแมลง จนถึง 1970 ทำให้มีการศึกษาเกี่ยวทางเลือกในการกำจัดแมลงอื่น ๆ ที่ไม่ใช้สารเคมี ถึงแม้จะมีความ เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้สารเคมีอยู่เช่นเคย

การจะให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริคแก่สสาร จำเป็นต้องพิจารณาถึง Dielectric permittivity ซึ่ง ค่านี้จะอยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อน ส่วนที่เป็นค่าจริงจะหมายถึง ความสามารถในการ เก็บพลังงานในรูปของสนามไฟฟ้า และส่วนจินตภาพจะหมายถึง พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูก กระจายตัวแปลงไปเป็นพลังงานในรูปแบบใหม่ คือพลังงานความร้อน ซึ่งคือหลักการพื้นฐานของ การให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริค หรือการให้ความร้อนแบบไมโครเวฟ ถ้าหากใช้คลื่นความถี่ใน ย่านไมโครเวฟ ค่า Dielectric permittivity ที่อยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อน สามารถเขียนได้ $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$ โดยที่ ε' คือ Dielectric constant และ ε'' คือ Dielectric loss factor ค่าไดอิเล็กทริค อีกรูปแบบ ที่นิยมใช้คือ Loss tangent สามารถเขียนได้ในรูป $\tan(\delta) = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$

การให้ความร้อนแบบไคอิเล็กทริค กำลังกระจายต่อหน่วยปริมาตรในวัสดุ Non-magnetic วัสดุเนื้อเดียวที่ได้รับพลังงานจากคลื่นวิทยุ RF energy สามารถอธิบายได้ด้วยสมการที่ (2.1) การให้ กำลังอย่างต่อเนื่องจะทำให้วัสดุมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่อเวลาที่เปลี่ยนไป (Heating rate: °C/s) อธิบายได้ด้วยสมการที่ (2.2)

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{vol}}{\rho C_p}$$
(2.2)

ความถี่ที่ใช้ในการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริดจะอยูในช่วง 1 – 100 MHz วัสดุที่จะนำมา ให้ความร้อนด้วยวิธีนี้จะอยู่ระหว่างเพลตตัวนำที่วางขนานกัน ความเข้มสนามไฟฟ้าระหว่างเพลต ขนานที่มีวัสดุไดอิเล็กทริด จะเท่ากับ Voltage ของสัญญาณ RF ที่ตกคร่อมระหว่างเพลตหารด้วย ความหนาของวัสดุ $E = \frac{V}{d}$ (V/m)

การให้ความร้อนแบบไมโครเวฟ เบื้องหลังการเกิดความร้อนจะเหมือนกับการให้ความ ร้อนแบบไดอิเล็กทริกต่างที่ความถี่ที่ใช้ ความถี่ย่านไมโครเวฟที่นิยมนำมาใช้ให้ความร้อน จะใช้ ความถี่ที่สูงมากกว่า 500 MHz ซึ่งมี 869, 915, และ 2450 MHz เป็นการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกมา เมื่อกลื่นกระทบกับวัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุจะดูดซับพลังงานแล้วแปลงเป็นพลังงานความ ร้อน ข้อดีของการให้ความร้อนแบบไมโครเวฟคือวัสดุมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงในระยะเวลาที่สั้น ทำให้ มีข้อเสียตามมาคือการควบคุมที่ลำบากและการกระจายตัวของความร้อนไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังไม่ สามารถใช้กับวัสดุที่มีความหนามากเกินไป เมื่อคลื่นตกกระทบวัสดุคลื่นจะยังสามารถเคลื่อนที่ใน วัสดุได้ อีกช่วงความยาวหนึ่งแต่พลังงานจะลดทอนเรื่อยไป ตามความลึกที่คลื่นเข้ามาในวัสดุ สามารถอธิบายได้ในสมการ (2.3) (Hou, Johnson, & Wang, 2016) รูปที่ 2.1 เป็นแผนภาพที่ช่วยทำ ให้เข้าใจเรื่อง Penetration depth เมื่อ Incident wave ที่มีพลังงานก่าหนึ่งตกกระทบวัสดุ จะมีพลังงาน บางส่วนสะท้อนออกไป ขึ้นอยู่กับวัสดุนั้นว่ามีความซึมซาบคลื่นได้ดีแก่ไหน พลังงานที่เข้าไปใน วัสดุจะลดทอนลงตามระยะความลึกที่มากขึ้น จนเมื่อพลังงานมีก่าเท่ากับ 1/e หรือประมาณ 37% เรียกความลึกนี้ว่า Penetration depth ระยะ<mark>ความลึ</mark>กนี้ขึ้นอยู่กับความถิ่ และชนิดของวัสดุ

$$d_{p} = \frac{c}{\omega \left[2\varepsilon' \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \right)^{2}} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{2}}}$$
(2.3)

้ความแตกต่างระหว่างการให้ความร้อนแบบไดอ<mark>ิเ</mark>ล็กทริคและการให้ความร้อนแบบ ใมโครเวฟ ในการให้ควา<mark>ม</mark>ร้อนแบบไคอิเล็กทริกจะใช้ความถี่ย่านความถี่วิทยุ RF อยู่ในช่วง 1 – 100 MHz ซึ่งโดยปกติที่ใช้โดยทั่วไปจะมีความถี่ 13.5, 27, และ 40 MHz การให้ความร้อนแบบไดอิ เล็กทริคเกิดขึ้นมาก่อนการให้กวามร้อนแบบไมโครเวฟ โดยในช่วง 1947 การให้กวามร้อนแบบ ้ใดอิเล็กทริกส่วนมากจะให้กว<mark>ามร้อนแก่วัสดุอยู่ระหว่างเพล</mark>ตขนานกันสองเพลต แต่ก็ยังมีอีกหลาย ฐปแบบในการให้ความร้อนไม่เพียงแต่เพลตขนานเท่านั้น การให้ความร้อนแบบไมโครเวฟก็ยังถือ ว่าเป็นการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริคชนิดหนึ่ง 1988 เพราะฉะนั้นสมการที่ (2.1) จะใช้กับการ ์ให้ความร้อนแบบไมโครเวฟได้ เป็นการพัฒนา การให้ความร้อนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ ้มีการผลิต Magnetrons ขึ้นมาใช้ การให้ความร้อนแบบไมโครเวฟจะใช้ความถี่ที่สูงกว่า 500 MHz ้ส่วนมากจะใช้ความถี่ 869, 915, และ 2450 MHz อย่างที่เคยกล่าวถึงไปแล้วว่าการให้ความร้อนแบบ ้ใดอิเล็กทริกจะให้วัสดุอยู่ระหว่างเพลตขนาน การให้กวามร้อนอย่างรวคเร็วทำได้โดยให้กวามต่าง ้ศักย์ระหว่างเพลตขนานสูงมาก โคยจำกัดที่ Dielectric breakdown ของวัสดุนั้น สำหรับรูปร่างทาง กายภาพของเพลตขนานทำให้มีความเข้มสนามไฟฟ้าที่ Uniform ถ้าวัสดุนั้นเป็นแบบ Homogeneous แตกต่างจากการให้ความร้อนแบบไมโครเวฟที่ การลดทอนและ Penetration depth มีความสำคัญ เนื่องจากความถี่ที่ใช้สูงกว่าการให้ความร้อนแบบ RF มาก ทำให้การให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มสนามไฟฟ้าที่ต่ำ อย่างไรก็ตามการประมาณความเข้ม

สนามไฟฟ้าจะเป็นไปอย่างซับซ้อนด้วยการที่มีการลดทอนในวัสดุและรูปร่างของวัสดุที่อาจจะไม่ สม่ำเสมอ ดังนั้นเพื่อที่จะให้วัสดุมีความร้อนทั่วกันจะนิยมหมุนวัสดุในขณะที่วัสดุเกลื่อนที่ผ่าน กลื่น แต่สำหรับการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก Penetration depth จะไม่มีผลมากเพราะความ ยาวกลื่นที่ต่ำเมื่อเทียบกับความถี่ย่านไมโกรเวฟ ในขณะที่รูปร่างของวัสดุจะมีผลอย่างมาก นาย R. S. Ferrari-John และคณะ (Ferrari-John et al., 2016) ศึกษาจากการจำลองบนคอมพิวเตอร์ พบว่า รูปร่างของวัสดุที่เป็นแบบทรงกลม จะให้ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าของวัสดุระหว่างเพลตมีความ Uniform มากที่สุด แต่ไม่ได้เข้มที่สุด จุดที่มีสนามไฟฟ้าเข้มที่สุดคือจุดที่วัสดุมีรูปร่างเรียวแหลม และคม เช่นตรงขอบของกล่องที่มีเหลี่ยม หรือ ตรงยอดของวัสดุรูปร่างพีระมิด ดังรูปที่ 2.2 อุณหภูมิ แปรผันตรงต่อความเข้มสนามไฟฟ้าตามสมการที่ (2.1)

การเลือกให้ความร้อนแก่วัสดุต่างชนิดกัน หากในผลผลิตข้าวหลังการเก็บเกี่ยว มีศัตรูคือ มอดข้าว การเลือกให้ความร้อนจำเพาะต่อมอดทำได้ ถึงแม้ว่ามอดข้าวจะปนผสมอยู่ในข้าว เมื่อให้ พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดสนาม ไฟฟ้าขึ้นในทั้งข้าวและมอดข้าว ความถี่ที่ได้รับสำหรับ มอดและข้าวจะเป็นความถี่เดียวกัน ที่แตกต่างกันคือค่า Dielectric loss factor ของข้าวและมอดข้าว ไม่เหมือนกันแม้ในความถี่เดียวกัน ทำให้สนามไฟฟ้าในข้าวและมอดไม่เท่ากัน หากเลือกให้มอคมี ความร้อนสูงกว่าข้าวทำได้โดยเลือกความถี่ที่เหมาะสม แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าวจะไม่ได้รับ พลังงาน เนื่องจากทั้งข้าวและมอดอยู่ผสมกัน ดังนั้นข้าวจึงได้รับพลังงานและถูกแปลงมาเป็น พลังงานกวามร้อนเช่นเดียวกันกับมอด เพียงแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าตามก่า Loss factor ในทาง กลับกันสามารถเลือกให้ความถี่ทำให้ข้าวร้อนมากกว่ามอดได้เช่นกัน นี่คือข้อได้เปรียบของการให้ ความร้อนแบบไดอิเลีกทริกคือการเลือกให้ความร้อนแก่วัสดุที่ต้องการถึงแม้ว่าวัสดุนั้นจะอยู่ปนกับ วัสดุอื่น

การทดลองการให้ความร้อนแก่แมลงในช่วงที่ผ่านมา (1929 - 2018) วัสดุที่ได้รับพลังงาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความร้อนสูงขึ้นด้วยอัตราหนึ่งความชันของอัตราการเพิ่มความร้อน (Heat rate) นี้ขึ้นอยู่กับความเข้มสนามไฟฟ้า และความถิ่ของสนามไฟฟ้า อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ Dielectric loss factor ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหากวัสดุนั้นมีความชื้นเพิ่มขึ้นเช่น เมล็ดข้าว อัตราการให้ความ ร้อนในเมล็ดข้าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อข้าวมีความชื้นสูงขึ้น การทคลองยังบอกด้วยว่าแมลงที่ปนเปื้อนใน ข้าว หรือในแป้งข้าว สามารถควบคุมได้ด้วยการให้ความร้อนแบบช่วงระยะเวลาสั้น เนื่องจากวิธีนี้ จะไม่ทำให้วัสดุข้าว หรือแป้งข้าวเสียหาย สำหรับการให้ความร้อนแบบช่วงระยะเวลาสั้น เนื่องจากวิธีนี้ จะไม่ทำให้วัสดุข้าว หรือแป้งข้าวเสียหาย สำหรับการให้ความร้อนที่ดีข้าวหรือแป้งข้าวควรจะมี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 40 – 60 °C ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของวัสดุนั้น แมลงมอดข้าวสามารถถูกกำจัด ได้ที่ความถี่ 13 และ 39 MHz โดยไม่ทำให้ข้าวหรือแป้งข้าวเสียหาย อย่างไรก็ตาม การนำการให้ ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกไม่ว่าจะแบบ RF heating หรือ Microwave heating ก็ยังไม่เป็นที่ แพร่หลายเนื่องจากต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับวิธีการใช้สารเคมีแบบเดิม



รูปที่ 2.1 แผนภาพกลื่นตกกระทบกับวัสคุไดอิเล็กทริกที่มีบางส่วนสะท้อนออกมา และระยะ ความลึกที่เรียกว่า Penetration depth ซึ่งขึ้นกับความถี่และชนิดของวัสคุดังสมการ (2.3) (Hou et al., 2016)





รูปที่ 2.2 ผลการ Simulation ของการให้ความร้อนแบบไคอิเล็กทริคกับวัตถุรูปร่าง ต่างแบบกัน 10 แบบ (Ferrari-John et al., 2016)

จากการทดลองอัตราการตาขของมอดข้าวขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลัก ความถิ่, ความเข้ม สนามไฟฟ้า, และ อัตราการเพิ่มความร้อน (Heat rate) (Nelson, 1996) อัตราการตาขของมอดยังมีใน รูปแบบของความล่าช้า (Delayed) แมลงบางชนิดอาจใช้เวลาถึง 2 – 3 สัปดาห์กว่าจะตายหลังจากถูก ให้ความร้อน ความล่าช้าของมอดข้าวใช้ระยะเวลา 1 – 8 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความถี่ที่ใช้ใน การให้ความร้อน ยังมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตราการตาขของแมลง เช่นการเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้า พบว่าอัตราการตาขของแมลงสูงกว่า ความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำ ที่ ความถิ่เดียวกัน นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มการใช้มอดดูเลชั่นมาช่วยเพิ่มอัตราการตาขของแมลง โดย ใช้สัญญาณแบบ Pulse-modulated ความกว้าง 5 – 40 ms และ 10 – 40 ลูกคลื่นสัญญาณต่อวินาที (Pulse per second) พบว่าการทำมอดดูเลชั่นของสัญญาณไม่ได้มีความแตกต่างจากการใช้สัญญาณ เดิม (CW) แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้าเป็น 4 kV/cm และใช้ Pulse สั้นลงถึง 50 µm ผลลัพธ์ยังคงไม่แตกต่างจากใช้ความเข้มสนามไฟฟ้า 1.4 kV/cm แบบต่อเนื่อง (CW)

พวกแมลงที่รอด จากการศึกษาพบว่าแมลงเหล่านี้ ยังมีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้แต่ อัตราการสืบพันธุ์ลดลงหลังจากที่ผ่านการให้ความร้อน เพราะผลกระทบจากความร้อนที่ทำให้ แมลงเกิดการบาดเจ็บ (Heat injuries) เช่นความร้อนส่งผลต่ออวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ ทำให้อัตรา การสืบพันธุ์ของแมลงลดลง ผลกระทบการบาดเจ็บจากความร้อนที่เกิดขึ้นกับแมลงที่สังเกตได้ แมลงมีขาไม่ครบ หรือรูปร่างของแมลงผิดแปลกไปหลังจากผ่านการให้ความร้อน

มีการศึกษาและทดลองการยืนยันเพื่อพิสูงน์ว่าการใช้ RF heating สามารถใช้กำจัดแมลงได้ จริง โดย (Zhou & Wang, 2016b) ทำการทดลองกำจัดมอดในข้าวสามชนิด rough, brown, and milled rice คือ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร โดยใช้เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเลีกทริคที่ ความถี่ 27.12 MHz ขนาดกำลัง 6 kW ดังรูปที่ 2.3 ตัวแปรที่ศึกษามี เวลาที่ให้ความร้อน อุณหภูมิที่ ให้ต่อข้าว โดยเริ่มจากการคงค่าเวลาที่ให้ความร้อนที่ ห้านาที แล้วมือุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 แบบ คือ 44, 46, 48 และ 50 °C ผลอัตรารอดของแมลงที่ได้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายกับ อุณหภูมินั้นแปรผันตรงต่อกัน โดยมีอัตราการตายสูงสุดที่ 50 °C จากนั้นได้เปลี่ยนตัวแปรใน การศึกษา ให้อุณหภูมิกงที่ 50 °C และให้ช่วงเวลาที่ให้ความร้อนแตกต่างกัน 4 แบบคือ 0, 2, 4 และ 6 นาที ผลอัตราการตายของมอดพบว่ายิ่งเวลาที่ให้ความร้อนมากขึ้นอัตราการตายของมอดสูงขึ้น ตามไปด้วย ซึ่งมอดข้าวสามารถกำจัด 100% ได้ที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 6 นาที นอกจากนี้ใน งานวิจัยยังศึกษาถึงคุณภาพของข้าวหลังผ่านการให้ความร้อน โดยผู้วิจัยได้สรุปว่าการกำจัดมอด ด้วยการให้กวามร้อนแบบไดอิเลีกทริกที่สามารถกำจัดได้ 100% ผลทางกายภาพของข้าวไม่ว่าจะ เป็น กวามชื้น โปรตีน กรดไขมัน สี ฯ ไม่มีกวามแตกต่างกันกับข้าวที่ไม่ได้ผ่านการกำจัดมอดอย่าง มินัยะสำคัญ และ ได้มีลักษณะงานวิจัยในทำนองเดียวกันนี้ (Vearasilp et al., 2015) ได้ใช้เครื่อง กำจัดมอดทำงานที่ 27 MHz ที่กำลัง 15 kW ดังรูปที่ 2.4 โดยทำการหอดองที่สองช่วงอุณหภูมิคือ 50 และ 55 °C ที่ช่วงเวลาการให้อุณหภูมิ 4 ช่วงคือ 0, 1, 3 และ 5 นาที ผลการทดลองของกลุ่มวิจัยนี้ พบว่า นอกจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ให้ความร้อนแล้ว กลุ่มอื่นทั้งหมดที่เหลืออัตราการตายของมอด อยู่ที่ 100% ซึ่ง แตกต่างจากผลการทดลองของอีกกลุ่ม ถึงแม้จะใช้ที่ความถี่เดียวกัน แต่ขนาดกำลัง ใม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้มอดตายได้ถึงแม้อุณหภูมิและเวลาจะไม่สูงมาก นอกจากนี้คุณภาพ ของข้าวเช่น ความชื้น โปรตีน กรดไขมัน สี ฯ ไม่มีความแตกต่างกันกับข้าวที่ไม่ได้ผ่านการกำจัด มอดอย่างมีนัยะสำคัญ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยข้างด้น และในกลุ่มวิจัยเดียวกันนี้ได้ทดลองศึกษา อุณหณภูมิและเวลา หลากหลายมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดมอด อย่างประหยัดพลังงานมากที่สุด (Wangspa, Chanbang, & Vearasilp, 2015) โดยใช้อุณหภูมิต่างกัน 5 รูปแบบคือ 50, 55, 60, 65 และ 70 °C และช่วงเวลาที่ให้ความร้อน 4 รูปแบบคือ 90, 120, 150 และ 180 วินาที พบว่าทุกช่วงเวลาที่อุณหภูมิ 50°C ไม่สามารถทำให้มอดตาย 100% ได้ นับเฉพาะอัตรา การตายมอดที่เท่ากับ 100% มี 55 °C 180 วินาที 60 °C ที่ 150 และ 180 วินาที 65 และ 70 °C ที่ 120, 150 และ 180 วินาที โดยทางคณะกลุ่มผู้วิจัยได้สรุปว่า ณ ตำแหน่งมีประหยัดพลังงานมากที่สุดคือ การใช้อุณหภูมิ 65 °C ที่ระยะเวลาการให้ความร้อน 120 วินาที

้ ใด้มีการพิจารณาถึงถักษ<mark>ณะก</mark>ารกระจายสนามใฟฟ้าสำหรับการกำจัดมอดข้าว ด้วยการให้ ้ความร้อนแบบไคอิเล็กทริค โ<mark>คย</mark>การใช้การกระจาย<mark>สน</mark>ามไฟฟ้าแบบทรงกระบอก หรือแบบ Coaxial และแบบแผ่นเพลตขนาน (Ponomaryova, De Rivera Y Oyarzabal, & Sánchez, 2009) ดัง รูปที่ 2.5 ทางผู้วิจัยได้สรุปว่า แบบเพลตขนานนั้นให้อัตราการตายของมอดได้ดีกว่าแบบ ทรงกระบอก งานวิจัยชิ้นนี้แตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมา ที่พูดถึงอุณหภูมิเป็นหลักในการหา ้ความสัมพันธ์กับอัตราก<mark>ารตายข</mark>องมอด งานวิจัยนี้จะพูดถึงความเข้มของสนามไฟฟ้าเป็นหลัก โดย ทำการทุคลอง 4 กวามเข้มสนามไฟฟ้าที่ต่างกันคือ 350, 700, 1000 และ 2000 kV/m ที่ระยะเวลา ต่างกัน 6 แบบคือ 0.5, 1, 5, 10, 20 และ 30 วินาที ใช้กวามถี่ 47.5 MHz ผลที่ได้ก่อนข้างน่าสนใจ เพราะไม่ใช้เพียงความเข้มสนามไฟฟ้าสูง และระยะเวลานาน งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ใหม่ในการกำจัดมอด เช่นที่ ความเข้มสนามไฟฟ้า 350 kV/m มอดตาย 100% ที่ระยะเวลา 5, 10 และ 20 วินาที เพียงแต่ที่ 30 วินาที มอดกลับตายไม่ทั้งหมด เป็นที่น่าแปลกใจ เพราะ โดยทั่วไปยิ่งมอด ้ได้รับพลังงานมากเท่าใค อัตราการตายของมอคจะสูงขึ้นตาม นอกจากนี้ยังเป็นที่แปลกใจเมื่อ ที่ ระยะเวลา 1 วินาที ที่ความเข้ม 700, 1000 และ 2000 พบว่า อัตราการตายของมอคคือ 100% แต่เมื่อ ระยะเวลาเพิ่มขึ้นอัตราการตายมอดกลับต่ำลง เช่นที่ 700 kV/m ที่ 5 และ 20 วินาที อัตราการตาย มอดไม่ใช่ 100% สุดท้ายที่ 2000 kV/m อัตราการตายมอดเป็น 100% ทุกช่วงระยะเวลา แม้ที่ 0.5 ้วินาที มอคยังตาย 100% ทั้งนี้มอคจะตายด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าหรือด้วยอุณหภูมิที่มาจากกำลัง ้สถเสีย ยังไม่มีข้อสรปที่ประจักษ์แจ้ง

มีกลุ่มนักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการตายของมอดด้วยการทำให้ร้อน นาย Rongjun Yan และ กณะ ได้ออกแบบการทดลองเพื่อหาช่วงอุณหภูมิที่มอดจะตายจากความร้อน โดยไม่ได้ใช้ความถิ่ กลื่นวิทยุหรือความเข้มสนามไฟฟ้า (Yan, Huang, Zhu, Johnson, & Wang, 2014) จากอุปกรณ์ที่ สร้างขึ้น รูปที่ 2.6 ให้มอดข้าวอยู่ในหลอด Chamber ที่ภายในมีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ Heater ที่ปรับค่าได้ และใช้กอมพิวเตอร์ในการเก็บบันทึกผล จากการทดลองได้ผลดังรูปที่ 2.7 ทดลองที่ อุณหภูมิต่างกันสี่แบบคือ 44, 46, 48, และ 50 °C ค่า N/N0 คืออัตราการรอด โดยที่ N คือจำนวนดัว มอดที่รอดชีวิต N0 คือจำนวนมอดตั้งต้น ผลที่ได้จากการทดลองที่อุณหภูมิ 50 °C เมื่อคงอุณหภูมิไว้ เป็นระยะเวลา 4 นาที ทำให้อัตราการรอดเป็น 0% และสามารถบอกได้ว่า Activation energy สำหรับ การฆ่ามอดกือ 505 kJ/mol การใช้ Heating rate ที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบ พบว่าที่ 1, 5, และ 10 °C /min ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการตายของมอดข้าวอย่างมีนัยยะสำคัญ



รูปที่ 2.3 เครื่องกำจัดแมลงด้วย Dielectric heating แบบสายพาน (Zhou & Wang, 2016b)

375^{ักยา}ลัยเทคโนโลยีสุร^{บโ}



รูปที่ 2.4 เครื่องกำจัดแมลงด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกแบบปล่อยข้าวไหลในแนวดิ่ง (Vearasilp et al., 2015)



รูปที่ 2.5 เครื่องกำจัดแมลงโดยใช้สนามไฟฟ้าสลับแรงสูง (ซ้าย) แบบ Coaxial และ (ขวา) แบบ เพลตขนาน (Ponomaryova et al., 2009)



รูปที่ 2.6 Setup ของชุดอุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่อศึกษาผลกระทบทางความร้อนที่มีต่อตัวมอดข้าว (Yan et al., 2014)



รูปที่ 2.7 ผลการทดลองจากการศึกษาผลกระทบทางความร้อนต่อตัวมอด (Yan et al., 2014)

นอกจากวิธีกำจัดมอดที่ได้กล่าวไป ยังมีวิธีอื่นอีกที่ได้มีการศึกษา เพื่อหาความเป็นไปได้ ที่ จะกำจัดหรือขับไล่หรือล่อให้ออกมา มอดข้าวที่ปนเปื้อนในข้าว มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ ตอบสนองต่อแสงของมอดข้าว โดยใช้ LED (Light-emitting Diodes) โดยนาย Ju-Hyun Jeon และ กณะพยายามที่จะล่อให้มอดข้าวมาติดกับดัก โดยใช้ความยาวกลื่นแสงที่แตกต่างกันห้าแบบ (Jeon, Oh, Cho, & Lee, 2012) โดยจัดการทดลองให้อยู่ใน Y-maze chamber ดังรูปที่ 2.8 จากการทดลอง พบว่าแสงที่ดึงดูดมอดข้าวมากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ สีน้ำเงิน (450 nm) สีเขียว (520 nm) สีแดง (660 nm) UV (365 nm) และ IR (730 nm)

การใช้สารเคมีรมมอดข้าวเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายถูกแต่ก็เป็นห่วงว่าจะมีสารเคมีตกค้าง จึงเป็น ที่มาของการหาสารเคมีทางเลือกที่สกัดมาจากพืชเพื่อนำมาทดแทน Br นาย Peter A. Follett และ คณะได้ใช้น้ำมันสกัดจากใบโหระพา Basil oil รมมอดข้าวแทน โดยใช้ปริมาตร 3 ml ความเข้มข้น 10% ใช้เวลา 10 นาที พบว่ามอดข้าวมีอัตรารอดต่ำลงหลังจากผ่านการรม Basil oil เมื่อเทียบกับชุด ควบคุม (รูปที่ 2.9) จากนั้นเมื่อผ่านไป 6 วันอัตรารอดจึงเป็น 0% (Follett, Rivera-Leong, & Myers, 2014) ต่อมานาย Farah Hossain และคณะได้ใช้ Basil oil ร่วมกับการใช้รังสีในการกำจัดมอด พบว่า ลำพัง Basil oil อย่างเดียวจะต้องใช้เข้มข้นข้นสูงเพื่อให้ได้ระยะเวลาที่สั้นลงสำหรับอัตรารอด 0% เช่นเดียวกับการใช้การฉายรังสีอย่างเดียวที่จะต้องการปริมาณ Dose สูง เมื่อนำทั้งสองวิธีมารวมกัน ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือ อัตราการรอด 0% ที่ก่า LC₅₀ ของ Basil oil 0.83 ul/ml และใช้รังสี 200 Gy ภายใน ระยะเวลาท้าวัน (Hossain, Lacroix, Salmieri, Vu, & Follett, 2014)

นาย Marissa X. McDonough และคณะได้ใช้ Ozone gas ความเข้มสูงในการกำจัดแมลงใน อาหาร การทคลองแบ่งเป็น 6 ความเข้มตั้งแต่ 50 ถึง 1800 ppm จากผลการทคลองพบว่า ในการ กำจัดมอดข้าว (S. oryzae (L.)) ตัวโตเต็มวัย ต้องใช้ Ozone ความเข้ม 1800 ppm เป็นเวลา 60 นาที นอกจากมอดแล้วในงานวิจัยยังได้ทคลองกับแมลงชนิดอื่นและสถานะอื่นในวงจรชีวิตเช่น ไข่ ตัว อ่อน ดักแด้ (McDonough, Mason, & Woloshuk, 2011)

นาย K.E. Law-Ogbomo และ D.A. Enobakhare ได้ทดลองกำจัดมอดข้าวด้วยผงจากใบยี่ หรา และผงจากใบป่าช้าเหงา (Leaf powder of Ocimum gratissimum and Vernonia amygdalina) โดยวัดผลจากอัตราการตายของมอด อัตราการวางไข่ น้ำหนักของเมล็ดข้าว และการแตกหักของ เมล็ดข้าว พบว่าใน Dose 4 g / 20 g grain สำหรับผงใบยี่หรา สามารถกำจัดตัวเต็มวัยได้ 100% เมื่อ ผ่านไป 21 วัน ในขณะที่ ผงใบป่าช้าเหงาต้องใช้ 5 g / 20 g grain จึงจะได้ การกำจัด 100% การใช้ผง ใบยี่หราสามารถลดน้ำหนักของข้าวที่หายไปได้ 48.90% เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่มีการ ใช้สารสกัดจากใบ ส่วนใบป่าช้าเหงาสามารถลดได้ 48.09% (Law-Ogbomo & Enobakhare, 2007)

มีนักวิจัยในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งได้สึกษาผลกระทบ จากการกำจัดมอดข้าวโดยใช้การให้ ความร้อนแบบอินฟราเรด (Infrared heating) (Duangkhamchan et al., 2017) นาย Wasan Duangkhamchan และคณะ ได้ทดสอบกับข้าวที่มีไข่ของมอดข้าวอยู่ภายใน การจัดการทดลองดังรูป ที่ 2.10 (ซ้าย) ใช้อุณหภูมิ 50 – 60 °C เวลาในการให้ความร้อนที่ 1 – 3 นาที พบว่าที่อุณหภูมิ 50 °C ด้องใช้เวลาถึง 3 นาทีเพื่อจะให้อัตราการตายของไข่มอดเป็น 100% ในขณะที่ อุณหภูมิ 55 และ 60 °C ใช้เวลา 2 นาทีอัตราการตายของไข่ 100% ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้าวคือ เมื่อให้ความร้อนเป็น ระยะเวลานานจะทำให้ความชื้นต่ำและมีน้ำหนักหายไป อีกทั้งยังทำให้ความแข็ง (Hardness) มีค่า สูงขึ้น เพื่อจะหาอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้อย่างเหมาะสม จึงทำ Desirability contour plot ดังรูปที่ 2.10 (ขวา) พบว่าจุดที่เหมาะสมคือค่าสูงสุดในกราฟ คือ 0.714 หมายถึงใช้อุณหภูมิ 53.59 °C เวลา ในการให้ความร้อน 1.2 นาที



รูปที่ 2.8 (ซ้าย) โมเคลสามมิติ Y-maze chamber และ (ขวา) ภาพ cross section ของ cross section แสคงตำแหน่งทางเข้าของมอดข้าว บริเวณมีคและบริเวณที่ใช้แสง (Jeon et al., 2012)





รูปที่ 2.9 อัตรารอดของมอดข้าวเมื่อถูกรมด้วย Basil oil ความเข้มข้น 10% และชุดควบคุมที่ไม่ ผ่านการใช้ Basil oil (Follett et al., 2014)



รูปที่ 2.10 (ซ้าย) Set up ของการให้ความร้อนแบบอินฟราเรคเพื่อกำจัดไข่มอค และ (ขวา) จุดที่ เหมาะสมสำหรับการให้ความร้อนแบบอินฟราเรค ที่ให้อัตราการตายของไข่มอคสูง ในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของข้าว (Duangkhamchan et al., 2017)

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ตัวเก็บประจุแบบเพลตขนาน (Parallel plate capacitor)

ตัวเก็บประจุประเภทนี้ประกอบไปด้วยแผ่นตัวนำที่มีพื้นที่ A สองแผ่นขนาด เท่ากัน วางในจุดศูนย์กลางและมุมเดียวกัน ห่างกันเป็นระยะ d หากมีความต่างศักย์ ΔV จะทำให้มี ประจุ +Q และ –Q ค่าความเก็บประจุ (Capacitance) หาได้จาก $C = Q/\Delta V$ สนามไฟฟ้าภายใน เพลตทั้งสองจะเกิดขึ้นดังรูป 2.11 จะเห็นว่าสนามไฟฟ้าไม่ใช่เส้นตรงตลอดทั้งเพลต โดยเฉพาะ บริเวณขอบที่มีความโค้งของสนามไฟฟ้ามาก เรียกเหตุการณ์นี้ว่า Edge effects และสนามไฟฟ้าที่ เป็น Non-linear ในบริเวณขอบจะเรียกว่า Fringing fields ในการหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่าง เพลต หาได้จาก Gauss's law คือการอินทิเกรตพื้นที่ปิดของบริเวณที่สนใจ ดังรูปที่ 2.12 จากบริเวณ นั้นทำให้ได้สนามไฟฟ้าเท่ากับ

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$
(2.4)

(2.6)

คือสนามไฟฟ้าจะเท่ากับความต่างศักย์ระหว่างเพลตหารด้วยระยะห่างของเพลต จะได้ค่าความเก็บประจของเพลตขนานเท่ากับ

 $\Delta V = Ed$

E =

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$
(2.7)

ทำให้
2.2.2 วัสดุใดอิเล็กทริค Dielectric materials

จากที่ได้รู้ว่า ค่าความเก็บประจุของเพลตขนานเท่ากับ สมการที่ (2.7) สมการนั้น ได้ใช้อากาศเป็นตัวกลางระหว่างเพลต แต่ถ้าตัวกลางระหว่างเพลตเป็นวัสคุอื่นที่ไม่ใช้อากาศ จะต้องมีเทอมที่คูณเข้ามาคือค่า Relative permittivity ค่าความเก็บประจุจะเพิ่มตามค่า Polarization ของตัวกลาง ค่า Relative permittivity เป็นคุณสมบัติเฉพาะวัสคุ ที่เปลี่ยนแปลงตามความถี่ ตัวเก็บ บางชนิดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับความถี่สูงเพราะจะมี การสูญเสียเกิดขึ้น การสูญเสียที่ว่านี้ไม่ ต่างจาก I^2R ในตัวต้านทาน คือกำลังสูญเสียไปเป็นความร้อน การสูญเสียในตัวเก็บประจุขึ้นอยู่ ความถี่ที่ใช้งาน อีกตัวแปรที่สำคัญคือ Electric dipole moment p ที่วัค Electrostatic effects ของสอง ประจุ +Q และ –Q ที่ห่างกัน a จะมีค่าเท่ากับ

$$p = Qa \tag{2.8}$$

ในภาวะปกติประจุรวมของอะตอมจะมีค่าเป็นศูนย์ โดยมีประจุบวกอยู่ตรงกลาง และกลุ่มอิเล็กตรอนวิ่งรอบ แต่ถ้าหากอะตอมถูกวางในสนามไฟฟ้าค่าหนึ่ง อิเล็กตรอนที่มีมวลน้อย กว่าจะถูกบังคับให้เคลื่อนตัวแยกห่างจากประจุบวก การที่อะตอมถูกเหนี่ยวนำให้แยกประจุลบและ บวก จะเรียกว่า Polarization P และจะเรียกอะตอมนั้นว่าอะตอมที่มีขั้ว Polarized atom

$$P = Np_{av} = \sigma_p \tag{2.9}$$

10

เมื่อ N คือจำนวนโมเลกุล และ p_{av} คือ Dipole moment เฉลี่ยต่อโมเลกุล และ σ_p คือ Polarization charge density เพื่อที่จะอธิบายว่าทำไม Polarization ถึงขึ้นอยู่กับสนามไฟฟ้า จึง กำหนดให้มี Electric susceptibility χ_e โดยที่

$$P = \varepsilon_0 \chi_e E \tag{2.10}$$

จากสมการที่ (2.5) ถ้าให้
$$\sigma = Q/A$$
 คือ Free surface charge density บนเพลต จะ

ได้

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{\sigma}_p \tag{2.11}$$

จากสมการที่ (2.9) และ (2.10) ทำให้

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \left(1 + \boldsymbol{\chi}_e \right) \boldsymbol{E} \tag{2.12}$$

จะใด้ความสัมพันธ์ระหว่าง Dielectric permittivity และ Electric susceptibility

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \tag{2.13}$$

Polarization mechanisms การพฤติตัวของความมีขั้วจะเกิดขึ้นตามความถี่ที่ ตอบสนองต่อ โมเลกุลหรืออะตอม ตามรูปที่ 2.13 ในรายละเอียดของพฤติกรรมอื่น นอกจาก Orientational (Dipolar) จะไม่ได้กล่าวถึง



รูปที่ 2.12 เส้นทางการอินทิเกรต เพื่อหาสนามไฟฟ้าระหว่างเพลตขนาน



รูปที่ 2.13 ค่า Dielectric permittivity ที่ขึ้นในความถี่ทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพ (Kasap, 2006)

Orientational (Dipolar) เกิดขึ้นกับ โมเลกุลของสารบางชนิด เช่น KCl หรือ H_2O ที่ จะมี Permanent dipole moment p_0 จากประจุลบ Cl⁻ ไปยังประจุบวก H⁺ ในของเหลวหรือแก๊สการ มีของสนามไฟฟ้านี้จะเกิดขึ้นแบบกระจัดกระจายไม่มีทิศทางแน่นอน ประจุยังพยายามที่จะหมุนตัว ตามสนามไฟฟ้าภายนอก แรงที่ โมเลกุลสัมผัสได้คือ Torque τ

$$\tau = Ep_0 \sin\theta \qquad (2.14)$$

โดยที่

$$p_0 = aQ \tag{2.15}$$

Dielectric loss วัสคุไดอิเล็กทริกที่อยู่ภายใด้สนามไฟฟ้าคงที่จะมีความเป็นขั้ว Polarization หรือมีค่า Dipole moment เท่ากับ

$$p = \alpha_d E \tag{2.16}$$

$$\alpha_d = \frac{p_0^2}{3kT} \tag{2.17}$$

รูปที่ 2.14 แสดงให้เห็นถึง เมื่อให้สนามไฟฟ้าคงที่ E_o ทำให้เกิด Dipole moment ค่าหนึ่ง และที่ t = 0 สนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจาก E_o เป็น E จากนั้น Dipole moment ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงค่าทันทีทันใด จะมีช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ Dipole moment ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าภายนอกเรียกว่า Relaxation process และช่วงเวลาที่ เปลี่ยนแปลงเรียกว่า Relaxation time τ แต่เมื่อวัสดุนั้นอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องแบบ Sinusoidal หรือ AC voltage ที่มีสนามไฟฟ้าเท่ากับ $E = E_0 \sin(\omega t)$ Dipole moment จะเท่ากับ

$$p = \alpha_d(\omega) E_0 e^{j\omega t}$$
(2.18)

เมื่อ $lpha_{_d}(\omega)$ มีค่าเท่ากับ

$$\alpha_{d}(\omega) = \frac{\alpha_{d}(\omega)}{1 + j\omega\tau}$$
(2.19)

ค่า $\alpha_d(\omega)$ เป็นจำนวนเชิงซ้อน ชี้ให้เห็นว่า p และ E นั้น Out of phase คังรูป ที่ 2.15 ที่ความถี่ต่ำ $\omega \tau \ll 1$ ค่า $\alpha_d(\omega)$ นั้นใกล้เคียงกับ $\alpha_d(0)$ ตอนที่ p และ E In phase อัตรา Relaxation time นั้นสูงมากที่ $\omega = 1/\tau$ และที่ความถี่สูง $\omega \tau \gg 1$ อัตรา Relaxation time จะ กลับมาต่ำเพราะ p และ E นั้น Out of phase สามารถแยกค่า Dielectric constant ใด้จาก

$$\varepsilon = 1 + \frac{N\alpha_d}{\varepsilon_0} \tag{2.20}$$

ซึ่ง ε จะอยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อนตาม $\alpha_d(\omega)$ เขียนในรูป $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$ ค่า Dielectric permittivity ε' และ Dielectric loss ε'' นี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ ค่า ε'' จะเป็น 0 ที่ความถี่ ต่ำและที่ความถี่สูง แต่จะสูงสุดที่ $\omega \tau = 1$ ค่า ε' ใช้คำนวณหาค่าความเก็บประจุจากสมการที่ (22) ตัวเก็บประจุในรูปที่ 2.16 มีวัสดุไดอิเล็กทริคอยู่ระหว่างเพลต ที่มีแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับตกคร่อม ดังนั้นค่าความนำไฟฟ้า (Admittance Y) จะเท่ากับ

$$Y = j\omega C + G_p \qquad (2.21)$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon'_r A}{d} \qquad (2.22)$$

$$Uaz$$

$$G_p = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon''_r \omega A}{d} \qquad (2.23)$$

ถ้าตัวเก็บประจุในอุดมกติจะไม่มีส่วนที่สูญเสียและ ไม่มีกำลังที่เกิดขึ้นจริง เพราะ G_p หรือ $1/R_p$ เป็น 0 แต่ในความเป็นจริงจะมีส่วนที่มีกำลังเกิดขึ้นจริงใน R_p เพราะว่า

$$P_{input} = IV = YV^2 = j\omega CV^2 + \frac{V^2}{R_p}$$
 (2.24)

ในส่วนหลังคือจำนวนจริง ฉะนั้นกำลังกระจายที่สูญเสีย Power dissipation จะ ขึ้นอยู่กับค่า \mathcal{E}''_{r} และความถี่ที่ตรงเงื่อนไข $\omega \tau = 1$ เนื่องจาก $1/\tau$ คืออัตราของการชนกันของ โมเลกุล Molecular collisions และเมื่อขณะที่ $\omega = 1/\tau$ สองเหตุการณ์ พลังงานสะสมโดย สนามไฟฟ้าและพลังงานถ่ายโอนสู่ Random collisions เกิดขึ้นในอัตราเดียวกัน ทำให้พลังงานถูก เปลี่ยนไปเป็นความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เหตุการณ์นี้เรียกว่า Dielectric resonance จุดที่ \mathcal{E}''_{r} สูง

$$P_{vol} = \frac{P_{loss}}{Volume} = \frac{V^2}{R_p} \times \frac{1}{dA} = \frac{V^2}{\frac{d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r'' \omega A}} \times \frac{1}{dA} = \frac{V^2}{d^2} \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r''$$
(2.25)

ຈະໃຫ້

$$P_{vol} = \omega E^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r'' = 2\pi f E^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r''$$
 (2.26)
HSD
 $P_{vol} = \omega E^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r' \tan(\delta)$ (2.27)
 $\alpha_d(0) \varepsilon_0$
 $\sigma_d(0) \varepsilon_0$
 $\sigma_$

รูปที่ 2.14 เมื่อมีสนามไฟฟ้าคงที่ค่าหนึ่งเปลี่ยนจาก E_0 เป็น E อย่างกะทันหัน ทำให้ Induced dipole moment ลดลงจาก $\alpha_d(0)E_0$ เป็น $\alpha_d(0)E$ การลดลงนี้เกิดขึ้นจาก Random collisions ของโมเลกุล (Kasap, 2006)



รูปที่ 2.15 ค่า Relative permittivity ในรูปของจำนวนเชิงซ้อน และเกิด Relaxation peak ที่ $\omega = 1/\tau$ (Kasap, 2006)



รูปที่ 2.16 (ซ้าย)ตัวเก็บประจุแบบเพลตขนานที่มีแรงคันไฟฟ้าสลับแบบ Sinusodal มีความ สมมาตรเท่ากับฝั่ง (ขวา) วงจรสมมูลของตัวเก็บประจุที่มีความนำ *G_p* ขนานกับตัว เก็บประจุ (Kasap, 2006)

บทที่ 3

การออกแบบการวิจัย

เพื่อที่จะให้ระบบกำจัดแมลงมอดข้าวในข้าวมีการประหยัดพลังงานสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ในขณะที่ต้องได้ผลการผลิตที่ยอมรับได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทาง ในการคำเนินการวิจัย และขอบเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมและจำกัดตัวแปรต่าง ๆ ในรูปที่ 3.1 คือ การวางแผนการออกแบบการทดลอง เริ่มจากการศึกษาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของเพลตขนาน โดย ใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย ตามด้วยการวัดค่าไดอิเล็กทริกของข้าวเพื่อหาข้อจำกัด การใช้งานของระบบกำจัดมอด จากนั้นออกแบบ Prototype ทดสอบศักยภาพของวงจรขยาย สัญญาณความถี่สูงกำลังสูง รวมถึงการออกแบบวงจร Matching network พร้อมกับสร้างขึ้นรูป เพลต และประเมินการทำงานของต้นแบบที่สร้างขึ้น สุดท้ายคือการออกแบบการทดลองกำจัดมอด และประเมินกุณภาพของข้าวหลังผ่านการกำจัดมอด ด้วยการนำข้าวดังกล่าวไปประกอบอาหาร แล้วทดสอบกับอาสาสมัครด้วยวิธี Blinded experiment



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการออกแบบต้นแบบของการกำจัดมอดข้าวสำหรับใช้ใน ครัวเรือน

วิธีการกำจัดมอดข้าว ใช้การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค จากพลังงานสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสลับช่วงคลื่นความถิ่วิทยุ ส่งผ่านไปยังมอดข้าว พลังงานที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปความร้อนในตัว มอดและข้าว การวัคอุณหภูมิจะวัดจากอุณหภูมิของข้าว เนื่องจากมอดข้าวมีขนาดเล็กการวัด อุณหภูมิของมอดโดยตรงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และไม่ทำกัน หลายงานวิจัยอาศัยอุณหภูมิของข้าวเป็น ดัวแปรตามเป็นหลักสำหรับอุณหภูมิ ปกติแล้วการวัดอุณหภูมิของข้าวที่ทำโดยทั่วไปมีสองวิธี วิธี แรกใช้ Fiber optical thermometer วิธีที่สองใช้ Imaging infrared thermometer ทั้งสองวิธีเป็นการวัด อุณหภูมิโดยใช้แสงอินฟราเรค ในการวิจัยนี้ใช้การวัดอุณหภูมิแบบ Imaging infrared thermometer (U5857A, Keysight) ชื่อเรียก โดยย่อของอุปกรณ์นี้คือ IR camera จากรูปที่ 3.2 IR camera รับ ข้อมูลภาพพื้นที่อุณหภูมิจากตัวอย่างทดลอง และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการพลีอตกราฟของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่อหน่วยเวลา (Heat rate) ที่ซึ่ง Heat rate นี้จะนำไปวิเคราะห์หากำลังความร้อน (Heat power) ที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ กำลังไฟฟ้า (Electrical power) ที่ป้อนเข้าไป เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบ



รูปที่ 3.2 IR camera หรือ Imaging infrared thermometer (U5857A, Keysight)

3.1 พารามิเตอร์ของเพลตที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะหาขนาดที่เหมาะสมของแผ่นเพลต จึงศึกษาก่าพารามิเตอร์ของรูปร่างทางกายภาพ ของแผ่นเพลตมีก่าพารามิเตอร์ดังนี้ กวามกว้าง กวามยาว และระยะห่างระหว่างเพลต โดยเบื้องต้น ได้ใช้การจำลองทางโปรแกรมกอมพิวเตอร์ เพื่อหาขนาดที่เหมาะสม จากนั้นสร้างและวัดผล การ จำลองทางโปรแกรมกอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม CST (Computer Simulation Technology GmbH, Dassault Systèmes company, Germany) รูปที่ 3.3 เพื่อหากวามสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ ส่งผลลัพธ์ต่อก่า S11 เป็นต้น

ความยาวของเพลตเป็นอัตราส่วนขึ้นตรงกับระยะเวลาที่ข้าวอยู่ในเพลต เมื่อเพลตยาวขึ้น ข้าวจะอยู่ในเพลตนานขึ้น ข้าวจะเริ่มเข้าสู่เพลตที่ปากทางเข้า และเคลื่อนที่ไปตามความยาวของ เพลต ระยะเวลาที่ข้าวอยู่ในเพลตสามารถ<mark>ควบคุม</mark>ได้จากอัตราการไหลของข้าวก็ได้

ความกว้างของเพลตคูณกับระยะห่างระหว่างเพลตคือพื้นที่ของข้าวที่จะเข้าไปได้ เมื่อความ กว้างมีค่ามากขึ้น ข้าวจะเข้าไปได้มากขึ้นทำให้ชีดจำกัดของอัตราไหลข้าวสูงขึ้น เพื่อรองรับการ ผลิตในปริมาณที่สูง ความกว้างของเพ<mark>ลต</mark>์จึงเป็นพา<mark>ราม</mark>ิเตอร์ที่สำคัญ

ระยะห่างของเพลตขนานเป็นตัวกำหนดความเข้มสนามไฟฟ้า ซึ่งแปรผกผันกันระหว่าง กวามเข้มสนามไฟฟ้ากับระยะห่างเพลต เมื่อระยะห่างมีค่ามากขึ้นความเข้มสนามไฟฟ้าจะมีค่าลดลง แต่หากระยะเพลตต่ำมากเกินไปจะมีผลเสียบางประการ เช่น เกิดการกระโดดของประจุไฟฟ้า หรือ ปริมาตรของข้าวที่เข้าเพลตน้อยลงทำให้กำลังการผลิตต่ำ หรือข้าวร้อนเร็วมากเกินไปควบคุม อุณหภูมิได้ยาก ๆ ดังนั้น การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการให้ความร้อน แบบไดอิเล็กทริกเพื่อการกำจัดแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

รัฐว_ัว_{ักยาลั}ยเทคโนโลยีสุรุบโ



รูปที่ 3.3 หน้า<mark>จอห</mark>ลักของ C<mark>ST</mark> เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา

3.2 การจำลองทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเดลของเพลตใน CST

เมื่อเปิด โปรแกรม CST ขึ้นมาจะแสดงหน้าแรกดังรูปที่ 3.3 ในขั้นแรกจะต้องสร้าง Template สำหรับใช้งานก่อนโดยเลือก Template แบบ MW & RF & Optical จากนั้นเลือก Circuit & Components แล้วเลือก Packages โปรแกรทจะถามว่าจะเลือกใช้ Solvers ตัวไหน ให้เลือก Time Domain ส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนในภายหลังได้ จากขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดหน่วย Units ของขนาดต่าง ๆ มิติของโมเดล หรือ

หน่วยของกวามถี่เป็นต้น ให้กำหนดดังนี้ Dimentions: mm อาลยเทคโบโลยสรี

Dimentions: Frequency: MHz Time: ns Temperature: Celsius Votage: V Current: Α **Resistance:** Ohm Conductance: S Inductance: Η Capacitance: F

เมื่อกำหนดหน่วยของขนาดเสร็จ โปรแกรมจะให้กำหนดช่วงความถี่ที่ต้องการจำลองผล ถึงแม้ว่าจะต้องการใช้งานหรือออกแบบเพียงความถี่เดียว แต่บางกรณีอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ กาดไว้ ดังนั้นการจำลองความถี่ให้ครอบคลุมกับความถี่ที่ต้องการใช้ จะเห็นถึงแนวโน้ม เช่นการ ปรับแต่งพารามิเตอร์จะช่วยให้ สามารถทำนาย คาดการณ์ผลการจำลองเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ ต้องการ อย่างไรก็ตามการกำหนดช่วงความถี่จะต้องกำหนดอย่างเหมาะสม ไม่เช่นนั้นการตั้งช่วง ความถี่ที่กว้างมากเกินไป จะส่งผลต่อการจำลองซึ่งจะทำให้ช้า และเกินความจำเป็น ดังนั้นการ กำหนดความถิ่จะต้องกำหนดอย่างเหมาะสม ในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้ช่วงความถี่ 10 – 2000 MHz นอกจากนี้โปรแกรมมีช่อง Monitors: ซึ่งยังไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกใด ๆ ลงไป จะเพิ่มเองภายหลัง หลังจากขั้นตอนนี้ สุดท้ายคือหน้า Summary รูปที่ 3.4 ที่จะสรุปข้อมูลที่ได้กำหนดไป ในขั้นตอนนี้ สามารถตั้งชื่อให้กับ Template ได้ เมื่อเสร<mark>ีจนล้วก</mark>ด Finish



รูปที่ 3.4 หน้า Summary ของการสร้าง Template ใน CST

หลังจากกำหนด Template ของโปรแกรม จะแสดงหน้าจอว่าง ๆ ในหน้าจอนี้สามารถขึ้น รูปชิ้นงาน 3D เพื่อนำไปจำลองทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักของการใช้โปรแกรม CST คือต้องการ ศึกษาพารามิเตอร์ของเพลตขนาน ดังนั้นจึงทำการสร้างโมเคลในโปรแกรมขึ้นมาโดยอาศัยจาก พารามิเตอร์พื้นฐานที่ต้องมี คือกวามสูง กวามยาว และระยะห่างระหว่างเพลต

ในการใช้โปรแกรมจำลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะต้องมีแหล่งกำเนิดสัญญาณ ซึ่ง ในกรณีนี้จะใช้ Discrete port เป็นแหล่งรับและกำเนิดสัญญาณ วงจรของเพลตขนานที่จะใช้ใน โปรแกรม CST เป็นดังรูปที่ 3.5 เริ่มจาก Discrete port ตัวที่ 1 ผ่านชุด Matching network คือตัว เหนี่ยวนำ Inductance แล้วจึงเป็นโหลดเพลตมีแผ่นตัวนำสองแผ่น ที่ขั้นระหว่างกลางด้วยวัสดุไดอิ เล็กทริก ปิดท้ายด้วย Discrete port ตัวที่ 2 ด้านท้ายระหว่าง Discrete port สองตัวเชื่อมเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือน Groud ของวงจร ในการขึ้นรูปโมเดลในโปรแกรม CST จะใช้การวาด Block แล้ว กำหนดคุณสมบัติทางวัสดุให้กับโปรแกรม เพื่อระบุว่า Block ไหนคือวัสดุอะไร การสร้างสายไฟ หรือตัวเหนี่ยวนำในโปรแกรมจะใช้ Lumped Element ที่เป็นอุปกรณ์ Passive รูปที่ 3.6 คือโมเดล เพลตขนานที่ใช้ PCB ในโปรแกรม CST แบบ 2 ports



รูปที่ 3.5 วงจรของโหลดเพลตขนานพร้อมชุด Matching network (Inductor)



รูปที่ 3.6 3D โมเคลของเพลต<mark>ขนา</mark>นพร้อม Port และ Matching network ที่ขึ้นรูปใน CST

การจำลองผลด้วยโปรแกรม CST จะต้องมีโมเดลก่อน จึงจะสามารถจำลองผลในโปรแกรม เมื่อมีโมเดล 3D ที่สร้างขึ้นรูป และกำหนดก่าคุณสมบัติให้กับวัสดุแต่ละชนิดแล้ว เมื่ออยากจะทราบ ผลของจำลองให้กดที่ Simulation แล้วไปที่ Solver ที่เลือกตอนแรก ซึ่งอาจจะเป็น Time domain หรือ Frequency domain จะมีหน้าต่าง Popup เด้งขึ้นมา ให้กด Start จะเริ่มทำการจำลองผลใน โปรแกรม การจำลองผลในโปรแกรม CST ระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของโมเดล ความ ซับซ้อนโมเดล ความละเอียดของความแม่นยำที่เลือก และช่วงของความถี่ที่ใช้ รวมถึงการดู Field Monitor ที่กำหนดไว้ ในขั้นแรกของการจำลองผลเป็นไปดังรูปที่ 3.7 จะเริ่มจากการสุ่มกำหนด ค่าพารามิเตอร์ค่าหนึ่งขึ้นมาก่อน จากนั้นลองปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อหาแนวโน้มความ เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวแปรที่สนใจคือ S11 เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงกวาม เข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่ทดสอบ DUT (Device under test) และความถี่ เนื่องจากในโมเดลมี 2 ports ดังนั้นก่าผลลัพธ์ที่ได้จาก S-parameter จะมีสี่ตัว คือ S11 S21 S12 S22 และเนื่องจากอุปกรณ์ที่ ทดสอบนี้มีกวามสมมาตรในเชิงเรขาคณิตฯ และไม่สามารถขยายสัญญาณเองได้ (Passive) ดังนั้นก่า S11 และ S22 จึงมีกวามเท่ากัน เช่นเดียวกันกับ S12 และ S21 ที่เท่ากัน ถึงแม้ว่าโปรแกรมจะมี ผลลัพธ์มาให้สี่ตัวแปร แต่จะดูเพียงแค่ S11 และ S21 หลังจากการจำลองผลเสร็จแล้วโปรแกรมจะ สร้างข้อมูลกราฟมาให้ รูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ผลลัพธ์ค่า S11 ที่ไ<mark>ด้จาก</mark>การใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์

การหาค่าพารามิเตอร์ของเพลตจะเริ่มจากค่าที่สุ่มเลือกมาค่าหนึ่ง จากนั้นจึงทคลองปรับที ละพารามิเตอร์เพื่อดูแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ S11 กระบวนการการทคลองคังรูปที่ 3.8 เมื่อ ได้ค่า S11 เป็นที่น่าพอใจ คือ S11 ไปตกที่ความถี่ที่ต้องการและมีค่าติคลบมากกว่า -10 dB จึงถือว่า ใช้ได้ จากนั้นจะเลือกโมเดลต้นแบบในโปรแกรม CST ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่รู้ชัคแล้วว่าจะให้ S11 ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ นำไปสร้างต้นแบบของจริงเพื่อนำไปทคสอบและประเมินขีค ความสามารถต่อไป



Study and experiment parameter of parallel plate using CST

รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเพลตขนาน โดยใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ช่วย

3.3 วัสดุที่ใช้สร้างเพลต

เพลตประกอบไปด้วยตัวนำที่มีพื้นที่ก่าหนึ่ง การเลือกใช้วัสดุที่มาทำเพลตต้องกำนึงถึงก่า กวามนำของวัสดุ โดยธรรมชาติของกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะเกลื่อนที่บริเวณผิวของตัวนำ ขึ้นกับ กวามถี่ โดยในกวามถี่ต่ำ กลิ่นจะเดินทางทั่วทั้งเนื้อตัวนำ แต่หากเป็นกวามถี่สูงกลิ่นจะเดินทาง เฉพาะบนผิวของตัวนำ การเลือกใช้เพลตจึงด้องกำนึงถึงลักษณะทางธรรมชาติของกลิ่น ในการให้ กวามร้อนแบบไดอิเลีกทริก เพลตที่ใช้จะต้องมีลักษณะผอม บาง เพื่อให้กลิ่นสามารถเดินทางใน ตัวนำได้ดี ทั้งยังต้องมีก่ากวามนำสูง การเลือกใช้เพลตจึงใช้แผ่น PCB (Printed circuit board) เนื่องจากวัสดุตัวนำเป็นเนื้อทองแดง ให้ก่ากวามนำสูง ทั้งยังบาง มีรากาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย PCB แบบหน้าเดียวโดยทั่วไปจะมีสองชั้น ชั้นของตัวนำ (Copper layer) และชั้นของวัสดุรอง (Substrate layer) วัสดุที่เป็น Substrate จะใช้ FR4 (Flame resistant) ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ดิดไฟ เหมาะกับเพลต งนานสำหรับการให้กวามร้อน ถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างเพลตจะอยู่ที่ 50 – 60 °C ซึ่งไม่ เพียงพอที่จะทำให้ติดไฟ แต่ในแง่กวามปลอดภัย และความกุ้มก่า รวมถึงการเข้าถึงได้ง่าย การใช้ PCB เป็นเพลตจึงนับว่าสมเหตุสมผล

3.4 ค่าสภาพยอมของข้าว (Permittivity of rice)

เนื่องจากการกำจัดมอดข้าว อาศัยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค ซึ่งวัสดุไดอิเล็กทริค ส่วนมากเป็นข้าว และข้าวที่นิยมบริโภคในประเทศไทยแบ่งออกใหญ่ ๆ ได้สองชนิดคือ ข้าวสาร และข้าวเหนียว ดังนั้นหากข้าวต่างชนิดมีค่าไดอิเล็กที่ต่างกัน จะส่งผลต่อการการทำงานของระบบ ซึ่งอาจทำให้ระบบที่ออกแบบใช้ได้ หรือไม่ได้ในบางกรณี จึงจำเป็นต้องวัดค่าไดอิเล็กทริคของข้าว ทั้งสองชนิด เพื่อยืนยันความสามารถในการทำงานของระบบกำจัดมอดข้าวที่พัฒนาขึ้น

การวัดค่าสภาพขอมของวัสดุจะใช้การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากโพรบ แล้วดูค่า สะท้อนกลับ จากนั้นแปลงค่าสะท้อนกลับเป็นค่าสภาพขอมของวัสดุ โดยทั่วไปค่าสภาพขอมจะอยู่ ในรูปของจำนวนเชิงซ้อน ส่วนที่เป็นค่าจริงเราเรียกว่า ค่าคงที่ใดอิเล็กทริค (Dielectric constant) และส่วนที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนเรียกว่า Dielectric loss factor หรือเรียกข่อว่า Loss factor เป็น พารามิเตอร์เอกลักษณ์ของแต่ละวัสดุ ในสมการ (1) ค่าการกระจายความร้อนต่อหน่วยปริมาตร จะ แปรผันตรงกับ Loss factor ถ้าอยากให้วัสดุนั้นมีอุณหภูมิขึ้นสูงในระยะเวลาที่สั้น ควรจะเลือก ความถี่ที่วัสดุนั้นมีค่า Loss factor สูงสุด เนื่องจากค่า Loss factor ขึ้นอยู่กับความถี่ ฉะนั้นการหาช่วง ความถี่ที่ดีที่สุดจึงสมควรทำ ใช้การวัดค่าไดอิเล็กทริกผ่าน Dielectric probe ร่วมกับเครื่อง Vector Network Analyzer หรือ VNA ค่าใดอิเล็กทริคที่ได้จะได้จากการวัด มีสองค่าจาก $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$ คือก่าคงที่ไดอิเล็กทริค Dielectric constant และ ค่า Dielectric loss factor ทั้งสองก่าเป็นค่าใดอิเล็กทริคของวัสดุ ที่ขึ้นอยู่กับ ความถี่ การวัดค่าใดอิเล็กทริคของข้าว ทำการวัดข้าวสองชนิดคือข้าวเหนียว และข้าวสวย ข้อจำกัด ของ Dielectric probe นี้คือวัดได้เฉพาะวัสดุเนื้อเดียวของแข็งหรือของเหลว หากวัสดุเป็นผงจะต้อง อัดให้แน่นก่อน การวัดค่าไดอิเล็กทริคข้าวจึงต้องบดข้าวให้ละเอียดก่อน จากนั้นอัดให้แน่น จึงจะ สามารถวัดก่าไดอิเล็กทริกของวัสดุที่เป็นก้อนเล็กได้

3.4.1 การวัดค่าสภาพยอมของข้าว (Measured of permittivity of rice)

เนื่องจากข้าวสารมีลักษณะที่เป็นก้อน และมีขนาดเล็กกว่าขนาดของโพรบวัดไดอิ เล็กทริก หากวัดก่าไดอิเล็กทริกของข้าวโดยที่ข้าวยังเป็นเม็ดอยู่ พื้นผิวที่โพรบสัมผัสกับข้าวจะมี ช่องว่างจากอากาศด้วย ทำให้ก่าที่ได้จากการวัดไดอิเล็กทริกไม่ใช่ก่าไดอิเล็กทริกที่แท้จริงของข้าว เนื่องจากมีส่วนที่เป็นช่องว่างอากาศ การแปรผลจะเพี้ยนไป ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างที่จะใช้วัดก่า ไดอิเล็กทริก จึงต้องนำข้าวไปบดให้ละเอียดก่อนเพื่อลดช่องว่างของอากาศ ข้าวที่บดละเอียดเป็นผง จะถูกนำไปอัดให้แน่น ก่อนที่จะทำการวัดก่าไดอิเล็กทริกต่อไป

การบดข้าวใช้เครื่องบดแบบละเอียดสูง Cross beater mill (PULVERISETTE 16, FRITSCH GmbH) รูปที่ 3.9 จากห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี สามารถ ปรับความเร็วในการบดได้ ในการบดข้าวนี้ทางผู้เรี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการ ได้แนะนำให้ใช้ ความเร็ว 2000 รอบต่อนาที ใช้ Filter ขนาด 1 micron เพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางของข้าวที่ถูก บดแล้วประมาณ 1 micron เนื่องจากข้าวที่ถูกบดนั้นผ่าน Filter แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกรองอีกรอบ สามารถนำข้าวที่ผ่านการบดไปใช้ได้ เมื่อบดข้าวเสร็จแล้วจะนำข้าวมาอัดให้แน่นเพื่อพยายามลด ช่องว่างอากาศให้น้อยที่สุด โดยที่ขนาดของตัวอย่างข้าว ที่จะนำไปวัดค่าไดอิเล็กทริก จะต้องมีพื้นที่ หน้าสัมผัสมากกว่าขนาดของหน้าสัมผัสของโพรบวัดไดอิเล็กทริก และต้องมีความสูงของตัวอย่าง ข้าวไม่น้อยกว่า 11 mm ตามสมการ (3.1) เนื่องจากถ่าไดอิเล็กทริก และต้องมีความสูงของตัวอย่าง จำวไม่น้อยกว่า 11 mm ตามสมการ (3.1) เนื่องจากถ่าไดอิเล็กทริก และต้องมีความสูงของตัวอย่าง อลิ่นจะสะท้อนจากขอบ หรือช่วงรอยต่อระหว่างวัสดุที่ต่างกัน ซึ่งจะทำให้การแปรผลผิดเพี้ยนไป เราทราบว่าก่าใดอิเล็กทริกของข้าวจะมีก่าอยู่ระหว่าง 3 – 12 F/m (Nelson, 1996) ซึ่งก่าไดอิเล็กทริก นี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ด้วย ดังนั้นจึงจะต้องเพื่อความสูงของวัสดุให้กรอบกลุม ทุกช่วงก่าไดอิเล็กทริก ของข้าวที่เป็นไปได้

$$t_{\min} = \frac{20}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$
(3.1)



รูปที่ 3.9 เครื่องบดวัสคุ Cross beater mill (PULVERISETTE 16, FRITSCH GmbH)

หลังจากเตรียมตัวอย่างที่จะใช้วัดค่าใดอิเล็กทริกเสร็จแล้ว การวัดก่าใดอิเล็กของ ข้าวที่บดและอัดให้แน่นแล้ว จะใช้โพรบวัดใดอิเล็กทริก Dielectric probe (N1501A, Keysight) ร่วมกับ VNA Vector network analyzer (N9918A, Keysight) และกอมพิวเตอร์ สำหรับแปรผลก่า การสะท้อนของกลื่นไปเป็นค่าใดอิเล็กทริก ในการวัดจะสามารถแปรผลก่าใดอิเล็กทริกออกมาเป็น จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งก่าจริงเรียกว่าก่ากงที่ใดอิเล็กทริก Dielectric constant และส่วนจินตภาพเรียกว่า ก่าสูญเสียของใดอิเล็กทริก Dielectric loss factor ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าก่ากงที่ใดอิเล็กทริกแต่ในความ เป็นจริง ก่ากุณสมบัติทางใดอิเล็กทริกของวัสดุนั้น จะขึ้นอยู่กับกวามถี่ และอุณหภูมิของวัสดุ (Nelson, 2004, 2005; Nelson & Bartley Jr, 2002)

การวัดค่าไดอิเล็กทริคโดยใช้ Dielectric probe (N1501A, Keysight) จะต้องติดตั้ง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลจากทาง Keysight การใช้งานโปรแกรมจะใช้ร่วมกับ USB token มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากเตรียมโปรแกรม ต่อ สาย Coaxial เข้ากับ Dielectric probe และ VNA จากนั้น เชื่อมต่อ VNA และคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย Network LAN ที่มีขั้วต่อแบบ RJ45 การจัดชุดทดลองการวัดดังรูปที่ 3.10

แต่ก่อนจะวัดค่าไดอิเล็กทริกได้ จำเป็นต้องทำการ Calibration ก่อน ซึ่งจำเป็นต้อง ทำทุกครั้งที่มีการวัด หลังจาก Calibration หนึ่งรอบแล้วจะวัดกี่ครั้งก็ได้ แต่หากเก็บชุดการทดลอง ้แล้ว จัดชุดการทดลองการวัดใหม่ หรือมีการเปลี่ยนช่วงความถี่ที่ใช้ในการวัด จำเป็นต้องทำการ Calibration เสมอ การ Calibration เริ่มจากการตั้งความถี่ที่จะใช้วัด เป็นช่วงความถี่ ในการวัดค่าไดอิ เล็กทริกของข้าวนี้ใช้กวามถี่ช่วง 10 – 1000 MHz เมื่อตั้งกวามถี่แล้ว โปรแกรมจะแนะนำขั้นตอน Calibration ให้แก่ผู้ใช้ ขั้นตอนที่ว่านี้คือ โปรแกรมจะให้ผู้ใช้วัด Dielectric probe กับอากาศ (Open calibration) คือปล่อยให้ Probe ไม่สัมผัสกับอะไรเลย นอกจากอากาศ เมื่อพร้อมให้กด Perform ้จากนั้นโปรแกรมจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแนะนำ ้ขั้นตอนถัดมากือให้ Probe วัดกับน้ำ จะต้องเ<mark>ป็น</mark>น้ำ DI เท่านั้น DI water (Deionized water) เป็นน้ำที่ ้มีความบริสุทธิ์สูงแทบจะปราศจาก ion <mark>ของแร</mark>่ธาตุอื่น ขั้นตอนนี้จะต้องระมัคระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากน้ำและความชื้นไม่เป็นมิตรต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ โดยเฉพาะอุปกรณ์ ้อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางชั้นสูงอย่าง VNA ที่มีร<mark>า</mark>กาสูง ซึ่งจำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ของอุปกรณ์ด้วย ในขั้นตอนนี้ให้ใช้น้ำ DI ใส่แก้วมีความสูงไม่น้อยกว่า 100 mm แล้วให้ Probe จุ่ม ในน้ำลงไปประมาณ 5 – 8 mm ห้ามงุ่ม Probe งนมิดขั้วต่อเด็ดขาด ในระหว่างนี้สังเกตด้วยว่า ้บริเวณหน้าสัมผัสของ Probe มี<mark>ฟอง</mark>น้ำก้างอยู่หรือไม่ ห<mark>ากมี</mark>ฟองน้ำอยู่ให้ค่อย ๆ ตะแครง Probe จน ้ไม่มีฟองน้ำค้างอยู่บริเวณหน้<mark>าส</mark>ัมผัสของ Probe จากนั้นวัคอ<mark>ุณ</mark>หภูมิของน้ำโดยใช้ Thermometer ค่า ้อุณหภูมิจำเป็นต้องตรงกั<mark>บค</mark>วามเ<mark>ป็นจริงเพื่อจะได้ค่าที่ได้จ</mark>ากก<mark>าร</mark>วัดใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด หลังจากอ่านอุณหภูมิข<mark>องน้</mark>ำ ให้ใส่ค่าอุณหภู<mark>มิเข้าไปใน</mark>โปรแกรมซึ่งจะมีช่องให้ใส่ เมื่อพร้อมให้ กด Perform ที่โปรแกรม จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายของการ Calibration คือการ Short calibration ซึ่ง ้งั้นตอนนี้สำคัญที่สุด เนื่อง<mark>จากการ Calibration นี้ อาศัยอุปก</mark>รณ์เพิ่มอีกสองตัว คือตัวยึดประกบ และแผ่นรอง Probe หากขาคชิ้นใคชิ้นหนึ่งไปขั้นตอนนี้จะไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะแผ่นรอง Probe ซึ่งเป็นวัสคุเฉพาะ ไม่สามารถใช้อย่างอื่นทดแทน ได้ และ ไม่ใช้ไม่ได้ วิธีคือให้ใส่แผ่นรองเข้า ้ไปในตัวยึดประกบก่อน จึงสวมเข้ากับ Probe การหมุนขันยึดประกบต้องก่อย ๆ ทำ และขันพอตึง มือไม่แน่นไม่หลวม เมื่อพร้อมแล้วกด Perform เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Calibration สำหรับ Dielectric probe

หลังจากเตรียมตัวอย่างที่จะวัดค่าใดอิเล็กทริคและ Calibration การวัดค่าใดอิเล็กท ริกให้นำ หน้าสัมผัสของ Probe สัมผัสกับวัสดุที่เตรียมมาให้ราบเรียบไปกับแนวของวัสดุ อาจจะมี ตัวช่วยในการกดวัสดุกับ Probe ให้แน่น เมื่อจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วให้กดวัดค่าใดอิเล็กทริคใน โปรแกรม ในขั้นตอนนี้จะใช้ช่วงเวลาหนึ่งในการคำเนินการ เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะให้กด แสดงผล ค่าผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูป *ɛ*' และ *ɛ*'' ซึ่งก็คือส่วนจริงและส่วนจินตภาพของค่าสภา พยอม (Permittivity) หรือค่าใดอิเล็กทริคของวัสดุ การเก็บผลการทคลองการวัด จะวัดค่าไดอิเล็กทริคทั้งหมด 10 ครั้งต่อข้าวหนึ่ง ชนิด เพื่อหาค่าเฉลี่ย และป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการวัด ในการ วัดนี้วัดที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25 °C



รูปที่ 3.10 การจัดชุ<mark>ดก</mark>ารวัดค่าไดอิเล็กทริก<mark>ขอ</mark>งข้าวโดยใช้ Dielectric probe

3.5 การออกแบบเครื่องกำจัดมอดข้าวสำหรับครัวเรือน

3.5.1 การออ<mark>กแบบเพลตสำหรับการให้ความร้อนแบบใ</mark>ดอิเล็กทริค

การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกส่วนมากจะให้วัสดุอยู่ระหว่างเพลตขนาน แล้ว จ่ายแรงดันเพื่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้น โดยแรงดันดังกล่าวต้องเป็นแรงดันแบบกระแสสลับเพื่อให้ สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นแบบสลับด้าน เพื่อให้โมเลกุลในวัสดุเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุน เนื่องจากการใช้ สำหรับครัวเรือนจึงต้องคำนึงเรื่องขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป อีกเรื่องที่ต้องกำนึงคือ เรื่องกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อเป็นการกำจัดตัวแปรที่จะมากไป จึงกำหนดให้อุปกรณ์นี้ใช้กำลังไม่ เกิน 1,000 W หรือ 1 kW การออกแบบเพลตและขนาดเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกใช้กับ กำลังไฟฟ้า 1 kW เป็นหัวข้องานวิจัยนี้

เพลตขนานทั้งสองมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม ภายในจะมีข้าวที่จะให้ความร้อน ข้าวมี คุณสมบัติเป็นวัสดุไคอิเล็กทริค ดังนั้นเพลตขนานที่มีข้าวอยู่ภายในจึงเสมือนเป็นตัวเก็บประจุตัว หนึ่ง ดังนั้นโหลดของกำลังไฟฟ้านี้จึงเป็นโหลดแบบความเก็บประจุ Capacitive load การจะส่ง กำลังไฟฟ้าสูงสุดไปยังโหลดจึงจำเป็นต้องมีการ Matching ที่ 50 Ω ซึ่งจะ Matching ได้จะต้องรู้ก่า ความเก็บประจุของเพลตที่มีข้าว การวัดค่า Impedance ของเพลตต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น Impedance meter หรือ Impedance analyzer จากนั้นจึงใช้ Smith chart หาค่าเหนี่ยวนำ (Conductive) หรือค่าความเก็บประจุ (Capacitive) เพื่อใช้ในวงจร Matching network ต่อไป วิธีที่นิยมปฏิบัติทั่วไป คือ ใช้ VNA วัดค่า S11 เพื่อดูแนวโน้มของ Impedance การตรวจสอบการ Matching ก็ใช้ VNA วัด ก่า S11 เช่นเดิม โดยดูจากขนาดแอมพลิจูดของ S11 ที่ความถี่ที่ต้องการซึ่งขนาดของแอมพลิจูดที่ ใช้ได้คือ -10 dB ลงมา ยิ่งติดลบมากยิ่งดี เพราะหมายถึงการสะท้อนกลับที่กวามถี่นั้นมีก่าน้อย

3.5.2 การเลือกใช้เครื่องขยายสัญญาณความถี่สูงกำลังสูง

อุปกรณ์ที่ใช้ขยายสัญญาณความถี่สูงกำลังสูง ที่นิยมใช้มีหลอดสุญญากาศ (Electronics tube) ซึ่งสามารถขยายสัญญาณกำลังสูงได้คี มีความคงทน และใช้ในระดับ อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสียที่มีประสิทธิภาพต่ำ (Alba & Berestov, 2016) อีกทั้งยังมี ขนาคใหญ่ รวมถึงความต้องการใช้การระบายความร้อนด้วยฉม ซึ่งต้องใช้มอเตอร์ขนาคใหญ่ ทำให้ เครื่องขยายสัญญาณกำลังสูงแบบที่เป็นหลอดสุญญากาศมีข้อได้เปรียบเรื่องรองรับกำลังไฟฟ้าใด้ สูง แต่มีจุดอ่อนคือประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับต่ำ (DC power to RF power) และขนาคที่เทอะทะ การออกแบบให้ใช้งานสำหรับครัวเรือนต้องมีขนาคไม่ใหญ่มาก เกินไป เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และต้องประหยัดไฟ ซึ่งได้เลือก LDMOS มาใช้เป็นอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ ซึ่งจะเรียกเครื่องขยายสัญญาณแบบที่ใช้ Semiconductor นี้ว่า SSPA (Solid state power amplifier) เทคโนโลยีของ LDMOS ในขณะทำงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มีขนาคเล็กที่มีกำลังไฟฟ้าต่อตัวสูง รวมถึงประสิทธิภาพที่ก่อนข้างน่าพอใจสำหรับกำลังไฟฟ้า ขนาค 1 kW ต่อหนึ่งตัว เครื่องขยายสัญญาณที่ใช้เป็นเครื่องขยายสัญญาณที่ได้มีการออกแบบและ พัฒนาขึ้นมาในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

SSPA นี้ใช้ LDMOS เบอร์ Freescale semiconductors (MRFE6VP61K25H) สอง ด้ว แต่ละด้วจะมี FET อยู่ภายในสองด้ว การใช้งานจะทำให้เป็น Amp class AB แบบ Push-Pull LDMOS หนึ่งตัวรองรับกำลังสูงสุดได้ 1.25 kW แต่ใช้สองด้วเพราะเนื่องจากต้องการแบ่งเบาภาค ระบายความร้อน หากใช้งานหนึ่งตัวที่กำลัง 1 kW จะทำให้เกิดความร้อนสูง หากระบายความร้อน ไม่ทันจะส่งผลให้ LDMOS เกิดความเสียหายได้ การใช้งาน LDMOS สองตัวทำได้โดยแบ่งกำลัง สัญญาณที่เข้ามาเป็นสองทาง เมื่อขยายสัญญาณผ่านตัว LDMOS มาแล้วจึงรวมสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง

ความสูญเสียในระบบที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง เช่น สูญเสียจากความร้อนใน Power supply หรือ สูญเสียจาก Mismatch ดังแผนภาพที่ 3.11 ระบบกำจัด มอดในข้าวด้วยการให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริค เริ่มจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V จ่ายไฟฟ้า ให้กับ Power supply (Keysight) เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 48 V สำหรับ Power amplifier และ Power supply 12 V สำหรับ Oscillator ที่จะส่งสัญญาณ RF ให้ Power Amplifier ประสิทธิภาพของ Amplifier หาได้จาก

$$PAE = \frac{RF_{out} + RF_{in}}{DC_{in}}$$
(3.2)

เมื่อ PAE คือ Power added efficiency (W)

DC_{in} คือ กำลังของไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนเข้าระบบ (W)

RF_{in} คือ กำลังของสัญญาณ RF ที่ป้อนเข้าระบบ (W)

RF_{out} คือ กำลังของสัญญาณ RF ที่ออกจากระบบ (W)

กำลังสัญญาณ RF ที่ออกจาก Power amplifier จะผ่าน Power meter เพื่อวัดหากำลัง สัญญาณ RF ที่แท้จริง โดยใช้ RF Power meter (Bird 4391A) จากนั้นกำลังของสัญญาณจะเข้า Matching network ก่อนที่จะเข้าโหลดเพลตขนาน การทำ Matching network เพื่อให้โหลดรับกำลัง ได้สูงสุด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เนื่องจากกำลังที่ถูกสะท้อน คือความสูญเสีย เป็นเหตุให้ ประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำ Matching network เพื่อส่งผ่านกำลังสูงสุด ให้แก่โหลด

3.6 การออกแบบวงจร Matching network

โหลดเพลตขนานจะมีสภาพเหมือนตัวเก็บประจุ ตามการอธิบายในบทที่ 2 ดังนั้นเพื่อที่จะ ทำให้ก่าความเก็บประจุ Capacitance มี Impedance เท่ากับ 50 Ω จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความเป็น Inductance คือตัวเหนี่ยวนำมาหักล้างความเป็นความเก็บประจุออกไป สำหรับการปฏิบัติ ทำ Matching network วิธีที่รวดเร็วคือการใช้ VNA Vector network analyzer (N9918A, Keysight) มา หาก่า S11 ก่านี้จะบ่งบอกถึงการที่สัญญาณที่ส่งออกไปสะท้อนกลับมาได้เท่าใด คือช่วงความถี่ใดที่ ส่งออกไปมีการสะท้อนกลับมาน้อย (น้อยกว่า -10 dB) หมายถึงช่วงความถิ่นั้นถูกรับโดยอุปกรณ์ ที่มาทดสอบได้ดี ตรงกันข้ามช่วงความถี่ที่มีการสะท้อนเยอะ(มากกว่า -10 dB) คืออุปกรณ์ที่นำมา ทดสอบไม่สามารถเอาช่วงความถิ่นั้นมาใช้ได้จึงสะท้อนออก สรุปได้ว่า ก่า S11 หากมีก่าต่ำ (น้อย กว่า -10 dB) ที่ความถิ่ใด ความถิ่นั้นสามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ที่มาทดสอบ อุปกรณ์ที่นิยมใช้ ก่า S11 คือประเภท สายอากาศ หรือโหลดชนิดพิเศษที่ใช้กับช่วงความถิ่สูง

การใช้ VNA ทำ Matching network โดยการต่อโหลด DUT (Device under test) เข้ากับ Port1 ของ VNA ซึ่งก่อนที่จะทำการวัดหรือก่อนที่จะใช้งาน VNA จำเป็นต้อง Calibration VNA ก่อน เพื่อให้ก่าที่วัดออกมามีความถูกต้องมากที่สุด หลังจาก Calibration เรียบร้อยแล้วต่อโหลดเข้า กับ VNA แล้วเลือก โหมดวัด S parameter ซึ่งหากต่อเพียง Port เดียว จะวัดได้เฉพาะ S11 ในกรณีที่ วัคสองพอร์ตจะเห็นค่า S11 S12 S21 และ S22 ในขั้นแรกค่าที่วัดได้จะเป็นค่าที่ยังไม่ถูก Matching เพื่อที่จะให้ S11 ไปตกที่ความถี่ที่ต้องการจะต้องปรับค่าความเหนี่ยวนำ หรือปรับขนาดของเพลต เช่นความสูง ความยาว หรือระยะห่างระหว่างเพลต การปรับขนาดความสูงและความยาวไม่สามารถ ทำได้อย่างสะดวก เนื่องจากจะต้องเปลี่ยนเพลตไปเลย ดังนั้นในขั้นนี้ จะเป็นการปรับความ เหนี่ยวนำและระยะห่างระหว่างเพลต

นอกจากนี้การ Matching ควรคำนึงถึงความกว้างของ Bandwidth เนื่องจากโหลดของระบบ เป็นเสมือนตัวเก็บประจุ แต่เป็นตัวเก็บประจุที่ไม่ใช่ก่าคงที่ เมื่อระบบทำงาน ข้าวซึ่งเป็น Dielectric material จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของ Dielectric material เปลี่ยน ก่าคุณสมบัติทางไดอิเล็กท ริคจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (Nelson, 2004, 2005; Nelson & Bartley Jr, 2002)

อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ Impedance matching คือใช้เครื่องมือ Impedance analyzer (E4990A, Keysight) วัดค่า Impedance ของเพลตขนานที่ออกแบบ จากนั้นใช้ Smith chart ในการออกแบบ วงจร Impedance matching (Bowick, Blyler, & Ajluni, 2008) เพื่อให้ฝั่ง Load มีค่า Impedance เท่ากันกับฝั่ง Source คือ 50 Ω

3.7 ประสิทธิภาพ

3.7.1 ประสิทธิภาพของเครื่องขยายสัญญาณ (RF power amplifier efficiency, η_{RF}) ภายในเครื่องขยายสัญญาณกวามถิ่วิทยุกำลังสูง RF power amplifier ประกอบไป ด้วยชุด Matching network ด้าน Input ก่อนที่จะเข้า LDMOS เพื่อขยายสัญญาณ จากนั้นสัญญาณจะ ออกมารวมกันที่ภาค Matching network ด้าน Output ชุดขยายสัญญาณกำลังสูงนี้ออกแบบการขยาย แบบ Class AB push-pull การวัดประสิทธิภาพของเครื่องขยายสัญญาณกำลังสูงจะวัดจาก กำลังไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าไปยังกำลังไฟฟ้ากระแสสลับความถิ่สูงขาออก

 $\eta_{RF} = \frac{RF_{out}}{DC_{in}}$ (3.3)

การปรับจูนภาค Matching network ทั้งค้ำน Input และ Output เป็นกุญแจสำคัญที่ ทำให้เครื่องขยายสัญญาณมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้การละเลยการปรับจูนอาจจะทำให้วงจรเกิด แปรปรวนนำไปสู่ Oscillated โดยถ้าภาค Matching network เกิด Oscillated จะทำให้มี Harmonics เกิดขึ้นจำนวนมากและเยอะ ส่งผลให้ Power amplifier ขยายทุกสัญญาณที่เข้ามา และอาจจะทำให้ เกิด Non-linear ทำให้สัญญาณมีความเพี้ยน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคโหลด ที่ออกแบบไว้ สำหรับความถี่เดียว เมื่อสัญญาณมีหลายความถี่ออกมา ความถี่อื่นที่โหลดไม่สามารถรับไว้ได้จะ ้สะท้อนกลับ กำลังที่สะท้อนกลับนี้จะกลับเข้าไปยัง LDMOS ทำให้ LDMOS เกิดความร้อนที่ตัวมัน เอง Heat dissipated สูงกว่าปกติ อาจจะนำไปสู่การ Overheat และทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ู่ขึ้น ตามเอกสารการใช้งานของ LDMOS ช่วงการขยายสัญญาณแต่ละช่วงจะให้ประสิทธิภาพไม่ ้เท่ากัน และเพราะว่า LDMOS นี้ออกแบบมาใช้สำหรับกำลังสูง ดังนั้นประสิทธิภาพที่ดีสำหรับ LDMOS คือช่วงกำลังสูง เมื่อสัญญาณที่เข้ามาไม่เพียงพอทำให้ LDMOS ทำงานในช่วงกำลังสูงได้ LDMOS จะยังคงขยายสัญญาณ แต่ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นเหตุผลให้การปรับจูน Matching network มีความสำคัญเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน (Thermal efficiency, η_{th}) 3.7.2

การแลกเปลี่ยนพลังงานคล<mark>ื่น</mark>แม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นความร้อน เกิดขึ้นจากสมการ (2.1) สมการนี้คิดในกรณีที่อุดมกติ การหาประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนพลังงานจึงคิดขึ้นจาก ้ กำลังความร้อนเกิดขึ้นที่ข้าว $P_{\scriptscriptstyle heat}$ เทียบกั<mark>บ</mark>กำลัง<mark>ค</mark>ลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ $RF_{\scriptscriptstyle out}$

$$\eta_{th} = \frac{P_{heat}}{RF_{out}}$$
(3.4)

$$P_{heat} = mC_p \left(\Delta T / \Delta t\right)$$
(3.5)

$$P_{heat} = nC_p \left(\Delta T / \Delta t\right)$$
(3.5)

$$P_{heat} = nC_p \left(\Delta T / \Delta t\right)$$
(3.5)

$$P_{heat} = nC_p \left(\Delta T / \Delta t\right)$$
(3.5)

$$P_{heat} = nC_p \left(\Delta T / \Delta t\right)$$
(3.6)

คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป (°C) ในช่วงเวลา Δt (s)

ແລະ

เมื่อ

 ΔT

3.7.3 ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ (Overall efficiency, $\eta_{overall}$)

เป้าหมายของการกำจัดมอดในข้าวคือการให้ความร้อนแก่ข้าวและมอดข้าว ความ ร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกวัดผลเทียบกับกำลังทางไฟฟ้าที่ใช้ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจะคำนวณ จากกำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ป้อนเข้าระบบ เทียบกับความร้อนที่เกิดขึ้นกับข้าว อุณหภูมิต่อหน่วยเวลา ดังนั้นประสิทธิภาพโดยรวมของระบบคือกำลังทางไฟฟ้า (Input) กับกำลังทางความร้อน (Output)

$$\eta_{overall} = \frac{P_{electrical}}{P_{heat}}$$
(3.6)

กำลังทางไฟฟ้าคือปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ ตามรูปที่ 3.11 แบ่งเป็นสามส่วน หลักคือ หนึ่งส่วนกำเนิดสัญญาณ สองส่วนขยายสัญญาณ และสามส่วนระบายความร้อน ส่วน กำเนิดสัญญาณ (Oscillator) สร้างสัญญาณความถี่วิทยุ 80MHz ขนาดกำลัง 10 W ใช้แรงคันไฟฟ้า กระแสตรง 12 V ใช้เครื่องมือ Power supply (Keysight, U8031A) เป็นอุปกรณ์ง่ายไฟให้ส่วนกำเนิด สัญญาณ ส่วนขยายสัญญาณ รับสัญญาณจากส่วนกำเนิดสัญญาณแล้วขยายสัญญาณขึ้นเป็น สัญญาณกำลังสูง ใช้ Power supply (Keysight, N8950A) ง่ายไฟให้ชุดขยายสัญญาณ ส่วนระบาย ความร้อน เป็นพัดลมที่พัดระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในภาคขยายสัญญาณ เนื่องจากกำลังที่สูญเสีย ใปจากการขยายจะเปลี่ยนไปเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ขยายสัญญาณ หากอุปกรณ์ขยาย สัญญาณมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์ขยายสัญญาณเกิดความเสียหายได้ เพื่อป้องกัน ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งพัดลมเพิ่มเพื่อระบายความร้อน



รูปที่ 3.11 ระบบการกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริคประสิทธิภาพสูง

3.8 การกำจัดมอดข้าวด้วยการให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริค

ในการกำจัดมอดข้าวโดยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก จะต้องควบคุมไม่ให้อุณหภูมิ ของข้าวสูงมากหรือต่ำมากเกินไป ไม่เช่นนั้นแล้วข้าวอาจเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถกำจัด มอดข้าวได้ทั้งหมด จากกราฟการให้ความร้อนของ Tang et al. (รูปที่ 3.12) (Hou et al., 2016) จะมี ช่วงพื้นที่สำหรับการกำจัดแมลงแบบระยะเวลาสั้น พื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเส้นทึบและเส้นประ เหนือเส้นทึบคือสามารถกำจัดแมลงได้ในอุณหภูมิหนึ่งต่อระยะเวลาที่ให้ หากการให้ความร้อนต่ำ กว่าเส้นทึบแมลงอาจจะถูกกำจัดไม่หมด เส้นประคือแนวคุณภาพของอาหาร หากการให้ความร้อน สูงกว่าเส้นประ อาหารอาจจะถูกทำลายไปบางส่วนจากความร้อน ส่งผลให้คุณภาพของอาหารที่ ผ่านกระบวนการนี้มีคุณภาพที่แย่ ดังนั้นการให้ความร้อนสำหรับการกำจัดแมลงที่ดีกวรจะให้ความ ร้อนที่อยู่ในช่วงพื้นที่ที่แรเงา คือเหนือเส้นทึบและต่ำกว่าเส้นประ หรือนัยหนึ่งคือให้ความร้อน ในช่วง 47.5 ที่เวลา 12 นาที ถึง 54 ที่เวลา 0.6 นาที



รูปที่ 3.12 ระยะเวลาที่ให้ความร้อนเทียบกับอุณหภูมิ และพื้นที่ของการกำจัดแมลงในขณะที่ยัง รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ (Hou et al., 2016)

การเตรียมมอดข้าวใช้มอดตัวโตเต็มวัย 30 ตัว กละเพศ และข้าวที่ปนเปื้อนมอดโดยกาดว่า จะมีไข่มอคภายในข้าวอยู่จำนวนหนึ่ง ต่อหนึ่งการทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ให้ความร้อนแก่มอคข้าวใช้ 2, 4, 10 วินาที เพื่อหาระยะเวลาที่ให้อัตราการ ตายมอคสูงสุค ในขณะที่ยังรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้อยู่

3.9 การประเมินคุณภาพของข้าวหลังการกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบ ใดอิเล็กทริค

เพื่อที่จะประเมินคุณภาพของข้าวที่ผ่านการกำจัดมอด จึงได้หาอาสาสมัครมาทคลองชิม อาหารที่ปรุงจากข้าวดังกล่าว โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระยะเวลาที่ให้ความร้อน แล้วคละสุ่มแบบไม่ให้ ผู้สมัครทราบว่าอาหารจานไหนมาจากอะไร เพื่อที่จะได้ข้อพิสูจน์ที่ไม่ได้มาจากอคติของ อาสาสมัครเอง วิธีการนี้เรียกว่า Blinded experiment โดยทคลองกับอาสาสมัครจำนวน 10 คน แต่ ละคนจะได้ชิมอาหารสามจาน แล้วให้ประเมินคุณภาพตามความกิดเห็นของอาสาสมัครแต่ละคน กะแนนที่ได้ทั้งหมดจะนำมาให้ตามอาหารแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธีนี้จะสามารถระบุได้ว่าอาหารที่ผ่าน การกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก มีความต่างหรือไม่ต่างจากอาหารปรุงจากข้าว ที่ไม่ผ่านการกำจัดมอด



บทที่ 4 ผลการวิจัย และอภิปรายผล

4.1 ผลการศึกษาพารามิเตอร์เพลตที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการใช้โปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ CST มาเป็นตัวช่วยในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ค่าพารามิเตอร์ของเพลต เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์เพลตและค่า Sparameter โดยเริ่มจากการขึ้นรูปโมเคลสามมิติ (3D model) ในโปรแกรม CST เพื่อสร้างโครงสร้าง ที่จำเป็นต่อระบบให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริก โดยใช้เพลตขนาน โดยส่วนประกอบจะมี เพลต ขนาน วัสดุไดอิเล็กทริกอยู่ระหว่างเพลต วงจร Matching network และ Discrete port สำหรับให้ โปรแกรมระบุรู้จุดที่ป้อนกำลังของ RF power หรือ จุดรับกำลัง RF power ด้วยการที่มี 2 ports จะทำ ให้ทราบถึงขนาดของ S11 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน และ S21 คือค่าการส่งผ่านกำลัง

ระหว่างขึ้นรูปโมเคลส<mark>ามม</mark>ิติ ต้องกำหนดชื่<mark>อตัว</mark>แปรขนาดของมิติของวัสดุด้วยเพื่อให้ ้สะควกต่อการเปลี่ยนแปลงค่า<mark>พาร</mark>ามิเตอร์ ส่วนที่ต้อง<mark>กำห</mark>นดขนาดจะมี ความสูง ความยาวของ เพลต ระยะห่างระหว่างเพลต ซึ่งระยะห่างอันนี้จะเป็นขนาดของวัสดุใดอิเล็กทริคด้วย จากนั้นจะมี ้ความหนาของแผ่น PCB ที่ใช้เป็นเพลต และความหนาของแผ่นทองแคงบน PCB ในขั้นแรก หลังจากขึ้นรูปสามมิติเสร็จแล้ว จะกำหนุดค่าคุณสมบัติของวัสคุไดอิเล็กทริกให้ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงมากที่สุด วัสดุไ<mark>ดอิเล็กทริกที่ใช้นี้คือข้าว ซึ่งมีค่าคุณสม</mark>บัติทางไดอิเล็กทริกดังรูปที่ 4.1 (Nelson, 2005) ซึ่งมีค่า ε' อยู่ในช่วงประมาณ 3 – 5 และค่า ε'' ในช่วงประมาณ 0.2 – 0.4 ที่มีจุด ยอคที่กวามถี่ 39 MHz เพื่อให้การจำลองผลใกล้เคียงกับกวามเป็นจริงจึงต้องกำหนดก่าคุณสมบัติ ทางใดอิเล็กทริกให้สอดกล้องกับชนิดของวัสดุ โดยการเปิดหน้าต่างกำหนดก่าวัสดุใน CST (Material Parameters) อยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอหลักใน Tree list ชื่อ Materials แล้วเลือกวัสดุที่เป็น ้ วัสดุไดอิเล็กทริกที่กำหนดไว้ ในที่นี้ชื่อว่า Rice ดังรูปที่ 4.2 (ซ้าย) จากนั้นไปที่ Dispersion เลือก User ในช่องของ Dielectric dispersion แล้วคลิก Dispersion list... จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ฐปที่ 4.2 (ขวา) ในหน้าต่างนี้ผู้ใช้กำหนดงุด ก่า $arepsilon' \epsilon'$ และกวามถี่ โดยใช้ก่างากใน รูปที่ 4.1 กวรที่งะ กำหนดจุดอย่างน้อยสองจุด เพื่อให้โปรแกรมสามารถ Fitting ค่าได้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ หลังจาก ้ กำหนดจุดแล้ว กด OK จะได้ค่าคุณสมบัติของวัสดุในโปรแกรม (รูปที่ 4.3) ใกล้เคียงกับค่าไดอิ เล็กทริคของข้าวในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ค่าไดอิเล็กทริดของข้าว (Wheat) และมอดข้าวในช่วง 5 kHz – 20 GHz (ซ้าย) เปรียบเทียบค่า Dielectric constant ของข้าวและมอด (ขวา) เปรียบเทียบค่า Dielectric loss factor ข้าว และมอดข้าว โดยมีจุด Relaxation peak ของมอดที่ประมาณ 40 MHz (Nelson, 2005)

aterial Parameters: Rice	×		Dielectric Dispersi	ion Fit		
roblem type: High Frequency	~					
ieneral Conductivity Dispersion 1	Thermal Mechanics Density		Eps			
Dielectric dispersion	Magnetic dispersion		Fitting scheme:	nth order 🔷 🗸		Jse data in frequency range
O Disp. model User	Disp. model O User					
Dispersion List	None	\sim	Max. order: 10	0 7	Erro	r limit: 0.1
			Used order: 1		Erro	r: 0.07047
			Data format:	(Real, Imag) 🗸		Details
			Freq. [MHz]	Eps'	Eps"	Weight 🔨
			10	4.1	0.4	1.0
			100	3.5	0.38	1.0
	Parameter conversion System: Gauss SI		1000	3	0.35	1.0
Basing field	Frequency: 00 KHz	-	5.5	122	5	1.0 🗸
	ลย	ทคเน	aou	Load File	Delete Clear List	

รูปที่ 4.2 กำหนดค่าไดอิเล็กทริคของวัสดุใน CST เพื่อให้มีก่ากุณสมบัติใกล้เกียงกับข้าวในความ เป็นจริง (ซ้าย) กำหนด Dielectric dispersion ที่กำหนดโดย User (ขวา) กำหนดจุดของ ก่าไดอิเล็กทริก โดยกำหนดสามจุดกวามถื่



รูปที่ 4.3 ค่าคุณสมบัติของวัสดุที่กำหนดโดยผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้มีความใกล้เคียงกับค่า ใดอิเล็กทริคของข้าว เพื่อให้การจำลองผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความแม่นตรง

หลังจากกำหนดค่าวัสดุ ไดอีเล็กทริดของข้าวแล้ว การจำลองผลการทดลองจะเริ่มจาก กำหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของเพลต ซึ่งมี ความยาว ความกว้าง และระยะห่างระหว่างเพลต โดย กำหนดค่าเริ่มต้นที่ 10 mm สำหรับทุกพารามิเตอร์ รูปที่ 4.4 แล้วปรับพารามิเตอร์ที่สนใจเพิ่มขึ้น ที ละ 10 – 20 mm ตามความเหมาะสม จากนั้นจึงเปลี่ยนไปดูพารามิเตอร์อื่น การเปลี่ยนพารามิเตอร์ ในโปรแกรม ให้เปลี่ยนในหน้าต่าง Parameter List เมื่อเปลี่ยนแล้วกด Parametric Update เพื่อให้ โปรแกรมอัพเดตพารามิเตอร์ตามที่กำหนด ในการจำลองนี้ได้เพิ่มพารามิเตอร์อีกตัวเข้ามาคือ Margin หรือระยะห่างระหว่างวัสดุใดอิเล็กทริก และขอบของเพลต เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการที่ สนามไฟฟ้าบริเวณขอบมีค่าที่ไม่ Uniform หรือ Fringing fields ในขั้นแรกจะให้ระยะห่างระหว่าง ขอบนี้เป็นศูนย์ แล้วจึงเพิ่มระยะห่างนี้เพื่อศึกษาต่อไป



รูปที่ 4.4 ขนาดเริ่มต้นของเพลตขนาน 10 x 10 x 10 mm โดยใช้ PCB เป็นเพลตและมีวัสดุ ใดอิเล็กทริคอยู่ภายในระหว่างเพลต

4.1.1 ความยาวของเพลต

การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ความยาวของ เพลต เพื่อหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ S11 โดยกำหนดค่าความยาวคังนี้ 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, และ 300 mm ทั้งหมด 11 ขนาด ในการจำลองผลจะเลือกการจำลองผลแบบ Par. Sweep คือการกำหนดค่าพารามิเตอร์ล่วงหน้า แล้วให้โปรแกรมจำลองผลตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ด้วยวิธีนี้สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 11 แบบคังกล่าว แล้วให้โปรแกรม จำลองผลตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสะควกสำหรับผู้ใช้ ไม่ต้องคอยรอการจำลองผลครบหนึ่ง ครั้งแล้วค่อยสั่งโปรแกรมทีละครั้ง รูปที่ 4.5 คือผลจากการจำลองผลด้วยโปรแกรม CST



รูปที่ 4.5 ผลการจำลองค่าพารามิเตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดของเพลต ค่า S11 มีแนวโน้มทาง ความถี่ต่ำลงเมื่อขนาดความยาวเพลตเพิ่มขึ้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 10 mm และ ระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm

จากผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงค่าความยาวของเพลต พบว่า เมื่อเริ่มต้นที่ความยาวเท่ากับ 10 mm ค่า S11 ที่ได้ไปลงที่จุดต่ำสุดที่ 210.2 MHz เท่ากับ -7.48 dB เมื่อเพิ่มความยาวขึ้น ค่าจุดต่ำสุดของ S11 มีแนวโน้มขยับไปทางซ้ายคือความถี่ที่ต่ำลง และยิ่งไป กว่านั้นคือค่า S11 ดีขึ้นเนื่องจากจุดต่ำสุดของ S11 ติดลบมากขึ้นบ่งบอกถึงการสะท้อนกลับที่ต่ำลง แปรความได้ว่าโหลดมีการซับกำลังได้มากขึ้น ค่า S11 ที่ดีควรจะติดลบมากกว่า -10 dB เพราะยิ่งติด ลบมากยิ่งมีการสะท้อนกลับมาน้อย ค่าต่ำสุดของ S11 และความถี่ที่ต่ำสุด เทียบกับความยาวที่ เปลี่ยนไปโดยมีก่าความกว้างและระยะห่างเริ่มต้นที่ 10 mm เป็นดังตารางที่ 4.1 การที่ความยาวของ เพลตเพิ่มขึ้นถึงแม้ความกว้างและระยะห่างระหว่างเพลตจะเท่าเดิม ทำให้พื้นที่ของเพลตเพิ่มมาก ขึ้น เมื่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ค่าความเก็บประจุเพิ่มขึ้นตามสมการที่ (2.7) และ (2.22) ซึ่งเป็น สาเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับ S11

ความยาวของเพลต (mm)	ความถี่ที่ Resonance (MHz)	S11 (dB)
10	210.2	-7.48
15	198.0	-7.75
20	174.3	-8.02
30	152.8	-7.98
40	137.5	-8.06
50	124.8	-8.08
70	95.7	-8.31
100	82.1	-8.48
150	67.1	-9.12
200	57.7	-10.44
300	46.4	-11.33

ตารางที่ 4.1 ผลการจำลองกวามถี่ที่เพลต Resonant เมื่อขนาดกวามยาวของเพลตเปลี่ยน

เพื่อยืนยันผลการทคลองที่ได้ จึงได้กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นเพิ่มอีกสองเงื่อนไข คือ ให้ค่าความกว้างเริ่มต้นเท่ากับ 50 mm และระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm และอีกเงื่อนไขคือ ค่าความกว้างเริ่มต้นเท่ากับ 10 mm และระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 50 mm แล้วดูผลที่ได้จากสอง เงื่อนไข ว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไม่ ผลจากการให้ความกว้างเริ่มต้นเท่ากับ 50 mm เป็นไป ดังรูปที่ 4.6 และตารางที่ 4.2 และผลของค่าเริ่มต้นระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 50 mm เป็นไปดัง รูปที่ 4.7 และตารางที่ 4.3



- รูปที่ 4.6 ผลการจำลองค่าพารามิเตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดของเพลต ค่า S11 มีแนวโน้มทาง ความถี่ต่ำลงเมื่อขนาดความยาวเพลตเพิ่มขึ้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 50 mm และ ระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm
- ตารางที่ 4.2 ผลการจำลองความถี่ที่เพลต Resonant เมื่อขนาดความยาวของเพลตเปลี่ยน โดยมี เงื่อนไขเริ่มต้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 50 mm และระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm

ความยาวของเพลต (mm)	ความถี่ที่ Resonance (MHz)	S11 (dB)		
10	113.4	-8.17		
15	98.46	-8.04		
20	85.97	-7.99		
30	73.47	-7.79		
40	1 aun 63.47 au	-7.60		
50	55.98	-7.85		
70	48.48	-8.60		
100	40.98	-8.82		
150	33.48	-9.16		
200	28.48	-10.14		
300	23.49	-11.27		



- รูปที่ 4.7 ผลการจำลองค่าพารามิเตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดของเพลต ค่า S11 มีแนวโน้มทาง ความถี่ต่ำลงเมื่อขนาดความยาวเพลตเพิ่มขึ้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 10 mm และ ระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 50 mm
- ตารางที่ 4.3 ผลการจำลองความถี่ที่เพลต Resonant เมื่อขนาดความยาวของเพลตเปลี่ยน โดยมี เงื่อนไขเริ่มต้น ที่ความกว้างเพลตเท่ากับ 10 mm และระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 50 mm

50 11111		
ความยาวของเพลต (mm)	ความถี่ที่ Resonance (MHz)	S11 (dB)
10	263.39	-6.88
15	240.90	-7.58
20	220.91	-8.11
30 78	135.92 aga	-8.76
40	178.43	-9.09
50	165.93	-9.12
70	145.94	-9.33
100	125.95	-9.64
150	104.63	-9.50
200	90.96	-9.05
300	75.97	-11.11

เมื่อให้ก่าเริ่มด้นของกวามกว้างเพิ่มเป็น 50 mm พบว่าจุดที่ S11 ต่ำสุดเริ่มด้นถูก งยับเสื่อนไปทางซ้าย คือกวามถิ่ต่ำลง และกวามถิ่ของจุดที่ S11 ต่ำสุดก็มีกวามถิ่ต่ำลงเมื่อเพิ่มความ ยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันกับแบบแรกที่กำหนดก่าพารามิเตอร์ทั้งสามตัวให้เป็น 10 mm สิ่งที่แตกต่างจากแบบแรกคือหนึ่ง ความถิ่ที่ S11 ต่ำสุดทั้งหมดถูกขยับไปทางซ้าย และสอง Bandwidth ของ S11 มีกวามกว้างมากขึ้น ซึ่งการที่ Bandwidth เพิ่มขึ้นหมายถึงโหลดสามารถรับมือ กับการเลื่อนของกวามถิ่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ Mismatch อาจจะนำไปสู่การสะท้อนกลับเข้า วงจรงขยายสัญญาณและอาจทำให้อุปกรณ์เกิดกวามเสียหายได้แต่ในเมื่อมี Bandwidth ที่กว้างกว่าทำ ให้โหลดสามารถรับกำลังได้ถึงแม้จะไม่ดีเท่าจุดที่ต่ำที่สุด ในบางกรณีก็สามารถลดการสะท้อน กลับไปยังวงจรงขยายสัญญาณได้ ในขณะที่หากให้ระยะห่างระหว่างเพลตเริ่มต้นเท่ากับ 50 mm ผล การทดลองที่ได้ก่า S11 มี Bandwidth ที่แถบมากกว่าสองแบบที่ผ่านมา ในขณะที่แนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงของกวามยาวยังกงรูปแบบเดิมคือกวามถิ่ของจุดที่ S11 ต่ำสุดก็มีกวามถิ่ต่ำลงเมื่อเพิ่ม กวามยาวมากขึ้น ถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นจุดค่ำสุดของ S11 จะอยู่ที่กวามถิ่สูงกว่าสองแบบที่ผ่านมา แต่ เมื่อเพิ่มกวามยาวมากขึ้น จุดต่ำสุดของ S11 มีกวามถิ่ต่ำลง จากผลการทดลองพรามิเตอร์กวามยาว ของเพลตทำให้สามารถได้ข้อสรุปว่า การเพิ่มกวามยาวของเพลตส่งผลให้ก่าดวามเก็บประจุสูงขึ้น แล้วส่งผลให้ก่า S11 แปรผกผันกับค่าความเก็บประจุ

4.1.2 ความกว้างข<mark>อ</mark>งเพลต

หลังจากที่ได้ข้อสรุปจากการทดลองเพิ่มความยาวของเพลต ขั้นตอนต่อไปคือ การศึกษาพารามิเตอร์ความกว้างของเพลต ผลลัพธ์ที่ได้ (รูปที่ 4.8 และตารางที่ 4.4) มีความ กล้ายคลึงอย่างมาก กับผลการทดลองของการปรับพารามิเตอร์ความยาวครั้งแรก สาเหตุเนื่องจาก กุณลักษณะทางรูปทรงเรขาคณิตฯ มีความเหมือนกัน เพียงแต่เพลตเหมือนถูกหมุนไป 90 องศา ดังนั้นก่าความเก็บประจุของเพลตจึงเหมือนกัน และเมื่อให้ก่าความยาวตั้งต้นเป็น 50 mm หรือให้ก่า ตั้งต้นระยะห่างระหว่างเพลตเป็น 50 mm ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันกับการปรับพารามิเตอร์ความยาว



รูปที่ 4.8 ผลการจำลองก่าพารามิเตอร์ S11 ของการเปลี่ยนขนาดของเพลต ก่า S11 มีแนวโน้มทาง กวามถี่ต่ำลงเมื่อขนาดกวามกว้างเพลตเพิ่มขึ้น ที่กวามยาวเพลตเท่ากับ 10 mm และ ระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 10 mm

ความยาวของเพลต (mm)	ความถี่ที่ Resonance (MHz)	S11 (dB)
10	210.92	-7.39
15	185.93	-7.77
20	168.43	-7.86
30	143.44	-8.11
40	125.95	-8.14
50 78	13.46 aga	-8.17
70	98.46	-7.78
100	83.46	-7.89
150	68.47	-9.18
200	58.47	-10.71
300	48.48	-11.39

ตารางที่ 4.4 ผลการจำลองควา<mark>มถี่ที่</mark>เพลต Resonant เมื่<mark>อข</mark>นาดความกว้างของเพลตเปลี่ยน
การที่ผลการทคลองปรับค่าพารามิเตอร์ความยาวและความกว้าง นั้นได้ผลลัพธ์ เหมือนกัน เป็นเพราะค่าความเก็บประจุของเพลตไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่ารูปทรงจะมีการขยับในคน ละทิศกัน แต่เมื่อค่าความเก็บประจุเท่าเดิม จึงทำให้ S11 ที่ได้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก เนื่องจากทุกการขยับหนึ่งครั้งของการปรับพารามิเตอร์ความยาว จะมีพื้นที่ กว้างคูณยาว เท่ากันกับ การปรับพารามิเตอร์ความกว้าง ดังนั้นส่วนที่จะมีผลต่อ S11 ที่จะศึกษาต่อไปคือพื้นที่ของเพลต และตามด้วยระยะห่างระหว่างเพลต

4.1.3 พื้นที่ของเพลต

เพื่อที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของเพลตและ S11 จึงทำการเก็บผล การทคลองเพิ่มในการปรับพารามิเตอร์สองตัวคือความยาวและความกว้างไปพร้อมกัน และ เนื่องจากพื่นที่ของเพลตส่งผลต่อค่าความเก็บประจุ การผลการทคลองที่ผ่านมา เมื่อเพิ่มความยาว หรือความกว้าง ในขณะที่ระยะห่างระหว่างเพลตมีค่าเท่าเดิม จะทำให้ค่าความเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อค่าความเก็บประจุเพิ่มขึ้นทำให้ จุดที่ S11 ต่ำสุดมีการขยับความถี่ลง ในขณะที่เมื่อให้ พารามิเตอร์เริ่มต้นของระยะห่างระหว่างเพลตมีค่าสูงขึ้น หมายความว่าค่าความเก็บประจุตั้งต้นมีค่า ต่ำลง ทำให้ค่า S11 เริ่มต้นมีความถิ่งยับขึ้นสูง แต่เมื่อเพิ่มพื้นที่ของเพลต ค่า S11 มีการขยับความถิ่ ลง ในลักษณะเดิม ซึ่งจุดที่ S11 ต่ำสุดนี้คือจุดที่มีการ Resonant ของเพลตกับตัวเหนี่ยวนำ ดังสมการ (4.1)

(4.1)

10

เมื่อค่ากวามเก็บประจูเพิ่มขึ้น ในขณะที่ก่ากวามเหนี่ยวนำเท่าเดิม จะทำให้กวามถี่ Resonant ลดลง สามารถปรับเพลตให้ได้ขนาด และความถี่ Resonant ตามที่ต้องการได้ การกำหนด พื้นที่เพลตจะกำหนดตามอัตราส่วนระหว่างกวามกว้างและกวามยาวด้วย โดยจะใช้อัตราส่วนกว้าง ต่อยาว 1:1, 1:1.5, 1:1.61, 1:2, 1:2.5, และ 1:3 ทั้งหมด 6 แบบ แต่ละแบบจะใช้ 3 ขนาด โดยมีขนาด กวามกว้างเริ่มต้นที่ 10, 30, และ 70 ผลการทดลองการจำลองพื้นที่ของเพลตในตารางที่ 4.5 จากผล การทดลองที่ได้ สนับสนุนข้อมูลเดิมที่ว่า เมื่อพื้นที่เพลตเพิ่มขึ้น ความถี่ที่ Resonance จะต่ำลง เนื่องจากค่าความเก็บประจุจากเพลตเพิ่มขึ้น แต่ค่าความเหนี่ยวนำเท่าเดิม จากแนวโน้มพบว่ายิ่ง พื้นที่เพิ่มขึ้นก่า S11 ยิ่งต่ำลง เมื่อพื้นที่ของเพลตเพิ่มขึ้นจะทำให้การดูดซับกำลังทำได้ดีขึ้น พื้นที่ ของเพลตแปรผกผันกันความถี่ Resonance เมื่อพื้นที่ต่ำ ความถี่ Resonance จะสูง เนื่องจากพื้นที่ เพลตต่ำทำให้ก่ากวามเก็บประจุด้า และเมื่อก่าความเก็บประจุต่ำในขณะที่ค่าความเหนี่ยวนำเท่าเดิม จะทำให้กวามถี่ Resonance สูงขึ้นตามสมการ (4.1)

Plate ratio	Width x Height (mm)	Area (mm ²)	Resonance frequency (MHz)	S11 (dB)
1:1	10 x 10	100	210.92	-7.3928
	30 x 30	900	92.924	-7.5866
	70 x 70	4900	42.018	-8.3263
	10 x 15	150	185.93	-7.7552
1:1.5	30 x 45	1350	75.97	-7.6988
	70 x 105	7350	33.487	-8.7826
1:1.61	10 x 16.1	161	180.93	-7.7629
	30 x 48.3	1449	73.471	-7.8008
	70 x 112.7	78 <mark>89</mark>	30.988	-8.9265
1:2	10 x 20	200	165.93	-7.9839
	30 x 60	1800	67.499	-7.9832
	70 x 140	9800	28.489	-9.8644
1:2.5	10 x 25	250	150.94	-7.8685
	30 x 75	2250	60.976	-8.0158
	70 x 175	12250	25.99	-10.482
1:3	10 x 30	300	140.94	-8.0406
	30 x 90	2700	53.479	-8.1667
	70 x 210	14700	25.99	-10.881

ตารางที่ 4.5 ผลการจำลองขนาดของเพลต ที่อัตราส่วน และพื้นที่ของเพลตต่างกัน เพื่อหา ความสัมพันธ์ของความถี่ที่ Resonance และการสะท้อนกลับ

4.1.4 สนามไฟฟ้าภายในวัสดุที่อยู่ระหว่างเพลต

เพื่อศึกษากระกระจายตัวของสนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ที่ความถี่ต่างกัน เพื่อหา ความถี่ที่เหมาะสมกับงานที่ใช้ในการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค จากสมการ (2.1) กำลังการ กระจายต่อหน่วยปริมาตรจะแปรผันตรงกับขนาดความเข้มสนามไฟฟ้ากำลังสอง ดังนั้นยิ่ง สนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงยิ่งเกิดการเปลี่ยนพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไปเป็นพลังงานความร้อน ได้ดี แต่นอกเหนือจากความความสนามไฟฟ้าแล้วยังต้องกำนึงถึงการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าใน วัสดุด้วย เนื่องจากการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ย่อมทำให้ความร้อนที่เกิดไม่ สม่ำเสมอตามไปด้วย การกำนึงถึงการเกิดความร้อนที่เสมอทั่วกันตลอดทั้งวัสดุจึงเป็นสิ่งที่ต้อง พิจารณาด้วย

ในการทดลองจะพิจารณาสนามไฟฟ้าที่ความถี่ 10, และ 80 โดยจะออกแบบเพลต ให้ S11 ไปลงที่ความถี่ดังกล่าวที่มี Magnitude ใกล้เคียงกันแล้วพิจารณาที่ความถี่ 10, 80, 500, และ 1200 MHz แต่ขนาดของเพลตแต่ละความถี่อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากค่าความเก็บประจุไม่เท่ากัน ส่งผลให้ความถี่ Resonant ไม่เท่ากัน ในรูปที่ 4.9 เป็นผลการทดลองของการทำให้เพลตใช้งานที่ ความถี่ 10 MHz ได้ความถี่ Resonant ที่ 10.1 MHz S11 เท่ากับ -7.24 dB มีความเข้มสนามไฟฟ้า สูงสุดที่ 456.14 V/m มีความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ Uniform เนื่องจากทั่วทั้งวัสดุมีความเข้ม สนามไฟฟ้าที่ไม่แตกต่างกันมาก เมื่อคำนวณเป็นกำลังสูญเสียในรูปของความร้อนจะมีอุณหภูมิที่ สม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณวัสคุ ในการพิจารณาจำเป็นต้องคิดมุมของเฟสด้วย เนื่องจากที่เฟสต่างกันจะ ส่งผลถึงความเข้มสนามไฟฟ้า มุมเฟสของสัญญาณในจุดที่มีความเข้มสนามไฟฟ้าสู่งสุดและต่ำสุด คือที่มุมเฟส 60, และ 150 องศา ตามข้อมูลในตารางที่ 4.6 ในรูปที่ 4.10 คือสนามไฟฟ้าในวัสดุที่มุม เฟส 60, และ 150 องศาตามลำคับ ผลการทดลองความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งกลางเพลตที่มุม เฟส 60, และ 150 องศา ตามข้อมูลในตารางที่ 4.6 ในรูปที่ 4.10 ผลิยสนามไฟฟ้าสิ่งสุดและต่ำสุด คือ 911.271 V/m เมื่อเทียบกับมุมเฟสอื่น และที่มุม 150 และ 330 มีความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำที่สุดคือ 0.583 V/m



รูปที่ 4.9 สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณเพลตขนานที่มุมเฟส 0 องศา (ซ้าย) มุมมองด้านบนเพลต สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในเพลตมีความเป็น Uniform สูง ถึงแม้บริเวณขอบจะมีการ กระจายตัวของสนามไฟฟ้าแบบ Fringing fields แต่สนามไฟฟ้าบริเวณภายในวัสดุไดอิ เล็กทริกยังคงมีความ Uniform (ขวา) มุมมองด้านข้างของเพลต ที่ขอบของเพลตมี สนามไฟฟ้ากระจายตัวออกมาจากเพลตเล็กน้อย



รูปที่ 4.10 สนามไฟฟ้าที่กะจายตัวบริเวณเพลต (บน) ที่สนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงสุดที่มุมเฟส 60 องศา และ (ล่าง) ที่สนามไฟฟ้ามีความเข้มต่ำที่สุดที่มุมเฟส 150 องศา

Phase (degree)	Electric field intensity (V/m)
0	456.14
30	789.475
45	880.371
60	911.271
90	788.892
120	455.13
135	235.291
150	0.583
180	456.14
210	789.475
225	880.371
240	911.271
270	788.892
300	455.13
315	235.921
330	0.583
360	456.14

ตารางที่ 4.6 ความเข้มของสนามไฟฟ้าเมื่อมุมเฟสเปลี่ยนไป ของเพลตที่ Resonance ที่ 10 MHz

ในรูปที่ 4.10 สนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงสุดที่มุมเฟส 60 และมีความเข้ม สนามไฟฟ้าเกือบเท่ากัน ทั่วทั้งบริเวณวัสดุที่อยู่ภายในเพลต เนื่องจากเพลตถูกออกแบบมาเพื่อ ความถี่ที่ใช้นี้คือ 10MHz แต่หากนำมาใช้ที่ความถี่สูง ที่ 80, 500, 1200 MHz สนามไฟฟ้าจะเป็นไป ดังรูปที่ 4.11 เพื่อให้เห็นรายละเอียดของสนามไฟฟ้าได้ชัดเจน ในแต่ละความถี่จึงไม่ได้ใช้สเกล สนามไฟฟ้าอันเดียวกัน ในรูปที่ 4.11 ไล่จากบนลงล่างคือที่มุมเฟส 0, 45, 90, และ 120



รูปที่ 4.11 การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในเพลต จากซ้ายไปขวาที่มุมเฟส 0, 45, 90 และ 120 องศา ที่ความถี่ 80 MHz, 500 MHz และ 1200 MHz

ในรูปที่ 4.11 (แถวแรก) คือสนามไฟฟ้าภายในวัสดุที่ความถี่ 80 MHz จากซ้ายไป ี้ขวาคือที่มุมเฟส 0, 45, 90, และ 120 สนามไฟฟ้ามีความเข้มอยู่ในช่วง 0 – 60 V/m ถึงแม้ว่าจะมี กระจายตัวของสนามไฟฟ้าค่อนข้าง Uniform ใกล้เคียงกับของความถี่ 10 MHz แต่เนื่องจาก ้สนามไฟฟ้ามีความเข้มที่ต่ำเกินไป เนื่องจากเพลตที่ทคสอบนี้มีค่า S11 ที่ความถี่ 80 MHz เท่ากับ -0.36 dB นับว่าแทบจะสะท้อนกำลังกลับหมด ที่ความถี่ 80 MHz สำหรับเพลตที่ออกแบบมาที่ ้ความถี่ 10 MHz จึงไม่สามารถใช้งานได้ แต่เพื่อศึกษาผลการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในความถี่ที่ ้ไม่ใช่ความถี่ที่ออกแบบ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของสนามไฟฟ้าภายในวัสดุระหว่างเพลตได้คื ้ยิ่งขึ้น จึงต้องพิจารณาการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในความถี่อื่น นอกจากนี้มุมเฟสที่ให้ความเข้ม สนามไฟฟ้าสูงสุดเป็นคนละมุมกับความเข้ม<mark>สน</mark>ามไฟฟ้าสูงสุดของ 10 MHz รูปที่ 4.11 (แถวกลาง) ้ คือสนามไฟฟ้าที่ความถี่ 500 MHz มีคว<mark>ามเข้ม</mark>สนามไฟฟ้าในช่วง 0 – 25 V/m น่าสนใจตรงที่ ้สนามไฟฟ้าที่กระจายตัวไม่สม่ำเสมอ มีช่<mark>วงหรือ</mark>แถบที่สนามไฟฟ้าเป็น 0 V/m ตลอคมมเฟส เป็น แถบที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนมุมเฟสเป็นมุมใด <mark>จ</mark>ะได้สน<mark>า</mark>มไฟฟ้าเท่ากับหรือใกล้เคียง 0 V/m และสุดท้าย รูปที่ 4.11 (แถวสุดท้าย) เป็นสนาม<mark>ไฟ</mark>ฟ้าของค<mark>วา</mark>มถี่ 1200 MHz ที่ความถี่นี้แถบหรือช่วงที่ ้สนามไฟฟ้าเท่ากับ 0 V/m ไม่ได้อยู่กับที่เหมือนของความถี่ 500 MHz แต่มีการเปลี่ยนหรือตำแหน่ง ้ของแถบที่เป็น 0 V/m มีความเข้มสนามไฟฟ้าช่วง 0 – 30 V/m ซึ่งสูงกว่าของความถี่ 500 MHz แต่ ้บริเวณที่มีความเข้มสูงเป็นเพี<mark>ยง</mark>บริเวณแคบเพียงจุค หรือสองจุดทั่วทั้งวัสคุ

ต่อ ไปเป็นการพิจารณาเพลตที่ออกแบบสำหรับความถี่ 80 MHz กระบวน การศึกษาจะเป็นแบบเดียวกันกับการศึกษาเพลตที่ความถี่ 10 MHz โดยจะพิจารณาที่ความถี่ที่ ออกแบบ จากนั้นจึงนำเพลตดังกล่าวไปศึกษาที่ความถี่อื่น เพลตที่ออกแบบสำหรับความถี่ 80 MHz มีก่า S11 เท่ากับ -7.58 dB ซึ่งใกล้เกียงกับเพลต 10 MHz ในรูปที่ 4.12 กือกระจายตัวของสนามไฟฟ้า ที่ความถี่ 80 MHz มุมเฟส 90 ซึ่งมีความเข้มสนามไฟฟ้าสูงที่สุดเท่ากับ 1837.88 V/m ข้อมูลผลการ ทดลองความเข้มสนามไฟฟ้ากับมุมเฟส 0 - 360 ในตารางที่ 4.7 จากข้อมูลในตาราง ที่ความเข้ม สนามไฟฟ้าต่ำที่สุดคือที่มุมเฟส 0, 180 มีก่าเท่ากับ 93.875 V/m และที่ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุดที่ มุมเฟส 90 และ 270 ในรูปที่ 4.12 คือสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มสูงสุดที่มุมเฟส 90 การกระจายตัว ค่อนข้าง Uniform แต่ความ Uniform แข่กว่าของเพลตความถี่ 10 MHz อาจจะเป็นเพราะเนื่องจาก ระยะห่างระหว่างเพลตของเพลตความถี่ 80 MHz มีระยะที่มากกว่า การกระจายตัวของสนามไฟฟ้า มีการกระจายตัวที่ดีเมื่ออยู่ภายในวัสดุ แต่ที่ขอบมีความไม่สม่ำเสมออยู่ สาเหตุที่บริเวณของขอบ เพลตมีกวามเข้มสนามไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเพราะ Edge effects ที่ทำให้สนามไฟฟ้าบริเวณขอบ มีความ Non-linear และการเกิดสนามไฟฟ้าดังกล่าวเรียกสนามไฟฟ้านั้นว่า Fringing fields ที่บริเวณ ขอบของวัสดุมีความเข้มสนามไฟฟ้าด่ำกว่าบริเวณตรงกลาง ห่างกันประมาณ 200 V/m และจุดที่ด่า ที่สุดคือบริเวณขอบมุมของวัสดุทั้งสี่ด้าน ที่บริเวณนี้มีความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำกว่าบริเวณกลางอยู่ ประมาณ 400 V/m

การเปลี่ยนพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นความร้อนที่เกิดขึ้น โดยใช้สมการ (2.1) ใน CST มีการคำนวณ Power loss dissipation (W/m³) อยู่ในชื่อ Power loss density ในรูปที่ 4.13 (ซ้าย) คือ Power loss density ในวัสดุ ไดอิเล็กทริก ผลที่ได้นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมเฟสของ สัญญาณ เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่นำมาคำนวณคือก่าสัมบูรณ์ของสนามไฟฟ้ายกกำลังสอง ผลการ ทดลองที่ได้สอดกล้องกับกวามเข้มสนามไฟฟ้า กล่าวกือ Power loss density แปรผันโดยตรงกับ ความเข้มสนามไฟฟ้า มีก่าสูงบริเวณตรงกลางวัสดุ ก่าสูงสุดที่ได้คือ 3781 W/m³ ที่ความถี่ 80 MHz ในขณะที่กวามถี่อื่นเช่น 10, 500, 1200 MHz มีก่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 0 W/m³ เท่านั้น เช่นเดียวกัน กับ SAR (Specific absorption rate) ในหน่วย W/kg ที่กำนวณใน CST รูปที่ 4.13 (ขวา) มีก่าสูงสุดที่ 4.2 W/kg บริเวณกลางวัสดุ แต่ที่บริเวณขอบและมุมทั้งแปดของวัสดุเป็นบริเวณที่มีค่าด่ำสุด สาเหตุ เพราะสนามไฟฟ้าที่บริเวณนั้นมีกวามเข้มต่ำ การที่สนามไฟฟ้าในวัสดุมีกวามเข้มตรงกลางวัสดุสูง เป็นเพราะเพลตถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่กวามถี่ที่ใช้งาน ทำให้กำลังถูกส่งผ่านมาได้ดี หากนำ เพลตมาใช้งานในกวามถิ่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมา จะทำให้กำลังส่วนมากถูกสะท้อนกลับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กลับรูปร่างของเพลตด้วย

 $SAR = C_p \frac{\Delta T}{\Delta t}$ (4.2)

เพื่อที่จะพยายามทำให้ทั่วทั้งวัสดุมีค่า Power loss ที่ Uniform จึงทำให้เพลตมีความ เหลื่อมวัสดุออกไป ผลการทดลองในรูปที่ 4.14 พบว่า การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าไม่มีความ แตกต่างจากการทำให้วัสดุเสมอกับขอบเพลต ทำให้ Power loss density มีการกระจายตัวที่ไม่ แตกต่างจากเดิม ที่บริเวณมุมและขอบยังมีค่าที่ต่ำกว่าบริเวณตรงกลาง จึงได้ทดลองทำให้เพลตมี ขนาดเล็กกว่าวัสดุ ผลที่ได้พบว่าที่ขอบและมุมของวัสดุยังคงมีความเข้มของสนามไฟฟ้าด่ำกว่า บริเวณตรงกลาง แต่การทำให้เพลตมีขนาดเล็กกว่าวัสดุไม่มากจะช่วยทำให้ ที่บริเวณขอบของความ กว้างมีค่าสนามไฟฟ้าในช่วงที่ต่ำ มีความแคบลง หมายความว่าบริเวณที่มีความเข้มสนามไฟฟ้าด่ำมี บริเวณน้อยลง ทำให้ในกรณีที่แย่ที่สุดคือ มีมอดข้าวไหลไปตามขอบ มอดจะยังได้รับพลังงานความ ร้อนจนตายได้ ในการออกแบบเบื้องต้นจากผลการทดลองที่ได้คือ ควรจะให้เพลตมีขนาดเล็กกว่า หรือเท่ากับขนาดของวัสดุระหว่างเพลตแต่เล็กกว่าไม่มาก ในการทดลองได้ให้ขนาดของเพลตมี ขนาดเล็กกว่าขนาดจองวัสดุไดอิเล็กทริกอยู่ 2 mm การนำไปใช้งานจริงคือวัสดุไดอิเล็กทริก จะเป็น ข้าวที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ผ่านเพลตในแนวตั้งฉากกับพื้นโลก ดังนั้นส่วนที่สำคัญคือขอบของด้าน กว้าง เนื่องจากถึงขอบของด้านยาวจะมีความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุจุดนั้นจะ ผ่านจุดตรงกลางเพลต ทำให้ยังกงได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อการฆ่ามอด



รูปที่ 4.12 การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของเพลตที่ Resonant ที่ 80 MHz ที่มุมเฟส 90 องศา ซึ่ง ทำให้มีควา<mark>มเข้</mark>มสนามไฟฟ้าสูงสุด



Phase (degree)	Electric field intensity (V/m)
0	93.875
30	1000.24
45	1365.96
60	1638.59
90	1837.88
120	1544.72
135	1233.2
150	837.644
180	93.875
210	1000.24
225	1365.96
240	1638.59
270	1837.88
300	1544.72
315	1233.2
330	837.644
360	93.875
	6

ตารางที่ 4.7 ความเข้มของสนามไฟฟ้าเมื่อมุมเฟสเปลี่ยนไป ของเพลตที่ Resonant ที่ 80 MHz

³ ว_ักยาลัยเทคโนโลยีสุรบโ



รูปที่ 4.13 ภาพตัดขวางของวัสคุได<mark>อิเล็</mark>กทริคที่อยู่ระหว่างเพลต (ซ้าย) การกระจายตัวของ Power loss density และ (ข<mark>วา)</mark> การกระจายตัวของ SAR



รูปที่ 4.14 ภาพตัดขวางของวัสดุ ใดอิเล็กทริกที่อยู่ระหว่างเพลต เพื่อดูการกระจายตัวของ Power loss density (ซ้าย) การเพิ่ม Margin ที่ขอบของด้านความกว้างเพลต 5mm และ (ขวา) เพิ่ม Margin ทั้งด้านกว้างและด้านยาวเพลตด้านละ 5 mm

4.1.5 ระยะห่างระหว่างเพลต

จากสมการ (2.6) เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าเมื่อระยะระหว่างเพลตสั้นลง ความเข้ม สนาม ไฟฟ้าจะสูงขึ้น และสมการ (2.22) ซึ่งบอกถึงค่าความเก็บประจุที่เพิ่มขึ้นเมื่อระยะระหว่าง เพลตขนานสั้นลง เมื่อระยะหว่างเพลตขนานเปลี่ยน จะทำให้ค่าความเก็บประจุเปลี่ยน และส่งผลให้ ความถิ่ Resonance เปลี่ยน ซึ่งถ้าหากเป็นเพลตที่มีการทำ Impedance matching ไว้แล้ว การ ปรับเปลี่ยนระยะของเพลตอาจจะต้องทำ Impedance matching ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันความ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแหล่งกำเนิดสัญญาณกำลังสูง หาก Mismatch จะมีกำลังส่วนใหญ่ที่ สะท้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดสัญญาณ ฉะนั้นระยะห่างระหว่างเพลตควรจะกำหนดไว้ตั้งแต่ตอน ออกแบบ อีกทั้งการปรับระยะระหว่างเพลต<mark>ขน</mark>านทำได้ลำบากหากมีการขึ้นรูปสร้างจริงไปแล้ว

4.2 ผลการวัดค่าสภาพยอมของข้าว (Permittivity of rice)

การ วัด ค่าสภาพขอมของข้าว ใช้ Dielectric probe (N1501A, Keysight) ร่วมกับ VNA Vector network analyzer (N9918A, Keysight) เพื่อหาค่า Dielectric constant และ Dielectric loss factor ในช่วงความถี่ 10 – 1000 MHz วัดค่าใดอิเล็กทริกข้าวสองชนิด แต่ละชนิดจะมีสามตัวอย่าง วัดซ้ำตัวอย่างละห้าครั้ง เพื่อขจัดค่ารบกวนอื่น ที่อาจทำให้การ วัดได้ผลคลาดเคลื่อนไป ผลการ วัด ข้าวขาวหรือข้าวเจ้า ได้ผลการ วัดในรูปที่ 4.15 ผลการ วัดที่ได้อาจมีความต่างจากค่าความเป็นจริง เนื่องจาก Dielectric probe ที่ใช้นี้ สามารถ วัดค่าไดอิเล็กทริกที่อยู่ในช่วงความถี่ 200 – 60000 MHz ทำให้ช่วงที่ต่ำกว่า 200 MHz ค่าที่วัดได้อาจจะเพียนไปจากความเป็นจริง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะ ไม่สามารถวัดค่าไดอิเล็กทริกในช่วงความถี่ที่ต้องการใช้งานคือ 80 MHz แต่ผลที่ได้จากการ วัด สามารถบอกได้ว่า ข้าวสาร (ข้าวเจ้า) และข้าวเหนียวมีความต่างกันของค่าไดอิเล็กทริกเล็กน้อย

ค่าใดอิเล็กทริคของข้าวสารมีค่า Dielectric constant และ Dielectric loss factor ทั้งสองค่า ต่ำกว่าข้าวเหนียวเล็กน้อย โดยค่า Dielectric constant ของข้าวสารจะมีค่าต่ำกว่าข้าวเหนียวโดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 0.37 และค่า Dielectric loss factor ของข้าวสารมีค่าต่ำกว่าข้าวเหนียวโดยเฉลี่ย 0.10 ค่า ใดอิเล็กทริคที่วัดนี้สามารถบอกได้ว่าข้าวทั้งสองชนิดมีค่าไดอิเล็กทริคที่ไม่เท่ากัน แต่เนื่องจาก ความต่างเพียงเล็กน้อยทำให้ระบบกำจัดมอดข้าวที่ออกแบบ สามารถใช้ได้กับข้าวทั้งสองชนิดคือ ข้าวสารและข้าวเหนียว



รูปที่ 4.15 ผลการ วัดค่า ใดอิเล็กทริดของข้าวสาร (เส้นทึบ) และ ข้าวเหนียว (เส้นจุด) ที่ความถี่ 10 – 1000 MHz (บน) ผลการ วัดค่า Dielectric constant คุณสมบัติทาง ใดอิเล็กทริดของ ข้าวสองชนิดมีก่า ใกล้เกียงกัน โดยข้าวสารมีก่าคงที่ ใดอิเล็กทริดต่ำกว่าข้าวเหนียว โดย เฉลี่ย 0.37 และ (ล่าง) ผลการ วัดก่า Dielectric loss factor ช่วงความถี่ที่ต่ำกว่า 300 MHz มีบางช่วงที่มีก่าติดลบ ซึ่ง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนื่องจาก Dielectric probe ที่ ใช้ เป็นประเภทความถี่สูง แต่ในทางตรวจสอบความแตกต่างระหว่างวัสดุ ใดอิเล็กทริด สองชนิด สามารถ ใช้ระบุถึงความแตกต่างกันหรือความเหมือนกัน ได้ ผลการ วัดที่ ได้ ข้าวสารมีก่าต่ำกว่าข้าวเหนียว โดยเฉลี่ย 0.10 ซึ่งแทบจะ ไม่แตกต่างกัน

4.3 ผลการทดสอบ Power amplifier

Power amplifier หรือเครื่องขยายสัญญาณกำลังสูง ใช้ LDMOS ในการสร้างเพื่อให้ได้ ้ประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับการขยายสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์อื่นที่ความถี่เดียวกัน ในการทคสอบ จะใช้ Dummy load 50 Ωแล้วดู RF power จาก RF meter เทียบกับกำลังไฟฟ้า (DC power) ที่ใช้ เพื่อ หาประสิทธิภาพของ Power amplifier ในการหาประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ใช้งานด้วย เนื่องจาก Power amplifier อาจมีประสิทธิภาพที่ดี แต่ไม่ใช่ความถี่ที่จะนำไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ้ดังนั้นจึงต้องปรับจูนให้ Power amplifier มีประสิทธิภาพที่ดีสำหรับความถี่ที่ใช้งาน จากรูปที่ 4.1 ค่า Dielectric loss factor ของมอคมี Relaxation peak ที่ความถี่ประมาณ 40 MHz จากสมการ (2.1) ถ้าให้สนามไฟฟ้าคงที่ แล้ว Plot ผลคูณระหว่าง ε'' , Dielectric loss factor และ f, Frequency จาก กราฟรูปที่ 4.1 จะ ได้ Power dissipation เท<mark>ียบกับ</mark>ข้อมูลความถี่ในตารางที่ 4.8 เห็นได้ว่า Relaxation peak ไม่ใช่จุดที่ทำให้ Power dissipation สูงที่สุด ในขณะที่เมื่อความถี่สูงมากไป จะทำให้ความ Uniform ของสนามไฟฟ้าภายในวัสคุ<mark>ไ</mark>คอิเล็ก<mark>ท</mark>ริคสูญเสียไป ซึ่งจะทำให้เกิคความร้อนที่ไม่ ู้สม่ำเสมอกันภายในวัสดุ จากผลการจ<mark>ำสอ</mark>งในหัวข้<mark>อที่</mark> 4.1 ความถี่ที่เหมาะสมจึงอยู่ในช่วง 80 – 120 MHz ถึงแม้ว่าที่ความถี่ต่ำจะมีความ Uniform ที่ดี แต่ Power dissipation แย่ และที่ความถี่สูงจะได้ Power dissipation ที่ดี แต่ความเป็น Uniform ของสนามใฟฟ้าแย่ และอาจจะทำให้ข้าวเกิดความ เสียหายจาก Overheating ได้ การเลือกใช้งานความถี่จึงเลือกกวามถี่ที่ 80MHz เนื่องจากที่ความถี่สูง กว่านี้ Power amplifier จะมีราคาสูงทั้งมีประสิทธิภาพที่ไม่เทียบเท่าความถี่ต่ำ ซึ่งความถี่ที่เลือกใช้นี้ ้เป็นความถี่ที่ใกล้เคียง<mark>ความ</mark>ถี่วิทยุ แต่ไม่ใช่ความถี่วิทยุ (88 – 108 MHz) จึงไม่รบกวนความถี่ ้ วิทยุกระจายเสียง ข้อดีข<mark>องการเลือกใช้ควา</mark>มถี่ใกล้เคียงค<mark>วามถี่วิ</mark>ทยุ คือสามารถคัดแปลงอุปกรณ์ ้งยายสัญญาณของวิทยุกระจ<mark>ายเสียงได้ โดยการปรับ Matchin</mark>g network อีกทั้ง Oscillator สามารถ หาซื้อได้ง่ายในรากาที่เหมาะสม

^{ุทย}าลัยเทคโนโลยีสุ^{รุง}

		0	
Frequency (MHz)	Rice weevil loss factor (\mathcal{E}_r'')	Power dissipation (MW/m ³)	
1	1.38	1.38	
5	1.8	9	
10	2.11	21.1	
20	2.19	43.8	
30	2.2	66	
40	2.29	91.6	
50	2.11	105.5	
60	2.09	125.4	
70	2.01	140.7	
80	1.98	158.4	
90	1.95	175.5	
100	1.89	189	
500	0.5	250	
1000	0.41 2 4	410	
2450	0.4	980	

ตารางที่ 4.8 Power dissipation ที่เกิดขึ้นในมอดที่กวามถี่ 1 – 2450 MHz เมื่อให้ $2\pi E^2 \varepsilon_0 = 1$

ะ ราว_{ภั}ยาลัยเทคโนโลยีสุรบาร เมื่อเลือกความถี่ที่จะใช้ จากนั้นส่วนที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ภาคกำเนิดสัญญาณ (Oscillator) สำหรับภาคขยายสัญญาณ เริ่มจากภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับ Oscillator ใช้ DC power supply 12 V (U8031A, Keysight) ซึ่งมีประสิทธิภาพ 92% และ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับ Power amplifier ใช้ DC power supply 48V (N8946A, Keysight) ที่มีประสิทธิภาพ 91.5% ตามที่ผู้ผลิตแจ้ง ในส่วนของ Oscillator จะให้กำเนิดความถี่ 80 MHz ซึ่งเมื่อจ่ายไฟฟ้าให้เริ่มทำงาน โดยจ่ายไฟฟ้า 12 V Oscillator กินกระแส 0.96 A ได้ RF power ที่ 80 MHz 2.5 W นับเฉพาะส่วนที่ Oscillator ใช้กำลังไฟฟ้าไป คำนวณได้จาก กำลังที่ใช้ + กำลังที่สูญเสียจากประสิทธิภาพของ Power supply จะเท่ากับ 12 V * 0.96 A + (12 V * 0.96 A) * (1 - 0.92) = 12.4416 W การชุดทดลองการ ทดสอบ Oscillator ดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 การทคสอบ Oscillator ที่ความถี่ 80 MHz โคยวัคกำลังส่งและ Harmonic ของสัญญาณ

การทดสอบ Oscillator นอกจากกำลังไฟฟ้าที่ใช้แล้ว ยังวัดกำลังของความถี่ที่ออกด้วย โดย ใช้ RF power meter (4391A, Bird) วัด RF power ใค้ 2.5 W และต่อเข้ากับ Spectrum analyzer (N9340B, Keysight) ก่อนที่สัญญาณจะเข้าที่เครื่อง Spectrum analyzer จำเป็นต้องต่อ Attenuator เพื่อลดทอนกำลังบางส่วนออกไป เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ เนื่องจาก Spectrum analyzer ส่วนมากจะรับ RF power ได้ไม่เกิน 2 W ในการทดลองนี้ใช้ Attenuator -20 dB ผลการวัด Spectrum ของสัญญาณที่มาจาก Oscillator ที่ความถี่พื้นฐานคือ 80 MHz วัดได้ 9.68 dBm ตามด้วยที่ Harmonic อันดับสองคือ 160 MHz ได้ -33.03 dBm ซึ่งต่างกันมากกว่า 40 dBm ถือว่าสัญญาณมี ความเป็น Sine สูงมาก ผลการทดสอบสัญญาณ Oscillator ที่ความถี่อื่นในตารางที่ 4.9 Oscillator ที่ ดีกวรจะกำเนิดสัญญาณเพียงความถี่เดียว แต่ในความเป็นจริงการกำเนิดสัญญาณความถี่จะมี Harmonic ตามมาด้วยเสมอ อยู่ที่ว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด จากผลการทดสอบ Oscillator ที่ได้ ถือ ว่าสัญญาณมีคุณภาพเนื่องจากความถี่ Harmonic มี Amplitude ต่ำกว่าความถี่พื้นฐานมาก

ความถี่ (MHz)	Amplitude (dBm)		
80	9.68		
160	-33.03		
240	-44.89		
400	-55.06		
560	-55.84		
640	-45.15		
720	-36.40		
⁷⁸¹ ลยเทคโนโลย			

ตารางที่ 4.9 ผลการวัด Harmonics ของ RF Oscillator ที่ความถี่ 80 MHz

เมื่อได้สัญญาณจาก Oscillator สัญญาณจะถูกส่งต่อไปยัง Power amplifier รูปที่ 4.17 เพื่อ งยายสัญญาณให้มีกำลังสูงขึ้น ซึ่งผลการทดสอบ Power amplifier เมื่อใช้กับ 50 Ω load ที่ 80 MHZ ได้ประสิทธิภาพ ที่ 93.3% P_{DC} = 449 W และ P_{RF} = 419 W วัดกำลัง DC จากที่ Power supply และ วัดกำลัง RF จาก RF power meter รูปสัญญาณในเฟสของกระแสใช้ Oscilloscope ที่ด้าน Probe ใช้ ขดลวดพันรอบแกนสาย Coaxial ที่ลอก Ground ที่หุ้มออก จำนวน 5 รอบ สัญญาณที่ได้ เป็นรูป Sine มีขนาดประมาณ 5 V เมื่อวัดดูสัญญาณ Harmonic จาก Spectrum analyzer พบว่ามี Harmonic อันดับคู่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.17 การทดสอบ Power amplifier ที่ความถี่ 80MHz

4.4 การออกแบบสร้างเพล<mark>ตขนา</mark>นสำหรับการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค

หลังจากที่ศึกษาการออกแบบเพลตจากการทดลองจำลองผลใน CST ขั้นต่อมาคือการสร้าง เพลตขนานเพื่อทดสอบใช้งานจริง โดยการออกแบบเพลตสำหรับความถี่ที่จะใช้งานโดยใช้แผ่น ทองแดงบางดังรูปที่ 4.18 ซ้ายคือเพลตขนาดเล็ก (5 x 5 x 1 cm) ขวาคือเพลตขนานขนาด (12 x 12 x 2 cm) ผลการ วัดที่ได้ดังรูปที่ 4.19 จากผลการ วัดพบว่าสำหรับเพลตขนาดเล็กความถี่ที่ Resonance จะสูงกว่าเพลตที่มีขนาดใหญ่กว่า ถึงแม้ว่าจะสามารถทำ Impedance matching ให้ใช้ได้กับความถี่ อื่น แต่ในทางปฏิบัติกวรเลือกใช้ขนาดของเพลตตามความเหมาะสมกับความถี่ที่ใช้ ข้อดีของการ เลือกใช้ความถี่สูง จะได้ Heat rate ที่สูงแต่ต้องแลกกับขนาดของเพลตที่เล็ก อีกทั้งการกระจายตัว ของสนามไฟฟ้าภายในเพลตที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ ส่งผลให้ Heat uniformly ต่ำ ในทางตรงกันข้าม การเลือกใช้ความถี่ต่ำ จะทำให้สามารถใช้เพลตขนาดใหญ่ขึ้นได้ และให้การกระจายตัวของความ ร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภายในบริเวณเพลต แต่ Heat rate ต่ำ ซึ่งจะร้อนได้ช้ากว่าการใช้ความถี่สูง การออกแบบเพลตขนาดจึงต้องกำนึงถึงความถี่ที่จะใช้งานด้วย



รูปที่ 4.18 เพลตที่ใช้ VNA วัค Impedance และ วัคค่า S11 (ซ้าย) เพลตขนาคเล็ก (5 x 5 x 1 cm) (ขวา) เพลตขนาคกลาง (12 x 12 x 2 cm)



รูปที่ 4.19 ผลการวัดเพลตขนานโดยใช้ VNA (ซ้าย) วัดเพลตขนาดเล็ก S11 อยู่ที่ความถี่ 77.13 MHz มีค่าประมาณ -25 dB และ (ขวา) ผลการวัดของเพลตขนาดกลาง S11 อยู่ที่ความถี่ 57.6 MHz ที่ -21 dB

หากต้องการใช้เพลตที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้ เพื่อรองรับกำลังที่สูงขึ้นหรือเหตุผลทางด้าน การเพิ่มกำลังทางการผลิตให้สูง การออกแบบเพลตขนาดใหญ่ก็ไม่ต่างจากการออกแบบเพลตขนาด เล็ก คือจะต้องคำนึงถึงการส่งผ่านกำลังสูงสุด เพื่อความปลอดภัยต่อเครื่องขยายสัญญาณกำลังสูง ในกรณีของการ Mismatch แล้วสัญญาณสะท้อนกลับเข้าสู่เครื่องขยายสัญญาณ หรือลดความ สูญเสียของกำลังที่เกิดขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นนอกจากการออกแบบเพลตและเลือกความถี่ที่ จะใช้แล้ว การออกแบบวงจร Impedance matching จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากวิธีการใช้ VNA สำหรับการทำ Impedance matching ที่ได้กล่าวไป อีกวิธีที่สามารถ ทำได้คือการใช้ Impedance analyzer วัดเพลตที่สร้างขึ้น รูปที่ 4.20 เครื่อง Impedance analyzer สามารถวิเคราะห์ค่าความต้านทาน ทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพ ตามความถี่ที่เลือกได้ อีกทั้งยัง สามารถบอกได้ว่า DUT (Device under test) นั้นเป็นก่าความเก็บประจุหรือก่าความเหนี่ยวนำเท่าใด โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้กำหนด การอ่านก่าให้กับเครื่องมือวัด

การสร้างเพลตโดยใช้เครื่อง Impedance analyzer ทำได้สองวิธี หนึ่งคือการทำให้เพลตมี Impedance ส่วนจริงเป็น 50 Ω จากนั้นนำ Inductance หรือ Capacitance มาหักลบหรือบวกส่วน จินตภาพให้เป็นศูนย์ ข้อสังเกตหนึ่งที่พบจากการวัดเพลต คือขนาดของเพลตมีผลต่อความถี่ที่เพลต มีส่วนจริง 50 Ω โดยขนาดของเพลตแปรผกผันกับความถี่ที่ 50 Ω หมายความว่ายิ่งเพลตขนาดเล็ก ความถี่ที่เพลตเป็น 50 Ω ยิ่งมีความถี่สูงขึ้น ทั้งนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าขนาดเพลตเท่าใดจึง จะได้ 50 Ω ที่ความถี่ใด เนื่องจากขึ้นอยู่กับวัสดุไดอิเล็กทริกที่อยู่ในเพลต ซึ่งมีความซับซ้อนสูง วิธี ที่ทำได้คือ Trial and try คือการทดลองสร้างเพลตและทำการทดลองวัดจริง

การวัดเพลตที่ขนาดแตกต่างกัน เพลตขนาด 4.5x7x30 cm แบบใน รูปที่ 4.20 Impedance ส่วนจริงที่มีค่าประมาณ 50 Ω อยู่ที่ความถี่ 7.6 MHz และมีค่าส่วนจินตภาพที่ -j644.34 Ω การที่ส่วน จินตภาพติดลบคือระบบที่นำมาวัดค่า Impedance มีความเป็น Capacitance สูงกว่า Inductance หาก จะ Matching ต้องนำ Inductance ที่มีขนาด +j644.34 Ω ที่ความถี่ 7.6 MHz เพื่อหักล้างส่วนจินตภาพ ให้ใกล้เคียง 0 มากที่สุด ซึ่งได้ค่า Inductance เท่ากับ 2.09 µH เมื่อนำ Inductance มาต่ออนุกรมกับ เพลต จะได้เพลตที่ Matching 50 Ω ที่ 7.6 MHz

วัดเพลตขนาด 4.5x7x13 cm ได้ Impedance 50.5-j510 Ω ที่ความถี่ 19.37 MHz (รูปที่ 4.21) วิธีการ Matching เช่นเดียวกันกับวิธีข้างต้น คือนำ Inductance มาหักล้างกับ Capacitance เพื่อให้ได้ 50 Ω ที่ส่วนจริงเพื่ออย่างเดียว เพลตขนาด 4.5x7x3.5 cm ได้ Impedance 50.9-j450.44 Ω ที่ความถี่ 55.68 MHz ตัวอย่างการ Matching เพลตด้วยวิธีนี้ถือ กำหนดความถี่ที่ต้องการ Matching จากนั้น สร้างเพลตแล้วนำไปวัด จากนั้นลดหรือเพิ่มขนาดเพลตเพื่อให้ได้ Impedance ที่ต้องการ unตัวอย่าง ด้องการออกแบบเพลตที่ความถี่ 95 MHz จากข้างต้น เพลตขนาด 4.5x7x3.5 cm ได้ที่ความถี่ 55.68 MHz แต่ที่ความถี่ 95 MHz ได้ Impedance 24.8-j48 Ω ส่วนจริงมีค่าต่ำกว่า 50 Ω ต้องเพิ่มความกว้าง ของเพลต เมื่อปรับความกว้างเพลตจนได้ระยะที่ได้ Impedance ประมาณ 50 Ω จากนั้นจึง Matching ด้วย Inductance โดยที่เพลตขนาดใหม่ 12x3.5x7 cm ได้ Impedance 47.1-j155.99 Ω (รูปที่ 4.22) ส่วนจริงมีค่าใกล้เคียง 50 หักลบส่วนจินตภาพโดยใช้ Inductance ขนาด 261.35nH จากนั้นยืนยันผล การ Matching โดยการใช้ VNA วัดเพลต รูปที่ 4.23 ได้ S11 เท่ากับ -10.24 dB ที่ความถี่ 95 MHz หลังจากสร้างเพลตเสร็จแล้ว ต่อไปคือการทดสอบให้ความร้อน รูปที่ 4.28 โดยใช้แหล่งกำเนิด สัญญาณความถี่สูงกำลังสูง 95 MHz 430 W ส่งกำลังไปยังเพลตโดยตรง จากนั้นวัดความร้อนที่ เกิดขึ้นที่ข้าว

อีกวิธีที่ใช้ออกแบบเพลตคือการกำหนด ขนาดของเพลตเพื่อให้ตรงกับความต้องการ สำหรับกำลังการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งถ้าหากเพลตมีขนาดเล็กมากเกินไป ไม่สามารถให้กำลังการผลิตที่ ต้องการได้ จึงต้องออกแบบเพลตที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่ Impedance จำเป็นต้อง Matching กับ RF power amplifier

ตัวอย่างการ Matching ที่ 25MHz เพลตขนาด 4.5x7x30 cm เมื่อนำมาวัดกับเครื่อง Impedance analyzer ที่ความถี่ 25 MHz ได้ค่าในรูปของ R±jX ได้เท่ากับ 19.64 - j131.87 Ω ที่ส่วน จินตภาพติดลบอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่นำมาวัดมีค่าความเป็น ความเก็บประจุเยอะกว่าความ เหนี่ยวนำ แต่เมื่อความถี่สูงขึ้นจนเลยจุด Self-resonance คือจุดที่อุปกรณ์นั้นมีค่า+j และ -j เท่ากัน หลังจากจุดนี้ อุปกรณ์นั้นจะมีค่าความเหนี่ยวนำมากว่าค่าความเก็บประจุซึ่งจะทำให้ Impedance ส่วนจินตภาพมีค่าเป็นบวก

เมื่อได้ค่า Impedance ของเพลตขนานแล้ว ต่อไปคือการออกแบบวงจร Impedance matching โดยใช้ Smith chart เพื่อที่จะทำให้ Impedance ฝั่ง Load มีค่าเท่ากับ 50 Ω ในการออกแบบ วงจรสามารถใช้เครื่องมือช่วยเหลือ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Online จาก www.will-kelsey.com เพื่อ มาวิเคราะห์วงจร โดยการใช้โปรแกรม เริ่มจากการกำหนดความถี่ที่จะใช้ และเลือกค่า Impedance ที่จะใช้ ในที่นี้ใช้ 50 Ω จากนั้นกำหนดค่า Impedance ใน Blackbox ขั้นตอนสุดท้ายคือการเลือก Component มาวางจนกว่าเส้นที่ลากจะมาหยุดที่ตรงกลางแผนภูมิ ซึ่งกีคือ 50 Ω ดังรูปที่ 4.25 จาก การใช้โปรแกรมช่วยจะได้วงจร Impedance matching คือตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมขนาด 990 nH และตัวเก็บประจุขนาด 155 pF ซึ่งเป็นค่าที่หาไม่ได้ทั่วไป ซึ่งหากใช้ก่าเก็บประจุขนาด 150 pF จะ เป็นค่าที่หาซื้อได้ทั่วไป ถึงจะไม่ได้ลงที่ 50 Ω อย่างที่ออกแบบไว้แต่สามารถยอมรับได้

การออกแบบเพลตที่กำลังการผลิต 100 kg/br ที่ความถี่ 95 MHz เนื่องจากข้าวมีความ หนาแน่น 1040 – 1100 kg/m3 ต้องการให้ข้าวอยู่ในเพลต 15 วินาที จะได้ขนาดเพลตเท่ากับ 4.5x7x14.5 cm เมื่อวัดเพลตที่ความถี่ 95 MHz ได้ Impedance 4.1+j120 Ω การที่ j เป็นบวกคือเพลต กลายเป็น Inductance แทนที่จะเป็น Capacitance ดังนั้นจึง Matching โดยการใส่ Capacitance ไป หักล้าง Inductance และเนื่องจาก Capacitor ที่ใส่ไปมีค่า Impedance ส่วนจริงด้วย ทำให้ระบบ โดยรวมมี Impedance ที่ใกล้เกียงระบบ 50 Ω ยืนยันการทดสอบโดยใช้ VNA รูปที่ 4.26 จากนั้น ทดสอบให้ความร้อนดังในรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.20 การใช้เครื่อง Impedance analyzer วัด Impedance ของเพลตขนานที่สร้างขึ้น



รูปที่ 4.21 เพลตขนาด 4.5x7x13 cm ได้ Impedance 50.5-j510 Ω ที่ความถี่ 19.37 MHz



รูปที่ 4.22 ออกแบบเพลตขนาด 12x3.5x7 cm ให้ใช้ได้กับระบบ 50 Ω ที่ 95 MHz



รูปที่ 4.23 ยืนผลการออกแบบเพลต โดยใช้ VNA ในการวัดค่า S11 ได้ -10.24dB @95 MHz



รูปที่ 4.24 การทดสอบเพลต (ซ้าย) ชุดทดสอบ RF power amplifier และเพลต (ขวา) วัดความ ร้อนของข้าวในเพลต



รูปที่ 4.25 การออกแบบวงจร Impedance matching โดยใช้ Smith chart



รูปที่ 4.26 การทดสอบผลการออกแบบเพลต 100 kg/hr ได้ S11 -10.2 dB ที่ความถี่ 95 MHz



รูปที่ 4.27 การทคสอบให้ความร้อนแบบ Dielectric heating ของการออกแบบเพลต 100 kg/hr ที่ ความถี่ 95 MHz

4.5 ผลการทดสอบระบบกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบใดอิเล็กทริค

ระบบกำจัดมอดข้าวในข้าวประกอบด้วย ภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC power) ภาคกำเนิด สัญญาณความถี่สูง (Oscillator) ภาคขยายสัญญาณความถี่สูงกำลังสูง (Power amplifier) และ โหลด เพลตขนาน (Parallel plate load)

ในผลการทคสอบ SSPA นั้นใช้ Dummy load ในการทคลอง ซึ่งเป็น Load ในอุดมคติ ไม่มี การสูญเสียกำลังเพราะ ไม่มีการสะท้อนกลับ แต่ในระบบกำจัคมอคข้าวต้นแบบนี้จะส่งสัญญาณที่ ้งยายแล้วไปยัง RF power meter ก่อนสัญญาณที่จะเข้าโหลดเพลตขนานที่มีข้าวอยู่ภายในระหว่าง เพลต แล้วใช้ IR camera วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง โดยต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล ้รูปที่ 4.28 ผลการทคสอบเบื้องต้นหลังจา<mark>กป้</mark>อนสัญญาณกำลังสูงไปยังโหลด กำลังของไฟฟ้า กระแสตรง DC power supply 48 V 22 A กับประสิทธิภาพ 91.5% คิดเป็นกำลัง 1056W กำลังที่ ส่งผ่านไปยังโหลด (Forward power) 773 W และมีกำลังบางส่วนสะท้อนกลับ (Reflected power) 7W ประสิทธิภาพของระบบแบบเพิ่มกำลังขาเข้า PAE ของระบบเท่ากับ 73.7% รูปที่ 4.29 เป็นข้าว ์ ที่ผ่านการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กท<mark>ริก</mark> ด้วยกำลัง 300 W ตั้งแต่ระยะเวลา 0 – 60 วินาที จุด S1 คือ อุณหภูมิแวคล้อม ที่อยู่บริเวณข้างเคียงของการทดลอง จุด S2 คืออุณหภูมิของข้าวที่ได้รับการให้ ้ความร้อน แต่เป็นเพียงจุดเดียว <mark>ซึ่ง พื</mark>้นที่ B1 คืออุณหภูม<mark>ิเฉลี่</mark>ยของข้าวที่อยู่ระหว่างเพลตขนาน เป็น อุณหภูมิที่จะนำไปพล็อตหา Heat rate และจุดสุดท้าย S3 เป็นอุณหภูมิบริเวณลวดทองแดงที่ใช้ทำ Coli เป็น Matching network ของเพลตขนาน ในรูปที่ 4.18 (บน) ที่เป็นจุดเริ่มต้นการให้ความร้อน ที่เวลา 0 วินาที อุณหภูม<mark>ิของ</mark>ทั้ง<mark>สามจุดมีความใกล้เคียงกั</mark>นมา<mark>ก เนื่</mark>องจากสภาวะแวดล้อมเคียวกัน ้ บริเวณใกล้เคียงกันย่อมม<mark>ือณหภูมิที่ไม่ต่างกันมาก อีกทั้งยังเป็นอณ</mark>หภูมิอ้างอิงว่าอุณหภูมิเริ่มต้นใน การทดลองนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ 25.0 °C เมื่อเวลาผ่านไป 7 วินาทีในรูปที่ 4.18 (กลาง) ซึ่งทำให้ อุณหภูมิของข้าวที่จุด S2 มีค่าประมาณ 50 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของข้าวที่ทำให้มอดเริ่มตาย (Vearasilp et al., 2015) จุด S1 ซึ่งเป็นอุณหภูมิสภาพแวคล้อมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และจุด S3 ที่ ้ถวดทองแดงมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 3.5 °C ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดการสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยง ้ไม่ได้ สุดท้ายรูปที่ 4.29 (ล่าง) เมื่อเวลาผ่านไป 60 วินาที อุณหภูมิของข้าวสูงอย่างมาก ที่จุด S2 151.8 °C แต่ที่สุงที่สุด อยู่ที่ 180 °C เป็นอุณหภูมิทำให้ข้าวเกิดความเสียหาย ไม่สามารถนำมาใช้ ้ประกอบอาหารได้ ในการทดลองได้ทดสอบเพื่อหาแนวโน้มของการเพิ่มของอุณหภูมิข้าวเมื่อเทียบ ้กับระยะเวลาที่เปลี่ยนไป เพราะการให้ความร้อนเพื่อกำจัดมอดข้าวจะไม่ให้อุณหภูมิข้าวเกิน 70 °C เนื่องด้วยกังวลว่าอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของข้าว ในการให้ความร้อนเพื่อการกำจัดมอดอุณหภูมิ ของข้าวจะอยู่ที่ 50 – 70 °C เท่านั้น

ประสิทธิภาพของระบบกำจัดมอดข้าวด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก เริ่มจาก ประสิทธิภาพของเครื่องขยายสัญญาณกำลังสูงซึ่งได้ 93.3% ต่อมาคือประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน ความร้อน ซึ่งเปลี่ยนจาก P_{RF} ไปเป็น P_{heat} คำนวณตามสมการ (3.4) และ (3.5) ซึ่งกำลังความร้อนที่ ได้จะมาจาก รูปที่ 4.30 Heat rate ของข้าว จะได้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ 94% สำหรับ P_{RF} = 300 W และ 96% สำหรับ P_{RF} = 773 W เมื่อกิดกำลังที่ใช้ทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการ แรก คือ P_{DC} จนมาเป็น P_{heat} จะได้ประสิทธิภาพที่ 64.1%



รูปที่ 4.28 การจัดชุดการทดลองระบบกำจัดมอดข้าวด้วยการให้กวามร้อนแบบไดอิเล็กทริก



รูปที่ 4.29 ข้อมูลภาพที่ได้จาก IR camera (U5857A, Keysight) ของการให้ความร้อนแบบ ใดอิเล็กทริคด้วยกำลัง 300 W ตั้งแต่เวลา 0 – 60 วินาที (บน) ที่เวลา 0 วินาที อุณหภูมิ ของทั้งสามจุดใกล้เกียงอุณหภูมิพื้นหลังที่ 25 °C (กลาง) เมื่อผ่านไป 7 วินาที อุณหภูมิ ของข้าวอยู่ที่ประมาณ 50 °C ซึ่งเพียงพอต่อการกำจัดมอดข้าว อุณหภูมิที่ Matching network เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 °C และอุณหภูมิพื้นหลังยังคงเท่าเดิม และ (ล่าง) ที่เวลาผ่าน ไป 60 วินาที อุณหภูมิของข้าวเท่ากับ 152 °C

การหา Heat rate ของการให้ความร้อนแบบใคอิเล็กทริคจะใช้อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณ B1 ใน ฐปที่ 4.29 โดยเปรียบเทียบสองกำลังที่ 300 W และ 773 W ที่เวลา 0 – 60 วินาทีได้ผลการทดลองดัง รูปที่ 4.30 ทั้งสองกำลังที่เปรียบเทียบกันมีอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 25.0 °C ในแต่ละช่วงเวลากราฟมีความ ้ชั่นไม่เท่าตลอดทั้งช่วง เนื่องจากเมื่อวัสดุไดอิเล็กทริกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ค่าไดอิเล็กทริกในวัสดุจะ เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ (Nelson, 2004, 2005; Nelson & Bartley Jr, 2002) เช่นเดียวกับข้าว ้ เมื่อข้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่าไดอิเล็กทริคในข้าวย่อมเปลี่ยนแปลงไป เมื่อค่าไดอิเล็กทริคเปลี่ยนทำให้ ้วงจรเพลตขนานมี Impedance ที่เปลี่ยนตาม แต่ในขณะที่ Matching network ยังคงมีค่าเท่าเดิมทำให้ การถ่ายโอนกำลังสูงสุดต่ำลง เนื่องจากโหลดเพลตขนาน Mismatch ไปจากเดิมเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในช่วงที่ Heat rate สูงที่สุดคือช่วงเริ่มต้นก<mark>าร</mark>ให้ความร้อน เมื่อนำข้อมูลที่ได้จาก Heat rate มา ้คำนวณเป็น Heat power เพื่อหาประสิทธิ<mark>ภาพขอ</mark>งการถ่ายโอนความร้อน Thermal efficiency ที่ใช้ กำลัง 300W ใด้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนที่ 94% จากสมการ (3.4) และกำลัง 773W ได้ ้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนที่ 9<mark>6</mark>% จาก<mark>ผ</mark>ลการทดลองที่ได้อาจจะมีค่าที่สูงมากกว่าความ เป็นจริงเนื่องจากค่า Specific heat capacity ของข้าวได้อ้างอิงจาก (Iguaz et al., 2003; Zhou & Wang, 2016a) ที่มีค่าอยู่ที่ประมาณ 1421 J/kg°C ซึ่งโคยปกติแล้วประสิทธิภาพการถ่ายโอนความ ร้อนโดยทั่วไปอยู่ที่ 76.5 – 79.5% (Hou et al., 2016) การศึกษาค่า Specific heat capacity ของข้าว แต่ละชนิดจำเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยต่อไป เนื่องจากข้าวในประเทศไทยอาจจะมีค่า Specific heat capacity ที่ต่างจากข้าวต่างประเทศ



รูปที่ 4.30 อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (Heat rate) ของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริคกับวัสดุไดอิ เล็กทริคที่เป็นข้าว (เส้นทึบ) ใช้กำลัง RF power 773 W Heat rate ที่ดีที่สุดเท่ากับ 10.5 °C/s และ (เส้นประ) RF power เท่ากับ 300 W ได้ Heat rate เท่ากับ 4.76 °C /s

4.6 ผลการทดลองการกำจัดมอดข้าวด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค และคุณภาพของข้าว

ผลทคลองการกำจัคมอดข้าวจากการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค ได้ตรวจสอบการอยู่ รอดของมอดหลังจากผ่านการกำจัดไปแล้ว 3 วัน ของการให้ความร้อนต่างช่วงเวลากัน 3 แบบ 2, 4, และ 10 วินาที และสองช่วง RF power ที่ 300W และที่ 773W ผลการทคลองการกำจัดมอดในตาราง ที่ 4.10

RF power และช่วงเวลาการ		มอด 30 ตัวในข้าว 100 กรัม			
ให้ความร้อน		อุณหภูมิ (°C)	อัตราการตายมอด (%)	คุณภาพข้าว	
0 W	Control	25.4	0	Normal	
300 W	2 s	34.53	3.33±3.33	Normal	
	4 s	42.37	7.77±1.92	Normal	
	10 s	60.42	91.11±8.38	Normal	
773 W	2 s	36.92	11.11±5.09	Normal	
	4 s	57.94	98.88±1.92	Normal	
	10 s	105.42	100	Bad	

ตารางที่ 4.10 อัตราการตายของมอดกับระยะเวลาในการให้ความร้อนและกำลังที่ใช้

การให้กำลังที่ 300 W ที่ 2 วินาที มอคมีอัตราการตายต่ำ เนื่องจากกำลังความร้อนที่ได้รับไม่ เพียงพอต่อการทำให้มอดตายได้ แต่ยังมีมอดบางตัวที่ตายหลังจากสามวัน อาจะเป็นเพราะมอดตัว โตเต็มวัยถึงอายุขัย หรือมอดมีกวามผิดปกติบางอย่างตั้งแต่กำเนิดจึงไม่แข็งแรง หรือด้วยสาเหตุอื่น แต่ไม่ใช่เพราะตายด้วยความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่ข้าวเพียง 34.53 °C เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อ การทำให้มอดตายเพราะกวามร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่ข้าวเพียง 34.53 °C เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อ การทำให้มอดตายเพราะกวามร้อน (Yan et al., 2014) ในด้านของกุณภาพและประสบการณ์การกิน รสสัมผัสของข้าวที่หุงแล้ว จากอาสาสมักร 5 คน ถูกสุ่มทั้งหมด 7 ตัวอย่างข้าวตามตาราง พบว่าการ ให้กะแนนของข้าวที่ผ่านการกำจัดมอดด้วยการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก 300 W, 2 s ในด้าน กะแนน ไม่มีความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญกับชุดควบคุม (Control) การทดลองต่อมาในการเพิ่ม ระยะเวลาการให้กวามร้อนเป็น 4 วินาที พบว่ามอดมีอัตราการตายสูงขึ้น แต่ไม่ตายทั้งหมด บางส่วนที่ตายอาจจะเป็นเพราะความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวมอด การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก อุณหภูมิที่เกิดขึ้นในวัสดุต่างก่าไดอิเล็กทริกกัน จะมีอุณหภูมิต่างกันในกรณีของข้าวกับมอดข้าว ที่ 80 MHz ค่า Dielectric loss factor ต่างกัน 5 เท่า ดังนั้น Power dissipation ของข้าวกับ มอดข้าวต่างกัน 5 เท่า อุณหภูมิที่มอดข้าวจะสูงกว่าที่วัดได้จากข้าว แต่จะเป็นเท่าใดต้องทราบค่า Specific heat capacity ของมอดข้าวที่ต้องศึกษาต่อไป ดังนั้นถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากข้าวจะ เท่ากับ 42.37 °C แต่อุณหภูมิที่เกิดในตัวมอดจะสูงกว่า และแม้เพียงระยะเวลาสั้น 4 วินาที ด้วยความ ร้อนที่เกิดขึ้นจึงทำให้มอดบางส่วนตายไป มอดที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สังเกตได้มีลักษณะเหมือน องก์ประกอบของร่างกายไม่ครบ เช่นบางตัวมีขาหลุด ขาไม่ครบ แต่ยังขยับได้อยู่ภายในสามวัน หลังจากการให้ความร้อน และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินเจ็ดวันหลังจากที่ให้ความร้อนด้วยกำลัง 300W และระยะเวลา 4 วินาที ด้านคุณภาพของข้าวได้คะแนนไม่ต่างจากชุดควบคุม สุดท้ายของการ ใช้กำลัง 300W คือให้ระยะเวลาการให้ความร้อน 10 วินาที มอดข้าวตายเกือบทั้งหมด 91.11±8.38% ในขณะที่คุณภาพของข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาสาสมัครไม่สามารถบอกถึงความต่างจากข้าวปกติที่ไม่ ผ่านการให้ความร้อน จากข้อมูลในเบื้องต้นทำให้สรุปได้ว่าอัตราการตายของมอดขึ้นโดยตรงกับ พลังงานที่ได้รับ

การทุดถองเพิ่มเติม โดยการใช้ RF power 773 W โดยให้ระยะเวลาการให้ความร้อน เช่นเดียวกันกับกำลัง 300 W โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิ อัตราการตายของมอคหลังจากสามวัน และ ้คุณภาพรสสัมผัสของข้าวที่หุง<mark>แล้ว</mark>ที่ผ่านการกำจัดมอด<mark>ด้วย</mark>การให้กวามร้อนแบบไดอิเล็กทริค ใน การทดลองต่อมา ใช้กำลัง 773 W ระยะเวลา 2 วินาที อุณหภูมิของข้าวไม่ต่างกันมากจากกำลัง 300 W ที่ระยะเวลาการให้ค<mark>วาม</mark>ร้อ<mark>นเดียว</mark>กัน แต่มอ<mark>ดมีอัตร</mark>าก<mark>ารต</mark>ายสูงกว่า เป็นเพราะความเข้ม ้สนามไฟฟ้าที่สูงกว่าม<mark>ากกว่าเท่าตัว อาจจะทำให้มอดม</mark>ีอัตราการตายที่สูงกว่า เนื่องจาก Power dissipation จะขึ้นโดยตร<mark>งกับความเข้มสนาม</mark>ไฟฟ้ายกกำลังสอง เมื่อความเข้มสูงกว่าทำให้มอดเกิด ้ความร้อนภายในตัวได้สูง <mark>แต่การที่อุณหภูมิของข้าวไม่แตกต่</mark>างกันมากเป็นเพราะข้าวมีปริมาณ (มวล) ที่เยอะ ตามสมการกำลังของความร้อน (3.5) เมื่อระยะเวลาที่ใช้น้อยพอกัน มวลเท่ากัน กำลัง ที่ใช้ต่างย่อมทำให้อุณหภูมิสุดท้ายต่างกัน ในการให้ความร้อน 2 วินาที อาจจะน้อยเกิดไปที่จะทำให้ ้อุณหภูมิของข้าวทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จึงทำให้อุณหภูมิที่วัดได้ไม่แตกต่างกันมาก แต่อัตราการตายของมอคสูงกว่า เพราะกำลังที่สูงกว่าทำให้ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงเกิดการเปลี่ยน พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อนได้สูงกว่ากำลังต่ำ ทำให้อัตราการตายมอด ้สูงกว่า การให้ความร้อนด้วยกำลัง 300 W 4 วินาที ในด้านมอดที่ยังไม่ตายมีลักษณะคล้ายกับการให้ ้ความร้อน 300 W 4 วินาที คือมีขาไม่ครบ เชื่องช้า อาจจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกไม่นาน หรือสูญเสีย ้ความสามารถในการขยายพันธุ์ ซึ่งต้องศึกษาต่อไป ในเบื้องต้นหลังจากสามวันการให้ความร้อน ด้วยกำลัง 773 W 2 วินาที อัตราการตายมอดข้าวเท่ากับ 11.11±5.09%

การทดลองต่อมาคือเพิ่มระยะเวลาการให้ความร้อนด้วยการใช้กำลังเท่าเดิม 773 W เมื่อ ทดลองให้ความร้อนเป็นระยะเวลา 4 วินาที พบว่าในบางครั้งของการทดลองไม่มีมอดมีชีวิตอยู่เลย และค่าเฉลี่ยอัตราการตายของมอดเท่ากับ 98.88±1.92% อุณหภูมิของข้าวอยู่ที่ 57.94°C ด้านรส สัมผัสของข้าวได้คะแนนไม่ต่างจากชุดควบคุม ถึงแม้ว่าอัตราการตายของมอดจะไม่ใช่ 100% ทุก ครั้งหลังจากสามวัน แต่มอดที่เหลืออาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน และถึงจะยังมีชีวิตอยู่ได้ ความสามารถในการขยายพันธุ์จะสูญเสียความสามารถไป

สุดท้ายการให้ความร้อน 773 W เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทำให้มอดตายทั้งหมด ใน งณะเดียวกันทางด้านคุณภาพของข้าวและรสสัมผัสจากการรับประทานข้าวที่หุงแล้ว ได้คะแนนแย่ ที่สุดที่มีการทดลอง เนื่องมาจากอุณหภูมิของข้าวที่สูงเกิน 100 °C อาจจะทำให้ส่วนประกอบของน้ำ ที่อยู่ในข้าวร้อนจนเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สและระเหยออกไป ซึ่งทำให้ความชื้นที่อยู่ในข้าวลด ต่ำลงมากจนข้าวแห้งและถูกความร้อนทำลายกุณภาพข้าว กลายไปข้าวที่มีรสสัมผัสที่ต่างจากเดิม เมื่อนำไปหุงหรือปรุงให้สุกด้วยวิธีอื่น และไม่สามารถนำมาประกอบอาหารให้รับประทานได้อีก ต่อไป ถึงแม้ว่ามอดจะถูกกำจัดทั้งหมดอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูง เพราะอุณหภูมิในมอดย่อมสูง กว่าที่ข้าว แต่ไม่สามารถนำข้าวที่ผ่านการกำจัดมอดมาใช้ได้ ดังนั้นการให้ความร้อนที่ช่วงกำลัง และระยะเวลาที่ให้ความร้อนนี้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ หรืออาจจะต้องมีการเป่าลมระบายความ ร้อนในระหว่างที่ให้ความร้อนซึ่งจะต้องศึกษาต่อไป

ในแง่ของการเก็บรักษาข้าวด้วยการกำจัดมอดผ่านการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก ที่ ประหยัดพลังงานมากที่สุด ถ้าเลือกระหว่างช่วงกำลังต่ำแต่ให้ระยะเวลาให้ความร้อนนาน 300 W ระยะเวลา 10 – 12 วินาที กับกำลังสูงในระยะเวลาสั้น 773 W ระยะเวลา 4 – 6 วินาที ช่วงของ อุณหภูมิที่เกิดขึ้น ของ 300 W จะมีอุณหภูมิในช่วง 60.4 – 65.5 และ 57.9 – 75.4 °C ตามลำดับ พลังงานที่ใช้จะอยู่ในช่วง 30 – 36kJ/kg และ 30.92 – 46.38kJ/kg นับว่าการใช้กำลังต่ำนั้นประหยัด พลังงานมากกว่าแต่ใช้เวลานานกว่าการใช้กำลังสูง ถ้าพิจารณาในแง่ของกำลังการผลิตนั้น การใช้ กำลังสูงจะได้ Throughput ที่สูงกว่า ความแตกต่างระหว่างสองกำลังไฟฟ้าที่ใช้อยู่ที่ Heat rate ซึ่ง กำลังสูงกว่าจะได้ Heat rate ที่มีความชั่นมากกว่า ทำให้อุณหภูมิที่เกิดขึ้นในข้าวสูงขึ้นเร็วกว่ากำลัง ท่ใช้งานต่ำ ซึ่งต้องศึกษาต่อไปว่าการให้อุณหภูมิสูงภายในระยะเวลาสั้น มีผลดีกว่าหรือแย่กว่าการ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างช้า ซึ่งอาจจะมีผลต่อคุณก่าทางโภชณาการของข้าว หรือทำให้คุณสมบัติ บางอย่างของข้าวเปลี่ยนแปลงไป

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ระบบกำจัดมอดข้าวที่พัฒนาขึ้นจาก SSPA (Solid-state power amplifier) สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในส่วนของ DC to RF power conversion คือการแปลงกำลังไฟฟ้าจากไฟฟ้า กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง เมื่อเทียบกับการใช้หลอดสุญญากาศ ซึ่งประสิทธิภาพ โดยทั่วไปของหลอดสุญญากาศอยู่ที่ 50 – 60% แต่ SSPA ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี LDMOS (Laterally Diffused MOSFET) ประสิทธิภาพโดยทั่วไปอยู่ที่ 70 – 80% และสามารถเพิ่มขีดจำกัดได้ โดยการ Optimization วงจร Power amplifier นอกจากนี้การออกแบบเพลตขนานที่ดีสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในส่วนของ Thermal efficiency คือการแปลงกำลังไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงไป เป็นกำลังความร้อน Electromagnetic energy to heat power dissipation conversion การ Matching เพลตมีผลอย่างมากกับสนามไฟฟ้าภายในเพลต รวมถึงความเข้มของสนามไฟฟ้าต่อมุมเฟสที่ เปลี่ยนไป ตลอดจนการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ

การกำจัดมอดด้วยการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำจะใช้เวลาในการกำจัดนานกว่าการใช้กำลังไฟฟ้าที่ สูง แต่การใช้กำลังไฟฟ้าต่ำจะประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้กำลังสูงในปริมาณข้าวเท่ากัน ซึ่ง อัตราการตายของมอดขึ้นโดยตรงกับพลังงานที่ได้รับ ตัวแปรที่มีผลกับพลังงาน กำลังไฟฟ้าที่ใช้ ระยะเวลาที่ให้มอดได้รับพลังงาน ความเข้มสนามไฟฟ้าระหว่างเพลต รวมถึงความถี่ที่เพลต Resonant เนื่องจากที่ความถี่สูง Power dissipation จะสูงขึ้นตามความถี่กูณกับค่า Dielectric loss factor และค่าพารามิเตอร์ S11 ของเพลตซึ่งหาก S11 ต่ำหมายถึงการสะท้อนกลับต่ำ แสดงว่ากำลังที่ เหลือถูกเพลตซับกำลังไปทั้งหมด

5.2 ข้อเสนอแนะ

ระบบกำจัดมอดประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ใช้สำหรับครัวเรือน เนื่องจาก กำลังไฟฟ้าที่ไม่ได้สูงมาก รวมถึงขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป เหมาะที่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน บ้าน กำลังความร้อนมาจากกำลังไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง การจะนำระบบกำจัดมอด ประสิทธิภาพสูงนี้ไปใช้กับขนาดอุตสาหกรรม จะต้องปรับปรุงในส่วนของประสิทธิภาพของ Power amplifier ที่ใช้อยู่ในงานวิจัยนี้เป็น Class AB Push-Pull ที่มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ ในทางทฤษฎี Class E สามารถให้ประสิทธิภาพได้ถึง 99.99% ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องศึกษา ต่อไป รวมทั้งการรวมกำลังจาก Power amplifier หลายโมดูลเพื่อให้ได้กำลังสูงนับเป็นเรื่องที่ท้า ทาย ส่วนการออกแบบเพลตสามารถทำนายผลได้ด้วยการจำลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนที่ จะนำไปขึ้นรูปเพื่อใช้งานจริงในส่วนของคุณภาพทางกายภาพหรือทางเคมีของข้าว เป็นสิ่งที่ต้อง ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะเพียงการทดลองหุงข้าวเพื่อรับประทานโดยอาสาสมัคร ไม่สามารถ บอกได้ว่าข้าวมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดไปบ้างในระดับโมเลกุล หลังจากที่ผ่านการให้ความร้อน แบบไดอิเล็กทริก อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิด Chemical shift ในข้าวซึ่งอาจส่งผลดีหรือผลเสียกับตัว ข้าวหรือแม้แต่กับผู้บริโภคได้ที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป



รายการอ้างอิง

- Alba, S. A., & Berestov, A. A. (2016). High power megahertz range solid state generator: Experimental tests with dielectric melting furnace. Paper presented at the International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM.
- Bowick, C., Blyler, J., & Ajluni, C. (2008). Chapter 4 Impedance Matching. In C. Bowick, J. Blyler, & C. Ajluni (Eds.), RF Circuit Design (Second Edition) (pp. 63-102). Burlington: Newnes.
- Davis, S. R. (2011). Rostrum structure and development in the rice weevil Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionoidea: Dryophthoridae). Arthropod Structure and Development, 40(6), 549-558. doi:10.1016/j.asd.2011.06.002
- Duangkhamchan, W., Phomphai, A., Wanna, R., Wiset, L., Laohavanich, J., Ronsse, F., & Pieters, J. G. (2017). Infrared Heating as a Disinfestation Method Against Sitophilus oryzae and Its Effect on Textural and Cooking Properties of Milled Rice. Food and Bioprocess Technology, 10(2), 284-295. doi:10.1007/s11947-016-1813-z
- Ferrari-John, R. S., Katrib, J., Palade, P., Batchelor, A. R., Dodds, C., & Kingman, S. W. (2016). A Tool for Predicting Heating Uniformity in Industrial Radio Frequency Processing. Food and Bioprocess Technology, 9(11), 1865-1873. doi:10.1007/s11947-016-1762-6
- Follett, P. A., Rivera-Leong, K., & Myers, R. (2014). Rice weevil response to basil oil fumigation. Journal of Asia-Pacific Entomology, 17(2), 119-121. doi:10.1016/j.aspen.2013.11.008
- Hossain, F., Lacroix, M., Salmieri, S., Vu, K., & Follett, P. A. (2014). Basil oil fumigation increases radiation sensitivity in adult Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Stored Products Research, 59, 108-112. doi:10.1016/j.jspr.2014.06.003
- Hou, L., Johnson, J. A., & Wang, S. (2016). Radio frequency heating for postharvest control of pests in agricultural products: A review. Postharvest Biology and Technology, 113, 106-118. doi:10.1016/j.postharvbio.2015.11.011
- Iguaz, A., San Martín, M. B., Arroqui, C., Fernández, T., Maté, J. I., & Vírseda, P. (2003). Thermophysical properties of medium grain rough rice (LIDO cultivar) at medium and low temperatures. European Food Research and Technology, 217(3), 224-229. doi:10.1007/s00217-003-0760-x
- Jeon, J.-H., Oh, M.-S., Cho, K.-S., & Lee, H.-S. (2012). Phototactic response of the rice weevil, Sitophilus oryzae linnaeus (Coleoptera: Curculionidae), to light-emitting diodes. Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 55(1), 35-39. doi:10.1007/s13765-012-0006-3
- Kasap, S. O. (2006). Principles of Electronic Materials and Devices (3rd ed.): McGraw-Hill.
- Law-Ogbomo, K. E., & Enobakhare, D. A. (2007). The use of leaf powders of Ocimum gratissimum and Vernonia amygdalina for the management of Sitophilus oryzae (Lin.) in stored rice. Journal of Entomology, 4(3), 253-257. doi:10.3923/je.2007.253.257
- McDonough, M. X., Mason, L. J., & Woloshuk, C. P. (2011). Susceptibility of stored product insects to high concentrations of ozone at different exposure intervals. Journal of Stored Products Research, 47(4), 306-310. doi:10.1016/j.jspr.2011.04.003
- Nelson, S. O. (1996). Review and assessment of radio-frequency and microwave energy for storedgrain insect control. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 39(4), 1475-1484.
- Nelson, S. O. (2004). Agricultural applications of dielectric spectroscopy. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 39(2), 75-85. doi:10.1080/08327823.2004.11688510
- Nelson, S. O. (2005). Dielectric spectroscopy in agriculture. Journal of Non-Crystalline Solids, 351(33-36 SPEC. ISS.), 2940-2944. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2005.04.081
- Nelson, S. O., & Bartley Jr, P. G. (2002). Measuring frequency- and temperature-dependent permittivities of food materials. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 51(4), 589-592. doi:10.1109/TIM.2002.802244
- Ponomaryova, I. A., De Rivera Y Oyarzabal, L. N., & Sánchez, E. R. (2009). Interaction of radiofrequency, high-strength electric fields with harmful insects. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 43(4), 43417-43427.

- Vearasilp, S., Thanapornpoonpong, S.-n., Krittigamas, N., Suriyong, S., Akaranuchat, P., & von Hörsten, D. (2015). Vertical Operating Prototype Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 5(Supplement C), 184-192. doi:https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.028
- Wang, S., & Tang, J. (2001). Radio frequency and microwave alternative treatments for insect control in nuts: A review. International Agricultural Engineering Journal, 10(3-4), 105-120.
- Wangspa, W., Chanbang, Y., & Vearasilp, S. (2015). Radio frequency heat treatment for controlling rice weevil in rough rice cv. Khao Dawk Mali 105. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 14(2), 189-197. doi:10.12982/CMUJNS.2015.0081
- Yan, R., Huang, Z., Zhu, H., Johnson, J. A., & Wang, S. (2014). Thermal death kinetics of adult Sitophilus oryzae and effects of heating rate on thermotolerance. Journal of Stored Products Research, 59, 231-236. doi:10.1016/j.jspr.2014.03.006
- Zakladnoy, G. A. (2018). Effect of Grain Infestation with the Rice Weevil Sitophilus oryzae L. (Coleoptera, Dryophthoridae) on the Quality of Grain and Grain Products. Entomological Review, 98(6), 659-662. doi:10.1134/S0013873818060015
- Zhou, L., & Wang, S. (2016a). Industrial-scale radio frequency treatments to control Sitophilus oryzae in rough, brown, and milled rice. Journal of Stored Products Research, 68, 9-18. doi:10.1016/j.jspr.2016.03.002
- Zhou, L., & Wang, S. (2016b). Verification of radio frequency heating uniformity and Sitophilus oryzae control in rough, brown, and milled rice. Journal of Stored Products Research, 65, 40-47. doi:10.1016/j.jspr.2015.12.003

์ ภาคผนว<mark>ก</mark>

บทความทางวิชาก<mark>ารที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแ</mark>พร่ในระหว่างศึกษา



รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา

Saeung, P., Santalunai, S., Thosdeekoraphat, T., & Thongsopa, C. (2018). Improved efficiency of insect pest control system by SSPA. Paper presented at the 2018 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2018.



ประวัติผู้เขียน

นายภาณุพงษ์ แซ่อึ้ง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เริ่มศึกษาระดับ ประถมศึกษาที่ โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนบ้านปะหลาน มหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนพยัคมภูมิวิทยาการ มหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2558 หลังสำเร็จการศึกษาภายในปีเดียวกัน ใด้เริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเข้ารับการศึกษาได้เป็นผู้ช่วยสอน วิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ วิชาปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาปฏิบัติการโฟตอนนิกส์ และวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสูง 1 ในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมทำวิจัย โดยเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อ "การออกแบบระบบควบคุมและการประยุกต์ใช้งานตัวตรวจรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0"

หัวข้อวิจัยที่มีความถนัดเป็นพิเศษคือ การออกแบบวงจรทางค้านคลื่นความถี่สูง การให้ ความร้อนแบบไดอิเล็กทริค และวิศวกรรมสายอากาศ มีงานอดิเรกด้วยการเป็นนักเขียนโปรแกรม กอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบระบบจัดการข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูล และออกแบบระบบการประยุกต์การใช้งาน IoT ร่วมกับตัวตรวจรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัย : ได้เสนอบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2018 ที่ Shaw Foundation Alumni House, National University of Singapore, Singapore. ในหัวข้อ Improved efficiency of insect pest control system by SSPA.